Zeitschrift für angewandte Physik

REIZEHNTER BAND

JANUAR 1961

HEFT 1

ielektrische Verluste unpolarer isolierender Flüssigkeiten durch Anreicherungsrandschichten

Von Johannes Jaumann und Chrysanth Marnet

Mit 16 Textabbildungen

(Eingegangen am 27. August 1960)

1. Problemstellung

Versuche, durch erprobte Reinigungsverfahren zu aldefinierten Werten des dielektrischen Verlustters (tg δ) zu gelangen, beseitigten in reinen Transmator- und Kabelölen sowie Tetrachlorkohlenstoff, geläufig, den Gang desselben mit der angelegten chselspannung bis zu einem mehr oder weniger tlichen Ionisationsknick.

Für die folgende Diskussion ist es wichtig festzellen, daß unsere Verlustfaktormessungen sich it auf das Verhalten bei hohen Feldern beziehen, dern daß wir den Grenzwert für möglichst schwache ehselfelder zu ermitteln versucht haben. Experitell war freilich durch die Empfindlichkeit der ering-Brücke eine untere Grenze der Feldstärke eben; der gemessene Verlustfaktor blieb aber noch etwa zum 10fachen Wert völlig ungeändert.

Aus diesem Grunde scheiden alle nichtlinearen kte, die in den Theorien von Schumann [1] und Böning [2] eine entscheidende Rolle spielen, aus. sind durch Grenzflächen beschränkte Ladungserwege mit variablen Ladungsträgerhäufungen den Grenzflächen, verbunden mit "Ionenstromten" und einer starken Abhängigkeit des Verlustors von der Laufzeit der Träger, d.h. von der amplitude, Schichtdicke und Zähigkeit, ferner lestfeldstärken für das Ablösen von Trägerthten oder das Freiwerden von Gleitionen. Diese gänge sind sicher für die Deutung der Erscheiten bei hohen Feldamplituden wesentlich.

Protzdem blieb aber bei Anwendung eines während Messung verstellbaren, luftdichten Kondensators n bei 50 Hz eine starke lineare Zunahme des Veruktors mit wachsendem Plattenabstand, unabhängig der Spannung, insbesondere auch bei konstant Itener Feldstärke bestehen. Die einzige Andeueines solchen Dicken-Effektes in der Literaturen wir nur in den Messungen von Möllinger [3]. ei höheren Frequenzen (800, 4000 Hz) wird naheer gesamte Verlustfaktor dem Plattenabstand proonal!

ährend der vom Abstand nicht abhängige Anteil Terlustfaktors, d.h. der auf den Abstand Null polierte Wert bei 50 Hz in gewohnter Weise fast rtional zur reziproken Zähigkeit der Flüssigkeit vachsender Temperatur stark zunimmt, trifft ür den abstandsabhängigen Anteil nicht zu. In Temperaturintervall in welchem die Zähigkeit wei Größenordnungen abnimmt, wächst er weals 30%. Im dünnflüssigen Tetrachlorkohlenstoff kaum höher als in dicken Isolierölen. Bei höheren ienzen (800, 4000 Hz) gelten diese Aussagen isch für den gesamten Verlustfaktor.

Eine Abhängigkeit vom Plattenabstand legt man gewöhnlich als eine Überlagerung von zwei Prozessen — im Volumen und an den Oberflächen — aus. Betrachten wir, statt des Verlustfaktors, die Energieverluste im gesamten Kondensator und halten bei der Abstandsänderung die Feldamplitude fest. Die naheliegende Annahme wäre dann, daß der Energieumsatz je Oberflächeneinheit und jener pro Volumeneinheit unabhängig vom Abstand bleiben. Dann würde der Gesamtverlust linear mit dem Abstand wachsen, seine Extrapolation auf den Abstand Null den reinen Oberflächenverlust liefern. Wir finden aber ein quadratisches Anwachsen des Gesamtverlustes mit dem Abstand. Die quadratische Extrapolation auf den Abstand Null liefert bei höheren Frequenzen nur einen verschwindend kleinen Rest. Bei 50 Hz liefert der extrapolierte Teil das geläufige dielektrische Verhalten.

Wir müssen also annehmen, daß mit wachsendem Abstand sich die Ladungsträger — oder was sonst immer die Wärmeproduktion pro Volumeneinheit bedingt — im Volumen des Kondensators unhomogen verteilen und zwar so sehr, daß dadurch auch die Feldverteilung unhomogen wird. Dann besteht die Möglichkeit, daß bei fester Trägerzahl im Gesamtvolumen und fester Spannungsamplitude der Gesamtenergieumsatz gegenüber einer homogenen Verteilung geändert wird.

Aus den Erfahrungen bei der Aufladung ausströmender isolierender Flüssigkeiten ist die Annahme einer Ladungsträgeranhäufung am Rand gerechtfertigt [4]. Die Verlustwinkelmessungen besagen unter dieser Annahme, daß

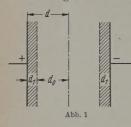
1. sieh die Anhäufungen mit dem Kondensatorvolumen (Abstand) stark ändern;

2. sie durch Temperaturerhöhung so stark aufgelockert werden, daß die Feldunhomogenität gemildert wird, und die Gesamtverluste etwa ungeändert bleiben.

Bei temperaturunabhängiger Feldverteilung würden sie ja stark mit der Temperatur wachsen.

So künstlich die Annahmen auf den ersten Blick erscheinen mögen, werden wir doch zeigen können, daß z.B. unter der Bedingung, daß alle im gesamten Kondensatorvolumen verfügbaren Ladungsträger (oder ein fester Bruchteil von ihnen) zum Aufbau von Anreicherungsrandschichten vor den Kondensatorplatten herangezogen werden, die wesentlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Derartige Anreicherungsschichten sind an den Grenzflächen von Elektrolyten (von Helmholtz als "Doppelschichten" eingeführt) durch die Erforschung der elektrokapillaren Phänomene gesichert. Die Anreicherungsschicht hat hier unter der Wirkung eines elektrischen Feldes parallel zur isolierenden Oberfläche eine viel höhere Beweglichkeit als senkrecht dazu, weil im ersten Fall die Flüssigkeit von den Ladungsträgern mitgenommen wird, im zweiten aber nicht, und die Teilchen die Reibung der Relativbewegung zur Flüssigkeit überwinden müssen. Die hohe Beweglichkeit der "Gleitionen" im Feld parallel der Oberfläche, gibt in Elektrolyten zu der Erscheinung der Elektroosmose Anlaß. Böning [5] hat darauf eine umfassende Theorie der dielektrischen Verluste in technischen Isolierstoffen mit Faserstruktur entwickelt und deren Geltungsbereich auf isolierende Flüssigkeiten ausgedehnt in denen vermutlich kolloidale Verunreinigung von Trägerschichten umgeben sind. Diese Theorie beschreibt das nichtlineare Verhalten bei hohen Feldstärken gut und erlaubt nicht den Grenzübergang zu



beliebig kleinen Feldern. Es wird sogar eine untere Grenze der Feldstärke ausdrücklich eingeführt.

In unserem Fall liegt die für unsere Deutung wesentliche Trägerschicht auf der Oberfläche genau senkrecht zum elektrischen Feld. Eine Gleitung wird durch dieses nicht ausgelöst, wohl aber

Trägerbewegungen senkrecht zur Oberfläche. Bei Anlegen eines statischen Feldes stellt sich eine neue Trägerverteilung mit geändertem Dipolmoment pro Flächeneinheit ein, eine "Polarisation der Doppelschicht", bei langsamer Feldänderung als "Randkapazität" meßbar, die in Reihe mit der dicken Flüssigkeitsstrecke liegt. Stellt diese selbst eine Kapazität dar (dielektrische Flüssigkeit), so ist der Zusatz zu gering, um meßbar zu sein, d.h. die Anforderungen an die geometrische Präzision der Kondensatorverstellung sind zu hoch. Ist die Flüssigkeitsschicht ein Widerstand (verdünnter Elektrolyt), dann kann die Randkapazität aber aus dem Phasenwinkel noch im gesamten Tonfrequenzbereich leicht bestimmt werden und hat für Elektrolyte eine quantitativ erfolgreiche Prüfung der Theorie geliefert. Wenn Feldfrequenzen gegenüber der Relaxationszeit, mit der sich die neue Gestalt der Grenzschicht einstellt, hoch ist, spielen nur noch Reibungskräfte der Träger eine Rolle, sie wirken wie ein Ohmscher Leitwert, der zur Kapazität des die Randschicht erfüllenden Dielektrikums parallel liegt. Dieser Leitwert entzieht sich bei Elektrolyten der Messung, wo er in Reihe mit einem viel zu hohen Widerstand liegt, dagegen muß er sich im trägerhaltigten Dielektrikum durch meβbare Phasenwinkel bemerkbar machen, sofern unsere Auffassung zutrifft. Kapazitives Verhalten von Elektrolytzellen und Ohmsche Verluste in Kondensatoren mit ladungsträgerhaltigen Isolierflüssigkeiten sind danach komplementere Ausdrücke für denselben Elektrodenprozeß, soweit sehr schwache Wechselfelder zur Anwendung kommen.

Um zu prüfen, welche Eigenschaften derartige Randschichten annehmen müssen, um mit den Versuchsergebnissen in Übereinstimmung gebracht werden zu können, idealisieren wir die unhomogene Verteilung durch drei homogene Schichten (Abb. 1). Die Randschicht d_1 mit dem Phasenwinkel φ_1 und die verlustfreie Hauptschicht $d_0 \gg d_1$ mit den festen Flächenkapazitäten C_1 und C_0 .

Der Verlustfaktor des gesamten Kondensators is dann

$$\label{eq:delta_def} \operatorname{tg} \delta = \frac{\sin \varphi_1 \cos \varphi_1}{C_1\!/C_0 + \sin^2 \varphi_1}$$

Das zusammengefaßte Ergebnis unserer Versuchs reihen läßt sich durch

$$\operatorname{tg} \delta = y \omega \, 2 \, d \cdot y = 60 \dots 140 \cdot 10^{-6} \operatorname{sec/em}$$

darstellen und ist wenig abhängig von der Flüssigkei ihrer Zähigkeit und der Temperatur. Bei 4000 Hz un 2d=0,3 cm Abstand nimmt der Verlustfaktor scho hohe Werte (>1) an, während er bei 50 Hz und kleiner Abstand die geläufigen stark temperaturabhängige niedrigen Werte $(0,001\dots0,01)$ aufweist.

Der Frequenzgang kommt im Modell zustande, wen die Randschichten frequenunzabhängige Wirkwider stände besitzen. Ihre Impedanzen müssen also unte Umständen beträchtlich hohe Werte, vergleichbar mider ganzen Kondensatorstrecke, annehmen $(C_1/C_0$ b. 0,2). Diese Wirkwiderstände müssen proportional de Kondensatorstrecke d wachsen.

Wenn man für die Randschichten etwa alle Träge zur Verfügung stellen will, die im Kondensatorvolt men enthalten sind, kann man zwar die Dickenabhär gigkeit ziemlich leicht deuten. Hingegen ist der no wendige hohe Wirkwiderstandsbetrag mit dieser kle nen Trägermenge niemals zu erreichen:

Im Gegenteil, beim Zusammenschieben aller Triger in dünne Schichten, wird der Wirkwiderstand de Kondensators verringert, wenn man lediglich die quas stationäre Leitfähigkeit betrachtet. Eine unhomoger Schicht hat bei gleicher Gesamtträgerzahl einen kleneren Wirkwiderstand als die homogene, anders brichtstationärer. Die Durchführung dieses Programm am Schluß der Arbeit zeigt:

- Daß in derartigen Anreicherungsschichten Tragerschwingungen möglich sind, die wie ein Sperkreis hohe elektrische Wechselspannung fast ohr Stromdurchgang aufnehmen können.
- 2. Daß zur Ausbildung solche Randschichten m ganz mäßige Kontaktpotentiale zwischen Flüssigke und Elektrode — wie bei Elektrolyten — genügen. I diese Verteilungen asymptotisch in das Innere de Kondensators weiterlaufen, ergibt sich zwanglos ein Abhängigkeit von der Kondensatordicke.

2. Versuchsanordnung

Die abgeschirmte Schering-Brücke wurde vorwigend mit einem Kathodenstrahloszillographen abg glichen [6]. Die Ankopplung des Verstärkers erfolg über einen hochgradig magnetisch abgeschirmten Tran formator. Die Vergleichskondensatoren waren "Mino flaschen" von Schott, der Präzisionsmeßkondensato (Abb. 2) hat Schutzringabschirmung, vergoldete Obe flächen und konnte innerhalb eines luftdichten, metens evakuierten Rezipienten mit Trockenmittel waußen im Abstand verändert werden. Vor jeder Filung wurde der Kondensator im Vakuum ausgeheiz

Mit Rücksicht auf andere zu erwartende Obe flächeneffekte wurden fallweise dielektrische Zw schenschichten bzw. dielektrische Abdeckungen d Kondensatorplatten aus Glimmer oder des in d Hochspannungstechnik bewährten Kondensatorp piers verwendet, die vor der Füllung ebenfalls i Vakuum des Kondensators sorgfältig getrocknet ware Als Dielektrika wurden benutzt:

- Ein Druckkabelöl, das von Felten und Guilume zur Verfügung gestellt war (Öl 1).
- 2. Ein Kabeltränköl von Shell K20 (Öl 2, 2a).
- 3. Ein helles leichtflüssiges Druckkabelöl Shell K 8 3) und
- 4. Tetrachlorkohlenstoff p.a. von Riedel de Haen.

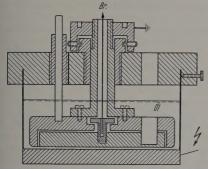


Abb. 2. Verstellbarer Schutzringkondensator (Maßstab 1:2)

Bei Öl 1 hatte eine besondere Nachtrocknung mit hgradig getrocknetem Stickstoff bei ~2 Torr einen rissen Einfluß auf das dielektrische Verhalten. Bei

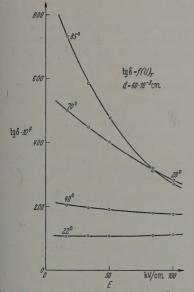


Abb. 3. Feldabhängiger Verlustfaktor bei 50 Hz. (Öl 1 vor dem Nachtrocknen)

anderen Stoffen wurden dabei keine Veränderungen erkt. Abb. 3 zeigt die Abhängigkeit des Verlustors von der Feldamplitude von Öl 1 vor der knung. Abb. 4 zeigt den Wirkstromanteil im ckenzweig, der — wie bei Liebscher — durch leichen der Widerstände der Brücke, aber ohne senabgleichkondensator erhalten wurde. Durch male Löschung dieses Wirkstroms mit dem letzn wurden dann die Meßpunkte erhalten. Da mit Brücke nur die Grundwelle abgeglichen werden 1, liefert dieser Abgleich einen äußerst empfinden Nachweis nichtlinearer Vorgänge. Das Bild tangew. Physik. Bd. 13



Abb. 4. Wirkstrom zum Meßpunkt 28* Abb. 3

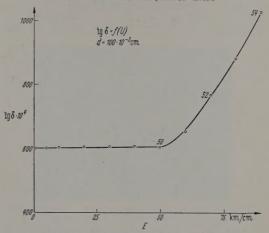
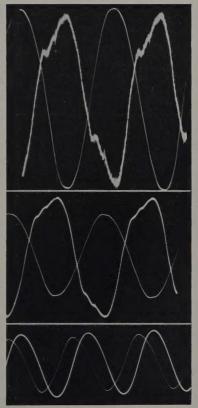


Abb. 5. Ionisationsknick in Tetrachlorkohlenstoff bei 50 Hz



. Abb. 6. Wirkstromanteile zu den Meßpunkten 50, 52, 54 von Abb. 5

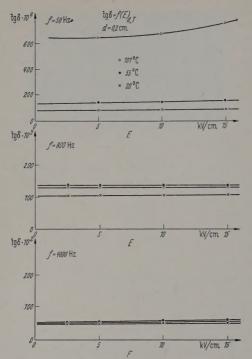


Abb. 7. Unabhängigkeit des Verlustfaktors von der Feldamplitude bei hinreichend kleinen Feldern (Öl 2). Ermittlung des Grenzwertes für die Amplitude Null

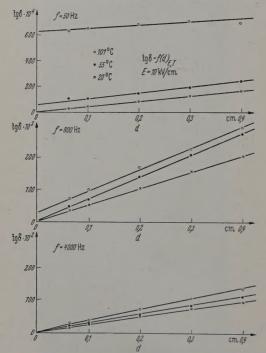


Abb. 8. Abhängigkeit des Verlustfaktors vom Plattenabstand bei fester Feldamplitude 10 kVeff/cm in Öl $2.\,$ Extrapolation des Verlustfaktors auf den Abstand Null "Volumen-Verlustfaktor"

zeigt schon ohne Abgleichen des Wirkstroms deutliche "Ionenstromspitzen", daneben ist der Gesamt-

strom durch die Brücke, abgezweigt von einem kleinen Shunt vor dem Erdungspunkt der Brücke, zu sehen. Nach der Reinigung zeigte der Verlustfaktor — wie normal — z.B. auch bei den anderen Ölen (vgl. Abb. 7) nur eine ganz schwache Steigung mit wachsender Spannung. Abb. 5 zeigt den entsprechen den Gangan Tetrachlorkohlenstoff mit einem scharfen Ionisationsknick. Abb. 6 zeigt die Wirkstromoszillogramme an den bezeichneten Meßpunkten 50, 52, 54

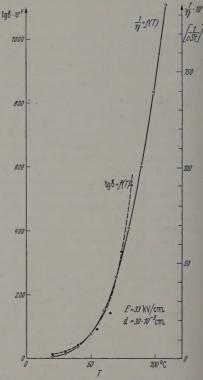


Abb. 9. Temperaturgang des Volumenverlustfaktors und der reziproker Zähigkeit von Öl $2\,$ bei $50\;\mathrm{Hz}$

Unser Problem befaßt sich mit Verlusten bei mölichst niedriger Spannung, unter sieherer Vermeidur aller nichtlinearen Effekte. Deshalb mußten die Einsatzpunkte derartiger Vorgänge sichergestellt werder und der Leser von der Abwesenheit derselben iden nachfolgend mitgeteilten Messungen überzeu werden.

Abb. 7 zeigt für Öl 2 die nahezu fehlende Spal nungsabhängigkeit. Gleichzeitig überzeugt man sic daß der Grenzwert für kleine Spannungen erreicht is Zahlreiche Oszillogramme der Wirkströme lassen nich die geringsten Verzerrungen erkennen.

Abb. 8 zeigt für Öl 2 bei fester Feldamplitude von 10 k $V_{\rm eff}$ /cm — aber sicher im Bereich des endgültige Grenzwertes für kleine Spannungen — die Abhängikeit vom Plattenabstand bei den Frequenzen 5 800 und 4000 Hz bei drei Temperaturen.

Der Verlustfaktor wächst in allen Fällen *linear n* dem Plattenabstand.

Wir betrachten zunächst die Messungen bei 50 H Hier hängt der Anstieg nicht wesentlich von d Temperatur ab. Hingegen wächst der auf den Abstaıll extrapolierte Verlustfaktor exponentiell mit der mperatur nahezu umgekehrt proportional zur Vissität (Abb. 9). Das legt die Annahme nahe, daß es h hierbei um den "normalen" dielektrischen Verlust Ölvolumen durch Ladungsträger handelt, deren Beglichkeit durch die Flüssigkeitsreibung bestimmt ist.

Abb. 10 zeigt den Einfluß einer elektrophoretischen dungsträgerabscheidung durch Anlegen einer hohen eichspannung von 10 kV/cm während einer Dauer a 2 Std. Die oberste Kurve ist vor der Abscheidung nessen, die unterste bei gleichzeitigem Anliegen von eich- und Wechselspannung. Dies wurde durch e Einweg-Ventilschaltung ohne Glättung erreicht. mittlere Kurve ist mit Wechselstrom kurz nach schalten der Gleichspannung gemessen. Die Abeidung betrifft nur den auf Abstand Null extraierten Verlustfaktor, der durch das Anlegen der eichspannung drastisch herabgesetzt wird. Nach schalten der Gleichspannung bleibt die Trägerhte noch längere Zeit (24 Std) stark vermindert. r elektrophoretische Effekt zeigt, daß es sich um Llungsträger, nicht um Dipole oder Wagnersche homogenitäten und ähnliches handelt. Die bei die-Versuch gemessene Dauer-Gleichstromleitfähig- $\sigma \sim 10^{-11} \, \text{S/m}$ liefert einen Verlustfaktor

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{\sigma}{\omega \cdot \varepsilon} \sim 10^{-3}$$

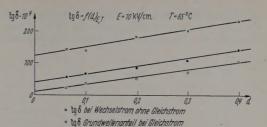
di größenordnungsmäßig mit dem gemessenen Grenzwt für den Abstand Null übereinstimmt. Der Ustand, daß gerade dieser von Ladungsträgern herfirt, spricht wieder dafür, daß es sich dabei um de "normalen" dielektrischen Verlust im Ölvolumen hadelt.

Der von der Dicke der Ölschicht abhängige Teil Verlustfaktors, wird von der elektrophoretischen gerverminderung im Ölvolumen nicht betroffen. Derreicht deshalb (nach der Minderung) ein Vielfaches (schsmal) des durch Trägerverminderung herabgesetzt, "normalen" Verlustfaktors.

Noch viel ausgeprägter wird der Einfluß des Ettenabstandes bei höheren Frequenzen: Der dickenstängige Anteil wächst proportional mit der Frequenz, während der auf Null extrapolierte etwa verkert mit der Frequenz abnimmt. Letzteres steht wier mit einer Entstehung durch bewegliche Ladigsträger im Volumen im Einklang. Dadurch tritter ber bei höheren Frequenzen gegenüber dem dickenstängigen Teil — den wir Oberflächeneffekten zusteiben — völlig zurück. Der überhöhte "Oberflächeneffekt" zeigt nunmehr auch eine schwache Temperstrabhängigkeit, aber höchstens eine lineare mit Twieswegs eine der Zähigkeit verkehrt proportionale wieder "Volumeneffekt" (Abb. 7, 8). Alle mitgeteil-Temperaturgänge waren reversibel.

Das Oszillogramm (Abb. 11) bei Öl 3 zeigt, daß der Wisstrom der diesem dickenproportionalen Verluststor entspricht, nicht die geringsten Nicht-Linearitäterkennen läßt, es entspricht dem größten Abstand m) bei $10 \, \mathrm{kV_{eff}}$ cm und $4000 \, \mathrm{Hz}$. Der Verluststor erreicht dabei einen Wert von $\mathrm{tg} \, \delta \sim 1!$

Die folgenden Versuche haben den Zweck, den Erluß der Elektrodenfläche festzustellen, der bei in Oberflächeneffekt naheliegend wäre. Abb. 12 (1) zeigt die Abdeckung der vergoldeten Kondenreplatten (einschließlich Schutzring) durch dünne



• \u00e4\u00e9 bei Wechselstrom nach \u00e4leichstrom
Abb. 10. Verlustktor bei der gleichzeitigen Einwirkung eines Gleichfeldes von 10 kV/cm und 2 8td nach der Einwirkung. Zum Vergleich der Verlustfaktor vor der "elektrophoretischen" Reinigung durch das Gleichfeld

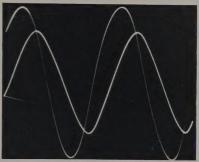


Abb. 11. Wirkstrom bei 4000 Hz und 10 kV $_{\rm eff}$ /cm Feldamplitude in Öl 3. 85° C 4 mm Plattenabstand wobei der dickenabhängige Anteil des Verlustfaktors "Oberflächenanteil" smal größer als der Volumenanteil ist. Der gesamte Verlustfaktor hat dabei den enormen Wert 1,02 ohne die geringste Nichtlinearität!

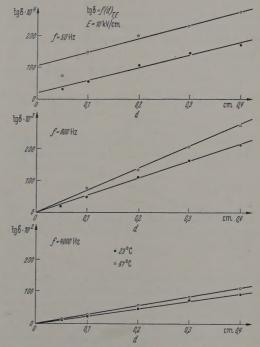


Abb. 12. Abdeckung der Kondensatorplatten mit dünnen Kaliglimmerplatten (Öl 2) keine Änderung gegenüber Abb. 8

Kaliglimmerplatten. Es hat sich gegenüber den blanken Platten nichts geändert.

Nunmehr wurde das Kondensatorvolumen durch eine dünne Glimmerplatte halbiert, die außerhalb des Kondensatorfeldes mit Federn aus Glimmer so gegen die zwei Platten abgestützt wurde, daß sie auch beim Verstellen des Plattenabstandes diesen stets halbiert.

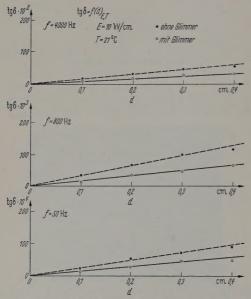


Abb. 13. Wirkung einer weiteren Glimmerplatte in der Mitte der Ölschicht parallel zu den Elektroden: Halbierung des Verlustfaktors gegenüber dem gleichen Zustand ohne Zwischenschicht

Abb. 13 zeigt den Verlustfaktor mit und ohne Halbierung. Letzterer setzt ihn beinahe auf die *Hälfte* herab. Das war nach dem Vorhergehenden zu erwarten.

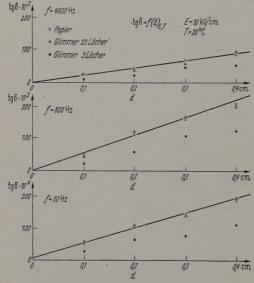


Abb. 14. Herabsetzung der Wirkung der Trennschicht von Abb. 13 durch Perforierung

Während aber vorher dazu der Plattenabstand und die Spannung halbiert wurde (Feldstärke konstant) bleibt nun all dies ungeändert und der Verlustfaktor war trotzdem halbiert, entsprechend der halbierten Ölschichtdicke, denn zwei Kondensatoren (Ölstrecken) in Reihe haben natürlich den gleichen Verlustfakto wie einer.

Nunmehr wurde die Glimmerplatte perforiert Abb. 14 (Öl 2) drei Löcher von 2,5 mm Ø von insgesam etwa 59 mm² Fläche verglichen mit einer Gesamtfläch von etwa 5030 mm² bewirken gerade schon ein merkliche Erhöhung des Verlustfaktors gegenüber de ganzen Glimmerplatte. 23 Löcher des gleichen Durch messers von insgesamt etwa 450 mm² Fläche hebe ihre Wirkung fast völlig auf, man mißt fast den Verlustfaktor der dem Metallplattenabstand ohne Glimmer entspricht. Hier muß bemerkt werden, da Zwischenlagen von einer oder mehreren Schichte aus Kondensatorpapier, das sorgfältigst im Vakuun getrocknet und getränkt wurde gar keinen Einflugauf den Verlustfaktor haben, sie wirken nicht al Trennschicht.

Randschichten sind mit einem - etwa kontakt potentialbedingten – Feld zwischen Oberfläch und Trägerraumladungsschicht verbunden. Die Feld energie sinkt mit der Zahl der Schichten, selbs dann, wenn diese dicker werden. Sobald die Trenn fläche perforiert wird besteht die Möglichkeit de Trägeraustausches zwischen den beiden Seiten und de Abbaues der Trägerschichten auf der Zwischenschicht Dazu ist allerdings nötig zu beachten, daß die stark mi Trägern angereicherte Oberflächenschicht den Trägen ("Gleit-ionen") parallel zur Oberfläche eine viel grö ßere Beweglichkeit verleiht, weil sich die ganze Flüssig keitsschicht mit den Trägern teilweise mitbewege kann, als senkrecht dazu. Die letzteren Bewegunge relativ zur Flüssigkeit sind für die Randschichtver luste maßgebend.

Die Gleitionenschicht wirkt aber wie eine gut lettende Oberflächenschicht, die durch die Perforations löcher auf die andere Seite der Trennschicht leich hindurchtreten kann, so daß der Strom die beide Randschichten kurzschließt. Dadurch beeinflußt di Zwischenschicht, wenn sie symmetrisch liegt, das Fel im Kondensator überhaupt nicht mehr.

In der Abb. 15 sind sämtliche Meßergebnisse zu sammengefaßt. Jeder Punkt entspricht einer Meßreih mit veränderlichem Plattenabstand und gibt die Ne gung $y\omega$ der Geraden tg $\delta = \text{tg } \delta_0 + y\omega d$ geteilt durc die Meßfrequenz ω an. Trotz des zwei Größenore nungen umfassenden Bereichs von Zähigkeit un Temperatur sowie Frequenz ergeben sich nur weni unterschiedliche Werte von y = 60 bis $149 \cdot 10^{-6}$ em/sei Die gewählte Abszisse ωd ist unwesentlich, da sich kei erkennbarer Gang zeigt. Ihr Produkt mit der Ordinat gibt das unmittelbare Meßergebnis. Neben dem lines ren Gang mit dem Plattenabstand ist das auffallendst Ergebnis die Unabhängigkeit von der reziproke Zähigkeit. Wenn bei gegebenen Strom durch den Kor densator — wie im verlustbehafteten Dielektrikum das Feld (fast) nicht von der Leitfähigkeit abhäng muß bei jeder Art von Träger oder Dipolbewegung de Verlustfaktor linear mit der Trägerbeweglichke wachsen. Ist das nicht der Fall, so muß es Stelle geben, an denen das Feld mit wachsender Beweglich keit abnimmt.

3. Das dielektrische Verhalten von Anreicherungsrandschichten

Eine Anreicherungsrandschicht entsteht, sobal der Ladungsaustritt aus der Elektrode, allenfalls at m Umweg des Ladungsaustausches, mit Energiegabe verbunden ist. Im Gleichgewichtsfall bildet
h dann eine Doppelschicht vor der Elektrode aus,
ren elektrisches Feld beim weiteren Durchgang des
dungsträgers einen gleich großen Energieverbrauch
ordert. In dieser Schicht halten sich Driftstrom
r Elektrode im Feld und Diffusionsstrom weg von

r Elektrode das Gleichgecht. Die Gegenladungen zen in der Oberfläche r Elektroden. Die Spanng an der ganzen Schicht lät nach Helmholtz biffusionsspannung".

Das Ziel dieses Abmitts ist nicht eine erlöpfende Diskussion der den Möglichkeiten, die besonders eintreten, m man mehrere Trägeren verschiedener Bewegikeit und Ladung beeksichtigt.

Es soll vielmehr an dem nkbar einfachsten Beiel (eine Trägerart ohne genladung) aufgezeigt rden, daß derartige ndschichten in niederd tonfrequenten elektriem Wechselfeld frenzunabhängige Wirklerstände der Größenord $ng~10^9~\Omega\cdot {
m cm^2}~{
m für}~1~{
m cm^2}$ ktrodenoberfläche anmen können, die für die utung der Versuche erderlich sind, ohne daß reme oder künstliche nahmen über die Trädichte, Beweglichkeit Idie Diffusionsspannung

nacht werden müssen. Es wird sich zeigen, daß ehr stark von der Randfeldstärke an der Elektrode l auf diese Weise auch von dem Kondensatorplatabstand abhängt.

Die Dichte I des Gesamtstromes, gleichbedeutend der magnetischen Wirbeldichte, ist für alle Quernitte des Kondensators gleich, also unabhängig der Längskoordinate x

$$\begin{split} I &= \varepsilon \, \frac{\partial E}{\partial t} + \varrho \, v - D \, \frac{\partial \varrho}{\partial x}, \\ v &= b \, E, \\ \varrho &= \varepsilon \, \frac{\partial E}{\partial x}, \\ D &= \frac{kT}{\varepsilon} \, b. \end{split}$$

t die Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger im el, ϱ ihre Raumladung. Wir zerlegen in eine staäre Lösung, I_0 , E_0 , ϱ_0 , v_0 und eine periodische E_1 , ϱ_1 , v_1 mit

$$I_1 = \bar{I} \exp\left(i \,\omega \,t\right)$$

. Es soll eine reine Wechselspannung am Konsator liegen $I_0\!=\!0$. Dann stellt der stationäre .f. angew. Physik. Bd. 13

Teil das thermische Gleichgewicht der Randschicht dar

$$O = \varrho_0 \, v_0 - D \, \frac{\partial \varrho_0}{\partial x} \,, \tag{1}$$

$$I_{1} = \varepsilon \frac{\partial E_{1}}{\partial t} + \varrho_{1} v_{0} + \varrho_{0} v_{1} - D \frac{\partial \varrho_{1}}{\partial x} + \varrho_{1} v_{1}$$
 (2)

unabhängig von x.

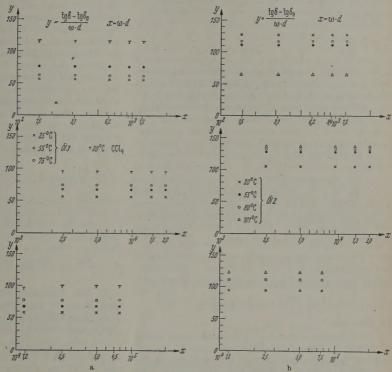


Abb. 15 a u. b. Zusammenfassung aller Meßergebuisse. Anstieg des "Oberflächenanteils" des Verlustfaktors mit der Dicke d (in mm) reduziert auf die Kreisfrequenz $\omega=1$ mit

$$y = \frac{\operatorname{tg} \delta_d - \operatorname{tg} \delta_0}{\omega \cdot d}$$

Aus (1) folgt mit der Bedingung, daß die Randfelder auf beiden Seiten entgegengerichtet und gleich groß sind

$$E = C \operatorname{tg} \frac{C}{2 \mathfrak{v}} x, \quad \mathfrak{v} = \frac{kT}{e}, \quad \alpha = \frac{C}{2 \mathfrak{v}} d.$$

Die Diffusionsspannung $U_0=-2$ t l
n cos α , die gesamte Trägerzahl q über der Flächene
inheit des Kondensators $2\,\varepsilon\,E(d)$ und die mittlere Trägerdichte im Kondensator

$$\bar{\varrho} = \frac{\varepsilon E(d)}{d}$$

sind allein durch die Randfeldstärke bestimmt. In Unkenntnis der Randbedingungen für die Trägerdichte oder Strömung brauchen wir Annahmen darüber, welche Größe beim Ändern des Kondensatorplattenabstandes 2d ungeändert bleibt:

- a) die Diffusionsspannung,
- b) die gesamte Trägerzahl,
- c) die mittlere Trägerdichte,

welche auch vor Einfüllen der Flüssigkeit in den Kondensator bestanden hat. Keine der Annahmen ist zwingend. Ein Teil des Spannungsabfalles kann bei kleinem Plattenabstand außerhalb des Plattenrandes liegen. Es können beim Ändern des Abstandes Träger über den Plattenrand austreten, obwohl sie größtenteils durch die Randschicht gebunden sind, wodurch b) und c) unsicher werden. Die drei Annahmen liefern für die Randfeldstärke E(d)

a')
$$\left(\frac{\pi}{2}\exp\frac{v_0}{2\mathfrak{v}}-1\right)\frac{2\mathfrak{v}}{d}$$
,

b')
$$\frac{q}{\varepsilon}$$
,

c')
$$\frac{d\overline{\varrho}}{\varepsilon}$$
.

In den Fällen b') und c') ist die Diffusionsspannung auch nur sehr wenig mit dem Abstand veränderlich. Die Annahmen a') und c') dürfen die äußersten Grenzen des Einflusses vom Plattenabstand auf die Randfeldstärke darstellen, aber diese liegen so weit auseinander, etwa 1/d bzw. etwa d, daß kaum eine theoretische Vorhersage möglich ist, aber auch kaum an einem Einfluß des Plattenabstandes auf die Randfeldstärke gezweifelt werden kann. In unserem Beispiel hängt die Randfeldstärke nicht von der Beweglichkeit, die, wie die reziproke Zähigkeit exponentiell mit der Temperatur wächst, ab. Das ändert sich sofort, sobald zwei Trägerarten verschiedener Beweglichkeit und Ladung bestehen. Für die weitere Behandlung brauchen wir noch die Randdichte

$$\varrho\left(d\right)=E^{2}(d)\,rac{arepsilon}{2\,\mathrm{n}}$$

und es ist bequem eine Randschichtdicke ⊿ durch

$$\frac{1}{\Delta} \equiv \left(\frac{dE}{dx}\right)_d / E(d) = E(d)/2v$$

zu definieren

Wir betrachten nun den nichtstationären Zustand (2). Der letzte Summand ist nichtlinear und für die irreversible Wärmeproduktion des Wechselfeldes in der Randschicht allein maßgebend. Die ersten vier linearen Glieder dagegen bestimmen in erster linearer Näherung (') das dielektrische Verhalten der Randschicht. Dem Sinne nach sind sie alle Funktionen von x, der Gesamtstrom I_1 aber nicht, deshalb mußer im Rahmen dieser Näherung verschwinden.

$$I_1' - \varrho_1' v_1' = 0.$$

Solange wir die Stromwärme im Wechselfeld der Randschicht vernachlässigen, kann eine beliebig hohe Wechselspannung

 $U_1 = \int_0^d E_1 dx$

an ihr liegen, ohne daß ein Wechselstrom fließt, ähnlich einem verlustlosen Sperrkreis oder einer in der Resonanzfrequenz erregten Plasmaschicht. Hier tritt die entgegengesetzte Phasenlage von Driftstrom $\varrho_0 \ v_1$ und Verschiebungsstrom $\varepsilon \frac{\partial E}{\partial t}$ durch die Massenträgheit ein, in unserem Fall durch die Trägerdichteschwankungen ϱ_1 im stationären Driftstrom v_0 . Die Trägheit der Ladungsträger ist in unserem Frequenzbereich völlig zu vernachlässigen.

Die Energiebilanz erhält man nach dem Poyntingschen Verfahren durch Multiplikation von (1) und von (2) mit $E=E_0+E_1$. Dabei liefert der gesamte Konvektionsstrom (Drift+Diffusionsstrom) $\varrho v-D\,\frac{\partial\,\varrho}{\partial\,x}$ die

elektromagnetische Leistung, die, mit dem äußerer Stromkreis des Kondensators bei konstantem Feld in demselben, mit seiner Feldenergie bei Stromlosigkeit ausgetauscht wird.

Der erste Näherungsschritt würde $I'_1 = \varrho'_1 v'_1$ liefem Es interessieren aber nur Lösungen in der Grundfrequenz. Daher ist ein nächster Schritt nötig mi einem Zusatzglied $I''_1 = \overline{I}''_1 \exp i \omega t$. Der Einfach heit halber behandeln wir den Fall des Energieaus tausches mit der Feldenergie im Kondensator alse verschwindendem Gesamtstrom $I'_1 + I''_1 = 0$. Das hazur Folge, daß in anderen Fällen nur der Energie umsatz in der ganzen Schicht für die Berechnung de Wirkstromes I''_1 benutzt werden kann. Es interessier nur der Grenzwert für unendlich kleine Amplitude auf dessen Ermittlung die ganze experimentelle Unter suchung eingestellt war. Dann entfallen kubische Glieder in den periodischen Größen. Bei der Auf stellung der Wirkstromkomponente kann endlich die Feldenergie weggelassen werden

$$\begin{split} I_1^{\prime\prime} \cdot \int\limits_0^d E_1 \, dx &= -\int\limits_0^d \left(\varrho_1^{\prime\prime} \, v_0 - \varrho_0 \, v_1^{\prime\prime} - D \, \frac{\partial \varrho^{\prime\prime}}{\partial \, x}\right) E_1^\prime \, dx \\ &= \int\limits_0^d \varrho_1 \, v_1 \, E_0 \, dx \end{split}$$

mit

$$U_1 = \int\limits_0^d E_1 \, dx = \overline{U}_1 \exp i \, \omega \, t \, , \quad \varrho_1 = \varepsilon \, \frac{\partial E_1}{\partial \, x} \, , \quad v_1 \, E_0 = E_1 v \, . \label{eq:power_sol}$$

und dem Umstand, daß die Wirkkomponente de Feldstärke in der Mitte des Kondensators größen ordnungsmäßig kleiner als am Rand ist. $E_1(0) =$ bleibt nach zeitlicher Mittelbildung über eine Period

$$N \equiv \frac{1}{2} \, \bar{I}_1^{\prime\prime} \, \bar{U}_1 \! = \varepsilon \, \frac{v_0}{4} \, \bar{E}_1^2(d) \, . \label{eq:N}$$

Die Stromwärme in der Randschicht ist durch di Randfeldstärkenamplitude und die Driftgeschwindig keit im Feld der stationären Doppelschicht allei bestimmt:

Wir benötigen eine Beziehung zwischen den Beträgen der Wechselspannung an der ganzen Randschicht \overline{U}_1 und der Randfeldstärke \overline{E}_1 welche eine Lösung von (2) zu entnehmen ist. Es genügt di lineare erste Näherung. Die Integration über die Randschicht liefert formal jedenfalls eine Beziehung \overline{U}_1 = $KE_1(d)$. Damit wird der Wirkwiderstand der Randschicht Δ

$$R=rac{\overline{U_1^2}/2}{N}=rac{2}{arepsilon\,v_0\,K^2}\,.$$

Der Blindwiderstand des restlichen, fast verlust freien Dielektrikums ist

$$X = \frac{d - \Delta}{\omega \varepsilon}$$
.

arDelta ist aber gegen d ganz zu vernachlässigen. Der $\mathbb V^{\mathrm{gr}}$ lustfaktor des gesamten Kondensators ist endlich

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{2\omega}{v_0 K^2 d} \,. \tag{2}$$

Es handelt sich bei der Lösung von (2) um eine Well in einem unhomogenen Medium, dessen Materialkor stanten $\varrho_0(x)$, $v_0(x)$ etwa mit eine Relaxationstiefe.

m Rand auf Null abfallen. Wir versuchen aber nächst, die Schicht durch ein homogenes Medium, $(d), v_0(d)$ von der ungefähren Dicke Δ zu idealisieren. er Ansatz

$$E_1' = \exp i(\omega t - k x)$$

(2) gibt mit

$$M = \frac{4D\omega}{v_0^2} (i + \operatorname{tg} \beta)$$
 ,

bei

$$tg\beta \equiv \frac{\varrho_0 b}{\varepsilon \omega}$$

r Verlustfaktor des Randschichtmaterials ist, für

$$\begin{split} M < 1 & \quad k_1 = \mathfrak{i} \left(\frac{v_0}{D} + \frac{\omega}{v_0} \operatorname{tg} \beta \right) - \frac{\omega}{v_0} \\ & \quad k_2 = -\mathfrak{i} \frac{\omega}{v_0} \operatorname{tg} \beta + \frac{\omega}{v_0} \\ M > 1 & \quad k_3 = \mathfrak{i} \left(\sqrt{\frac{\omega}{D}} \operatorname{tg} \beta + \frac{v_0}{2D} \right) - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega}{D}} \operatorname{tg} \beta \end{split}$$

und (2) stellen die Verschleppung eines periodisch gebenen Randzustandes durch den Driftstrom v_0 r "Driftwellen". (1) läuft mit dem Driftstrom und rd lediglich durch die Stromwärme gedämpft. läuft gegen den Driftstrom mit einer so hohen impfung, daß die Relaxationsstrecke

$$\delta = \frac{D}{v_{\rm o}} = \frac{\mathfrak{v}}{E_{\rm o}(d)}$$

el kleiner als die Wellenlänge $\lambda = v_0/\nu$ ist. Es han-It sich also fast um eine quasistationäre Schwingung s elektrodennahen Teiles $\delta < \Delta$ der Randschicht. und (4) sind modifizierte Diffusionswellen (Skinekt). Sie können unter unseren Versuchsbedingunn nur bei den höchsten Frequenzen auftreten. Ihre ndringtiefe ist dann noch kleiner als bei (2). Da auf r einen Seite die Elektrode, auf der anderen das clustfreie Dielektrikum an die homogene Schicht nzt, können, solange die Grenzbedingungen für 1 Teilchenstrom nicht geklärt sind, Wellen von den Seiten in die Schicht eindringend angenommen rden. Wahrscheinlicher aber sind Wellen von der ektrode weg, also in unserem Frequenzbereich nur Ihre Relaxationsstrecke $\delta = \Delta/2$ ist kleiner als wirksame Randschichtdicke △ daher ist die homone Schicht eine brauchbare Näherung daraus folgt $=E_{\mathfrak{o}}(d)/\mathfrak{v}$

$$\operatorname{tg} \delta_{1} = \frac{2\omega \, \mathfrak{v}^{2}}{b \, E^{3}(d) \, d} \,. \tag{3a}$$

bllenlänge λ und Eindringtiefe der umgekehrt lauden Welle (1) sind viel größer als die Randschicht Δ , Lösung wird auch quasistationär. Hier genügt ar die homogene Schicht nicht als Näherung, aber n kann annehmen, daß die Lösung der unhomogenen eichung im wesentlichen wieder eine quasistationäre iwingung ist, nur mit dem Unterschied, daß die aze Randschicht mitschwingt und etwa $K=1/\Delta$ zu zen ist, dann folgt:

$$tg \, \delta_2 = 4 \, tg \, \delta_1. \tag{3b}$$

beiden Diffusionswellen dringen noch weniger Randschicht ein als (1). Unter Verwendung des Ausdrucks für die Randdichte wird genähert

$$tg_{3,4} = \frac{8 v^2 \omega^2}{b^2 E^5(d) d}$$
 (3c)

Die Abhängigkeit des Verlustfaktors von dem Kondensatorplattenabstand 2d und der Temperatur wird im wesentlichen durch die hohe Potenz der Randfeldstärke vermittelt. In unserem vereinfachten Beispiel (vgl. S. 8) ist die Randfeldstärke proportional d^{-1} , d^{+1} , d^{0} , wenn entweder Diffusionsspannung U_{0} oder die Anfangsträgerdichte der Füllung $\bar{\varrho}$ oder Gesamtträgerinhalt des Kondensators q unabhängig von d ist, Temperaturabhängigkeit fehlt und bleibt deshalb im Verlustfaktor bestehen.

Der Fall konstanten Diffusionspotentials und das Auftreten von Driftwellen liegt im Gang von Frequenz und Plattenabstand dem Versuchsergebnis am nächsten:

$$\mathrm{tg} \; \delta_1 = \frac{1}{4 \, b \; \mathfrak{v}} \; \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2} \exp \frac{v_0}{2 \, \mathfrak{v}} - 1\right)^3} \, \omega \, d^2.$$
 (3d)

Durch geringfügige Änderungen in der Annahme über die Ausbildung der Randschicht kann man die Potenz von d stark beeinflussen, also ist die diesbezügliche Übereinstimmung mit dem Versuch für den Anfang genügend.

Die Beweglichkeit von elektrolytischen Ionen in einer Flüssigkeit von 1000 c St die unserem Öl entspricht, kann auf $5\cdot 10^{-4}~{\rm cm}^2/{\rm V}\cdot{\rm sec}$ geschätzt werden. Das Versuchsergebnis für tg δ/ω 2d liegt bei 10^{-5} sec pro cm.

Nach (3a) ist hierfür eine Randfeldstärke E(d)

148 V/cm bei 4 mm

370 V/cm bei 1 mm

Plattenabstand erforderlich. Die zugehörigen Diffusionspotentiale sind nach $(3\,\mathrm{d})$

$$U_0 = 0.30 \text{ V}$$

 $U_0 = 0.275 \text{ V}$.

Dieser Wert entspricht durchaus den im Elektrolyten beobachteten Randschichten. Die Randdichte berechnet sich für einfach geladene Ionen zu

$$n(d) = 0.53 \cdot 10^{12} \, \text{cm}^{-3}$$

in der Mitte des Kondensators verbleiben nur

$$n(0) = 0.38 \cdot 10^{7} \, \mathrm{cm}^{-3}$$

die mittlere Trägerdichte vor Ausbildung der Randschicht ist

$$ar{n} = rac{1}{d} \int\limits_0^d n \, dx = 0.93 \cdot 10^9 \; \mathrm{cm}^{-3}.$$

Die Gleichstromleitfähigkeit bei $10~\rm kV_{eff}/cm$ war in einem konkreten Fall $10^{-13}~\Omega^{-1}~\rm cm^{-1}$, daraus ergibt sich *mit dem obigen* Schätzwert der Beweglichkeit $n=1,25\cdot 10^9~\rm cm^{-3}$. Die Übereinstimmung ist wohl Zufall, zeigt aber, daß es nicht abwegig ist, anzunehmen, daß die für die Gleichstromleitfähigkeit maßgebenden Träger dieselben sind, welche die Randschicht aufbauen, und daß das extrem vereinfachte Randschichtmodell nicht unbrauchbar ist.

Wir haben nur den Grenzwert für kleine Wechselfelder betrachtet. Bei den Versuchen konnten mit Rücksicht auf die Empfindlichkeit 10 k $V_{\rm eff}$ /cm nicht wesentlich unterschritten werden. Der Verlustfaktor war aber bis zu fünf- oder zehnmal höheren Feldstärken noch ungeändert und der Verluststrom noch völlig sinusförmig. Der Schubweg der betrachteten elektrolytischen Ionen wäre bei $10~{\rm kV_{eff}/cm}$ Amplitude bei

50, 800, 4000 Hz

näherungsweise

 $3 \cdot 10^{-2}$, $2 \cdot 10^{-3}$, $4 \cdot 10^{-4}$ cm.

Die "Dicke" der Randschicht beträgt in unserem Beispiel $\Delta=3,4\cdot 10^{-4}$ cm. Obwohl nun vom experimentellen Standpunkt aus kaum ein Zweifel sein kann, daß sich bei noch kleineren Amplituden der

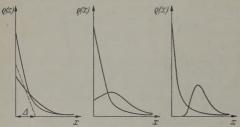


Abb. 16. Endlagen der Randdichteverteilung bei kleineren, mittleren und großen Schwingungsamplituden. (Qualitativ) ⊿ Randschichtdicke

Verlustfaktor nicht mehr ändert, also der Vergleich von Experiment und Theorie zulässig ist, muß ein Grund angegeben werden, weshalb die Ergebnisse der Theorie auch in einem Amplitudenbereich richtig bleiben, wo die verwendeten Näherungen ungültig sind.

Wir haben in einem konkreten Beispiel die numerische Integration der Differentialgleichung (2) für große Amplituden vorgenommen. Die Randbedingung war verschwindender Konvektionsstrom (Drift+Diffusionsstrom), d. h. keine Adsorption und kein Ladungsaustausch der Träger an der Wand. Es zeigt sich dabei, daß die ganze Randschicht von der Elektrode abgehoben wird und ungefähr den Schubweg zurücklegt, dabei nach beiden Seiten durch Diffusion und Raumladungsfeld etwas zerfließend (Abb. 16).

Nun haben wir schon einleitend bemerkt, daß die einfache Trägerbewegung im mittleren Kondensatorwechselfeld, ganz gleich, ob sie über den Kondensatorverteilt sind oder zu Randschichten gehäuft, nicht ausreicht, um die gemessenen hohen Verlustfaktoren zu begründen. Es bedarf dazu der örtlichen Feld-überhöhungen in den sperrkreisartig wirkenden Anreicherungsschichten. Nun ist es aber nicht wesentlich, daß sich diese am Rand befinden, sondern nur, daß sie bestehen, und das hat unser numerisches Beispiel gezeigt. Während der Dauer einer halben Schwingung werden sie durch Diffusion und Raumladungsfeld nicht aufgelöst.

Das Bestehen derartiger Anreicherungsschichten kann das dielektrische Verhalten von Flüssigkeiten einschneidend verändern. Es könnte aber auch die Deutung mancher nichtlinearer Erscheinungen, die bei großen Feldamplituden oder kolloidalen Verunreinigungen beobachtet werden, merklich ändern. Endlich könnten derartige Randschichten auch für den elektrischen Durchschlag von Flüssigkeiten Bedeutung haben, etwa indem sie als Teilstücke verschleppt, leitende Bahnen bilden mit Felderhöhung in restlichem Dielektrikum oder Wärmedurchschlag in der Bahn, endlich durch Labilität der Randschicht in starken Feldern. Unter Umständen muß auch der bekannte Einfluß isolierender Zwischenschichten auf den Durchschlag eine abgeänderte Deutung erfahren.

Zusammenfassung

Der dielektrische Verlustfaktor tg δ von sorgfältig getrockneten und luftfreien Isolierölen sowie Tetrachlorkohlenstoff ist für hinreichend kleine Spannungen völlig unabhängig von der Spannungsamplitude und wächst trotzdem linear mit dem Plattenabstand des Meßkondensators. Der Zuwachs gegenüber sehr kleinem Abstand ist fast unabhängig von der Temperatur, während der Grundwert bei 50 Hz mit der reziproken Zähigkeit, wie gewöhnlich, leicht um zwei Größenordnungen geändert werden kann. Der dickenproportionale Zusatz wächst linear mit der Frequenz, so daß bei 4000 Hz der Gesamtverlustfaktor Werte von der Größenordnung 1 (Phasenwinkel von 45°) erreicht, denen gegenüber der Grundwert bei kleinem Abstand ganz zurücktritt. Unterteilung des Kondensators mit Glimmerplatten verringert den Zusatz im selben Maß als die Teilstrecken kleiner werden.

Es wird gezeigt, daß die nach Gleichstrom- oder 50 Hz-Messungen anwesenden Ladungsträger zu Anreicherungsrangschichten vor den Elektroden oder Trennflächen gehäuft, ausreichend hohe Wirkwiderstände bilden können, wenn man Diffusion und Raumladungsfelder berücksichtigt. Die Trägerdichteschwankungen im stationären Konvektionsstrom des Randfeldes bewirken einen "induktiven" Blindleitwert, der den Ladungsstrom des Dielektrikums in der Randschicht wie in einem Sperrkreis oder einer Plasmaschwingung kompensiert. Für den Aufbau der Randschicht genügt, wie für die Helmholtzsche Doppel schicht von Elektrolyten, eine Kontaktspannung von einigen Zehntel Volt. Die beobachtete Verlustwinkelerhöhung im Dielektrikum wird als Komplement zum kapazitiven Verhalten von Elektrolytstrecken be Tonfrequenz betrachtet.

Wir danken den Stadtwerken Düsseldorf für die zur Verfügungstellung eines Meßplatzes und die Förderung der Arbeit. Der eine von uns dankt Herrn Prof. Dr. W. VOGEL für die erste Anleitung in der Hochspannungsmeβtechnik.

Literatur: [1] SCHUMANN, W.O.: Z. Physik 79, 53: (1932). — Arch. Elektrotechn. 27, 155 (1933). — Z. techn Phys. 14, 23 (1933). — [2] BÖNING, P.: Elektrische Isolier stoffe. Sammlung. Braunschweig: Vieweg & Sohn 1938. [3] MÖLLINGER, U.: Verlustmessung an Transformatorol Arch. Elektrotechn. 18, 450 (1927). — [4] LOEB, L.B.: Static electrification. Berlin: Springer 1958. — [5] BÖNING, P. Elektrische Isolierstoffe. Sammlung. Braunschweig: Vieweg & Sohn 1938. — [6] LIEBSCHER, E.: Wiss. Veröff. Siemens-Konz 21, 74 (1942).

Professor Dr. Johannes Jaumann Dr. Chrysanth Marnet, II. Physikalisches Institut der Universität Köln

Das Verhalten verschiedener Flüssigkeiten bei der Elektrostatischen Zerstäubung

Von Klaus Schultze

Mit 11 Textabbildungen

(Eingegangen am 14. Juli 1960)

In dieser Arbeit wird der Vorgang der Elektroatischen Zerstäubung untersucht¹. Für die Zerstäungseigenschaften einer Flüssigkeit ist besonders die üssigkeitsmenge charakteristisch, die in der Zeitheit zerstäubt werden kann. Es werden deshalb Anschluß an die Arbeiten von Straubet [1], [2] ausflußmengen verschiedener Flüssigkeiten unterzichen äußeren Bedingungen verglichen. Es sollen bei auch die Beziehungen untersucht werden, die ischen der Ausflußmenge und den Gasentladungen stehen, die während der Zerstäubung in den Geten hoher Feldstärke auftreten.

1. Versuchsanordnung

Für die Messungen wurde eine schon von Zeleny [3] d English [4] verwendete Anordnung gewählt bb. 1). Die Düse war stets mit dem negativen Pol

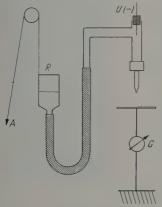


Abb. 1. Schema der Versuchsanordnung. A Aufzug; R Reservoir; U Hochspannung; G Galvanometer

Cleichspannungsquelle (U≤12 kV) verbunden, Platte war geerdet. Der Abstand zwischen der se und der Gegenelektrode betrug 15 mm. Das weau des Flüssigkeitsspiegels im Reservoir wurde die Höhe des Düsenausganges eingestellt (Druck o); Genauigkeit der Druckeinstellung ±0,3 mm issigkeitssäule). Während der Zerstäubung wurde das issigkeitsreservoir durch einen Aufzug in dem Maße die Höhe gezogen, in dem der Flüssigkeitsspiegel och die Zerstäubung in dem Reservoir absank. Auf se Weise blieb während einer Messung der Druck auf i Düsenöffnung konstant. Aus der notwendigen Gewindigkeit des Aufzuges bzw. dem Absinken der issigkeit im Reservoir wurde die Ausflußmenge utimmt.

Für die photographischen Aufnahmen wurde als Lichtquelle eine einmalige Kondensatorentladung benutzt. Die Tröpfehen und ihre Bahn sind durch Striche wiedergegeben, die im Abstand der Maxima und Minima des Funkenüberschlages heller und dunkler erscheinen. Um unerwünschte Reflexe zu vermeiden, wurden die Glasdüsen berußt. Sie sind deshalb auf den Bildern schwarz, und es ist im Streulicht nur der von der Lichtquelle direkt beleuchtete Rand zu sehen. Dementsprechend muß man sich auf der rechten, dunklen Seite die Umrisse der Düse symmetrisch ergänzt denken. Die Düsen sind senkrecht zur Außenwand der Kapillare abgebrochen und dann entweder als Düsen mit scharfem Rand direkt verwendet worden (Abb. 4d), oder aber sie wurden nur am Rand etwas abgerundet (Abb. 2-5). Als Größenvergleich wird unter den Aufnahmen immer der Außendurchmesser der jeweiligen Düse (Φ_a) angegeben. Der Druck wird in Millimetern der zerstäubten Flüssigkeit angegeben. Für die Aufnahmen sind abgesehen von Abb. 2 (Metalldüse) durchweg Glasdüsen verwendet worden.

2. Das Auftreten von Raumladungen während der Zerstäubung

Das Düsenende ist von der Flüssigkeit benetzt. Wird die angelegte Spannung langsam erhöht, so bildet sich am Düsenende ein halbkugelförmiger Tropfen. Durch die Aufladung des Tropfens entsteht ein Druck, der entgegen der Oberflächenspannung auf die Flüssigkeitsoberfläche nach außen wirkt. Die Größe des resultierenden Druckes ist

$$p=rac{2\,\gamma}{r}-rac{arepsilon_0}{2}rac{U^2}{r^2}$$

 $\gamma=$ Oberflächenspannung, r= Tropfenradius, $\varepsilon_0=$ Dielektrizitätskonstante des Vakuums, U= Spannung.

Wenn beim Ansteigen der Spannung der Druck nach außen schließlich den Druck der Oberflächenspannung überwiegt, wird der Tropfen verformt. Er spitzt sich zu, und aus dieser Tropfenspitze wird ein Faden herausgezogen. Mit wachsender Länge wird der Faden immer dünner, bis er in Tropfen zerfällt (Abb. 3). Die Arbeit, die für die Fadenbildung und den Flüssigkeitszerfall aufgewandt werden muß, wird aus der Verkleinerung der elektrischen Feldenergie gewonnen, wenn ein Faden aus der Spitze des Tropfens in Richtung auf die Gegenelektrode herauswächst. Wenn die zerstäubten Tröpfehen geladen sind, verändern sie die Form und Stärke des elektrischen Feldes [5]1. Sie schirmen die Düse bzw. die Spitze des an ihr hängenden Flüssigkeitstropfens ab. Auf Abb. 5a kann man sehen, wie bei einer Tropfenfolge die Tröpfehen abwechselnd nach rechts und nach links fliegen, d.h. die Tröpfehen fliegen immer in die Richtung, in der die vorhergehenden schon am weitesten abgezogen worden sind. Denn in dieser Richtung ist die Feldstärke am größten. Normalerweise

¹ Mit dem Ausdruck "Elektrostatische Zerstäubung" ulen verschiedene Zerstäubungsverfahren bezeichnet. Häuthandelt es sich um mechanische Zerstäubungsverfahren, lenen die Aufladung des Zerstäubers lediglich die Stabilität Größenverteilung des Aerosols beeinflußt. In dieser leit werden die Vorgänge untersucht, bei denen der Flüstitszerfall nur durch die Instabilität hochaufgeladener sigkeitsoberflächen eintritt.

¹ Diese Betrachtungen gelten nicht für isolierende Flüssigkeiten (Gruppe I).

Abb. 2—5. Zerstäubungsformen von Flüssigkeiten verschiedener Leitfähigkeit¹



Abb. 2. Gruppe I. Zwiebelstäuben an Metalldüsen, pulsierend. $U=12,4\,\mathrm{kV}$ p=0; $\Phi_a=1,3\,\mathrm{mm}$; M-Xylol



Abb. 3. Gruppe II. Zertropfen des Flüssigkeitsfadens. U=5,2 kV; p=0; $\Phi_a=0,66$ mm; Isoamylacetat



Abb. 4 a. Gruppe III. Feinste Zerstäubung, stationär, nicht pulsierend U=6.2 kV; p=0; $\phi_a=1,29$ mm; Methaol-Benzolgemisch (1:1)



Abb. 4b. Gruppe III. Kräftige, pulsierende Zerstäubung. Wechsel der Zerstäubungsrichtungen (vgl. Abb. 4c). U=10 kV; p=0; $\varphi_\alpha=1,29$ mm; Methanol-Benzolgemisch



Abb. 4 c. Gruppe III. Herabsetzung der Feldstärke an der Tropfenspitze am Ende einer Zerstäubungsphase. U=10 kV; p=0; $\varphi_a=1,29$ mm; Methanol-Benzolgemisch



Abb. 4 d. Gruppe III. Zerstäubung an scharfkantigen Düsen bei hoher Spannung. Gleichzeitige Zerstäubung von acht Kegelspitzen aus. U=12,4 kV; p=3 mm; $\Phi_{\mathfrak{g}}=1,2$ mm; Aceton



Abb. 5a. Gruppe IV. Koronaentladung an der Tropfenspitze bzw. an der Oberfläche des Flüssigkeitsfadens. U=7,5 kV; p=50 mm; $\Phi_a=0.66$ mm; Glyoerin



Abb. 5b. Gruppe IV. Unterbindung der Zerstäubung durch das Zusammenziehen der Koronaentladung an der Tropfenspitze. $U=9.5\,\mathrm{kV};\;p=0;\;\Phi_g=0.66\,\mathrm{mm};$ Trichloressigsäure (20%)



Abb. 5 c. Gruppe IV. Abtropfen bei Erhöhung des Druckes gegenüber Abb. 5b. Keine Zerstäubung! Die Entladung brennt weiter an der Tropfenspitze. $U=9.5~{\rm kV}:$ $p=15~{\rm mm};$ $\Phi_g=0.66~{\rm mm};$ Aqua dest.

¹ Allgemeine Erläuterungen zu den Aufnahmen S. 11; s. auch Tabelle 1.

Ilzieht sich diese Erscheinung nicht wie auf Abb. 5a einer Ebene, sondern im Raum. Dementsprechend obachtet man einen Kegel von Flüssigkeitströpfchen Abb. 4a). Die Aufladung der zerstäubten Tröpfehen nmt mit der Leitfähigkeit der Flüssigkeit und mit r angelegten Spannung zu. Bei großen Tropfenlungen (U > 6 kV, $\sigma > 2 \cdot 10^{-8} \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1}$) beginnt die rstäubung zu pulsieren. Die Feldstärke wird an der opfenspitze durch die entstehenden Tröpfehenblken so stark abgesenkt, daß die Zerstäubung immer iwächer wird (s. Abb. 4c) und schließlich ganz fhört. Der Tropfen zieht sich zusammen, um sich einer anderen Richtung neu zuzuspitzen. Die

licher Mittelwert, sinkt an dem Ansatzpunkt unter die Instabilitätsgrenze (Höhe der Instabilitätsspannungen s. [3], [8]). Die Zerstäubung ist dann völlig unterbunden (vgl. auch [9]). Der Tropfen ist stabil und halbkugelförmig.

3. Die Einteilung der Flüssigkeiten

Je nachdem, ob die eben besprochenen Erscheinungen bei den einzelnen Flüssigkeiten in stärkerem oder schwächerem Maße auftreten, ändert sich das Verhalten der Flüssigkeiten, ihre Ausflußmenge und die Feinheit der Zerstäubung. Die Aufladung der aus-

Tabelle

	Flüssigkeitsgruppe	Leitfähigkeit (20° C) [Ω ⁻¹ cm ⁻¹]	Elektrische Stromstärke [10 ⁻⁶ A]	Ausflußmenge	Abb	Zerstäubung
	Isolierende Flüssigkeiten	10-18 - 4 · 10-13	< 0,001	<0,01	2	Nur an Metalldüsen Instabilität d. T.
	Grobzerstäubende Flüssigkeiten	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	0,02- 0,15	<0,6	3	Zertropfen des Flüssigkeitsfadens: Grobe Zerstäubung
į.	Feinzerstäubende Flüssigkeiten	$2 \cdot 10^{-8} - 5.8 \cdot 10^{-6}$	0,2 -15,0	0,62-1,35	4	Regelloser Zerfall des Fadens: Feine Zerstäubung
E.	Flüssigkeiten mit vorherrschenden Entladungserscheinungen .	$ 6,4\cdot 10^{-8} < G $	<30	<0,002	5	Abtropfen von Düse: Keine Zerstäubung

Als Bereichsgrenzen sind in der Tabelle jeweils die kleinsten und größten Werte angegeben worden, die innerhalb einer Gruppe den einzelnen Flüssigkeiten gemessen wurden. Die Ausflußmengen wurden bei 10 kV gemessen. Als Düse wurde abgesehen 1 der ersten Gruppe eine Glasdüse verwendet (Innendurchmesser 0,33 mm; Außendurchmesser 0,66 mm).

Untersuchte Flüssigkeiten:

Gruppe: Benzol, Meta-Xylol, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, Toluol, Transformatorenöl.
Gruppe: Monochlorbenzol, Chloroform, Isoamylacetat, Monobrombenzol, Oktanol, Parafinum liquidum, Propionsäure. . Gruppe: Aceton, Äthanol, Äthylenchlorid, Eisessig, Isoamylalkohol, Isobutylalkohol, Methanol, n-Propanol.

. Gruppe: Aqua dest.. Natronlauge, Salpetersäure, Salzlösungen (gesättigte Lösungen in Wasser): Kaliumjodid, Natriumbsulfat, Zinnchlorid, Trichloressigsäure (20% in Wasser), Wasserstoffsuperoxyd, Aqua dest. mit oberflächenaktivem Mittel cen K [γ (Oberflächenspannung) = 31,6 dyn/cm; zur Verfügung gestellt von der BASF].

Zrstäubungsrichtungen wechseln dann regelmäßig er unregelmäßig miteinander ab. Bei hohen Spanngen treten auch mehrere Zerstäubungsrichtuna gleichzeitig auf (s. Abb. 4d).

Eine Erniedrigung der Feldstärke an der Tropfenberfläche kann auch durch Koronaentladungen enthen (über entsprechende Raumladungseffekte bei Metallspitzenkorona vgl. [6]). Je größer die Leitligkeit einer Flüssigkeit ist, desto stärker ist die Bronaentladung, die an ihrer Oberfläche einsetzt, d desto größer ist der Strom, der zwischen Düse ad Platte gemessen wird. Bei großen Strömen B. bei Wasser), ist die Zerstäubung sehr schwach H die Ausflußmenge verschwindend gering (p=0). [7] hat nachgewiesen, daß bei Unterdung der Korona auch an Wasser eine kräftige estäubung auftritt (Experimente bei erhöhtem lftdruck). Die Entladung verteilt sich während der erstäubung über die ganze Oberfläche des Flüssigtsfadens (s. Abb. 5a). Am Ursprung des Fadens sie besonders stark. Bei höherer Spannung >8,1 kV) zieht sich die Entladung bei sehr gut tenden Flüssigkeiten auf einen einzigen Ansatzonkt zusammen; sie zeigt einen charakteristien Aufbau mit dem Faradayschen Dunkelraum sischen dem negativen Glimmlicht und der positiven Sule (s. Abb. 5b). Die Feldstärke, genauer ihr zeitgestoßenen Tropfen und der Koronastrom wachsen beide mit der Leitfähigkeit einer Flüssigkeit. Deshalb wird das Verhalten einer Flüssigkeit durch die Größe ihrer Leitfähigkeit charakterisiert. Man kann die Flüssigkeiten nach ihrem Verhalten bis zu 12 kV in 4 Gruppen einteilen¹:

I. Isolierende Flüssigkeiten $10^{-18} \, (\text{Benzol}) < \sigma < 4 \cdot 10^{-13} \, \Omega^{-1} \, \text{cm}^{-1} \, (\text{Åther})^2$

Eine Instabilität des Tropfens bzw. eine Zerstäubung kann nur an Metalldüsen beobachtet werden. Man kann den Flüssigkeitstropfen als ein nichtleitendes Dielektrikum idealisieren. Die Tropfenform entsteht durch die Kräfte, die das elektrische Feld auf ein Dielektrikum ausübt: Die Flüssigkeit wird als

zwiebelförmiger Tropfen um das Düsenende herum in den Gebieten höchster Feldstärke gehalten (s. Abb. 2). Die Ausflußmenge ist außerordentlich gering (siehe Tabelle).

Nach Abschluß dieser Arbeit wurde eine Veröffentlichung von V. G. Drozin bekannt [10]. Die dort gegebene Einteilung der Flüssigkeiten stimmt anfangs (Gruppe I, II) mit der hier vorgeschlagenen überein. Dort werden die Flüssigkeiten bis

Experimente wurden nur an Glasdüsen durchgeführt. ² Die Werte für die Leitfähigkeit sind Tabellenwerte; in Klammern werden die Flüssigkeiten genannt, auf die sich diese

zu $10^{-5} \Omega^{-1} \, \mathrm{cm}^{-1}$ als nichtleitende Dielektrika

Werte beziehen.

II. Grobzerstäubende Flüssigkeiten $2\cdot 10^{-11}$ (Brombenzol) $<\sigma<2\cdot 10^{-8}\,\Omega^{-1}$ cm⁻¹ (Chloroform)

Die Zerstäubungserscheinungen treten an Glasdüsen und an Metalldüsen in gleicher Weise auf. (Bei gleichem Öffnungsdurchmesser gleiche Ausflußmenge!) Diese Tatsache läßt sich nur so erklären, daß der Tropfen jetzt nicht mehr als nichtleitendes Dielektrikum behandelt werden darf, sondern daß die Instabilität des Tropfens durch seine Aufladung mit wahren Ladungen entsteht. Der Tropfen, der an der Düse hängt, nimmt jetzt auch eine andere Gestalt an (s. Abb. 3). Die Aufladung der wegfliegenden Tropfen ist infolge der kleinen Leitfähigkeit aber noch so gering, daß nur ein einfaches Zertropfen des Flüssigkeitsstrahles zu beobachten ist. Bei Spannungen über 10 kV kann eine schwache Entladung auftreten, sie hat aber keinen Einfluß auf die Zerstäubung.

III. Feinzerstäubende Flüssigkeiten

$2\cdot 10^{-8}$ (Äthylenchlorid) $<\sigma\!<\!5,\!6\cdot 10^{-6}\,\Omega^{-1}$ cm $^{-1}$ (Methanol)

Die Leitfähigkeit ist jetzt so groß, daß die Tröpfehen eine starke Aufladung erfahren. Dadurch wird die Feldstärke an der Tropfenspitze großen Schwankungen unterworfen, die ihrerseits eine regellose Zerstäubung des Flüssigkeitsstrahles verursachen. Die Koronaentladung beeinflußt die Ausflußmenge (Abb. 4).

IV. Flüssigkeiten mit vorherrschenden Entladungserscheinungen

$$6.4 \cdot 10^{-8} \, \Omega^{-1} \, \mathrm{cm}^{-1} \, (\mathrm{Glycerin}) < \sigma$$

Hier überwiegen nicht die Zerstäubungs- sondern die Entladungserscheinungen. Die Zerstäubung wird in einem bestimmten Spannungsbereich völlig unterbunden; auch bei höheren Spannungen entsteht keine Zerstäubung, sondern nur ein Abtropfen (s. Abb. 5).

Die Grenze zwischen der 3. und 4. Gruppe ist nicht scharf. Sie erstreckt sich über einen größeren Leitfähigkeitsbereich, weil sie auch von der Oberflächenspannung bestimmt wird. (Die Feldstärke muß im Mittel kleiner sein als der Instabilitätswert, wenn der Tropfen stabil sein soll.)

4. Betrachtung der Ausflußmengen

Bei der Messung der Ausflußmengen stößt man auf Erscheinungen, die nur durch das Auftreten der oben besprochenen Raumladungen zu erklären sind. Zum Beispiel kann die Ausflußmenge eine unstetige Funktion der Spannung sein. Wenn man die Spannung steigert, so treten sprunghaft Änderungen der Ausflußmenge beim gleichzeitigen Wechsel zwischen bestimmten Tropfenformen bzw. Zerstäubungserscheinungen auf. Bei der Zerstäubung von Aceton tritt solch ein Sprung bei dem Übergang vom stabilen Tropfenkegel zum unregelmäßigen Wechsel der Zerstäubungsrichtungen auf. Die Ausflußmenge steigt dort sprunghaft auf den sechsfachen Wert an (s. Abb. 6: Übergang bei 6kV). Der Grund für diese Erscheinung liegt darin, daß die Tropfenspitze des stabilen Kegels (U<6 kV) immer durch Raumladungen abgeschirmt ist; dagegen ist beim Sprühen (U>6 kV) diese Abschirmung durch

den laufenden Wechsel der Zerstäubungs- und Entladungsrichtungen zeitweise aufgehoben.

Außerdem kann es vorkommen, daß die Ausflußmenge eine mehrdeutige Funktion der Spannung ist. d.h. es können in bestimmten Spannungsbereichen verschiedene Tropfenformen mit unterschiedlicher Ausflußmenge eingestellt werden. Beispielsweise wurde an einem Methanol-Wasser-Gemisch (1:1) folgendes beobachtet: Zwischen 8,2 und 9,5 kV kann sowoh ein normales Sprühen mit einer Ausflußmenge von 0,61 cm³/min als auch ein stabiler Tropfen auftreten an dessen Oberfläche lediglich eine Entladung vor sich geht (25 µA). Die beiden Formen sind in einem Bereich von $-6 \,\mathrm{mm} Flüssigkeit einstellbar$ Bei höherem Druck ist nur das Sprühen und bei niedrigerem Druck nur die stabile Tropfenform mög-Welche Erscheinung man innerhalb dieses Druckbereiches beobachtet, hängt nur davon ab, von welchem Ende des Bereiches aus die Einstellung für den Druck erfolgte.

Solche unstetigen und mehrdeutigen Funktionen lassen sich nicht durch eine allgemeine Ausflußformel erfassen, die für alle Flüssigkeiten und alle Spannungsbereiche gelten könnte. Es soll deshalb nur der Einfluß der einzelnen Konstanten einer Flüssigkeit auf die Ausflußmenge besprochen werden.

Der Einfluß der Flüssigkeitseigenschaften auf die Ausflußmenge

Die wichtigsten Größen sind die Leitfähigkeit und die Zähigkeit. Wenn man den Einfluß der Leitfähigkeit nachprüfen will, braucht man deshalb Flüssigkeiter gleicher oder wenigstens annähernd gleicher Zähigkeit und unterschiedlicher Leitfähigkeit. Solche Flüssigkeiten kann man sich durch Mischungen herstellen In Abb. 7 ist die Ausflußmenge von Methanol-Wassel und Methanol—Tetrachlorkohlenstoff-Gemischen aufgetragen. Die Messungen wurden mit einer Glasdüse (Innendurchmesser 0,33 mm; Außendurchmesser 0,66 mm) durchgeführt. Die Leitfähigkeit der Methanol—Tetrachlorkohlenstoff-Gemische hängt exponentiell von der Konzentration des Methanolgehaltes ab [11]. Durch diese Abhängigkeit ist das außerordentlich steile Ansteigen der Kurve zwischen 92% bis 85% Tetrachlorkohlenstoff zu erklären. Der Abfall der Kurve zwischen 25 bis 60% Wasser entsteht durch das Absinken des zeitlichen Mittelwertes der Feldstärke infolge eines immer stärker werdenden Koronastromes. Für Mischungen mit einem Wassergehalt von über 50% kann an Stelle der Zerstäubung eine nicht abbrechende Korona an einem stabilen Tropfen eingestellt werden (Kurventeil B). In Abb. 8 ist die Ausflußmenge der untersuchten Mischungen in Abhängigkeit von der Stromstärke aufgetragen. Die Stromstärke wächst mit der Leitfähigkeit einer Flüssigkeit. Eine solche Darstellung der Ausflußmenge in Abhängigkeit von der Stromstärke ist zweckmäßig, weil die Stromstärke für die Herabsetzung der Feldstärke die entscheidende Größe ist. Man sieht an Abb. 8, daß die Ausflußmenge zunächst mit wachsender Stromstärke zunimmt. Bis zu 0,15 µA entspricht das Aussehen der Zerstäubung dem Verhalten der II. Flüssigkeitsgruppe (s. Tabelle). Dann setzt das Sprühen ein (III. Gruppe), und die Ausflußmenge bleibt nach Durchlaufen eines Maximums annähernd

Instant. Bei einer Stromstärke von etwa 15 µA Iginnt dann der Übergang zwischen der III. und I. Flüssigkeitsgruppe.

In Abb. 9 ist die Abhängigkeit der Ausflußmenge vn der Zähigkeit angegeben. Es wurden für die Issung organische Flüssigkeiten unterschiedlicher Zhigkeit und annähernd gleicher Leitfähigkeit vervndet. Die Abnahme der Ausflußmenge mit zu-

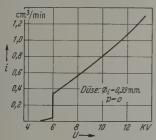
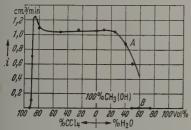


Abb. 6. Abhängigkeit der Ausflußmenge von der Spannung

ramender Zähigkeit ist auf den Strömungswiderstand Glasdüse zurückzuführen.

Neben den bis jetzt genannten Konstanten haben Oberflächenspannung und die Dichte einen Einfluß die Zerstäubungsmenge, weil für die Zerstäubung



bb. 7. Ausflußmengen von Mischungen verschiedener Leitfähigkeit

eie bestimmte Oberflächenarbeit und Beschleuni-Augsenergie aufgebracht werden muß. Ein Unterlied in der Oberflächenspannung wirkt sich bei der tersuchung verschiedener Flüssigkeiten auf die sflußmenge nur bei niedrigen Spannungen aus. In ist nämlich der Unterschied zwischen den Aus-Bmengen durch die unterschiedlichen Instabilitätsnzen (Einsatzspannungen) gegeben. Bei hohen Innungen ist eine Abnahme der Ausflußmenge mit hsender Oberflächenspannung nicht mehr nachvisbar. Vermutlich werden bei hohen Spannungen IkV) die Geschwindigkeiten der Tropfenspitze bzw. Flüssigkeitsfadens so groß, daß die für die Zer-Albung notwendige Oberflächenarbeit nur noch den Bruchteil der notwendigen Beschleunigungsrgie beträgt (Einzelheiten s. [12]). Der Einfluß der hte auf die Ausflußmenge fällt praktisch nicht Gewicht, weil die Dichten der meisten organi-Flüssigkeiten sich nur wenig voneinander "rerscheiden.

Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Derschiede in der Zerstäubungsmenge, die durch die igkeit und die Oberflächenspannung der einzelnen sigkeiten gegeben sind, sich durch geeignete Wahl is äußeren Versuchsbedingungen ausgleichen lassen be der Düsenöffnung, hydrostatischer Druck,

Elektrodenabstand s. unten). Allein die Unterschiede, die durch die Leitfähigkeit hervorgerufen werden, sind nicht auszugleichen.

Der Einfluß des Druckes und der Düsenöffnung auf die Ausflußmenge

Die Flüssigkeitsmenge, die durch Instabilität einer Oberfläche bei einer bestimmten Spannung vernebelt werden kann, ist begrenzt. Man kann durch

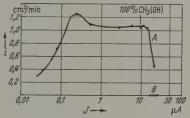


Abb. 8. Ausflußmenge verschiedener Mischungen als Funktion des Stromes

eine Erhöhung des hydrostatischen Druckes zwar den Durchfluß durch die Düse erhöhen und dadurch den Strömungswiderstand der Düse ausgleichen, aber

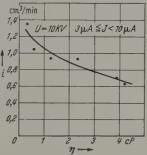


Abb. 9. Abhängigkeit der Ausflußmenge von der Zähigkeit ($U=10~\mathrm{kV}$)

man kann die Zerstäubung dadurch nicht erzwingen. Wenn nun durch höheren Druck größere Flüssigkeitsmengen aus der Düse ausfließen, als bei einer bestimmten Spannung vernebelt werden können, ändert sich die Zerstäubungsform; es werden dann in regelmäßigen Abständen ganz große Tropfen ausgeschleudert. Der Durchmesser dieser Tropfen ist dann ungefähr so groß wie der der Düse, d.h., er übertrifft den Durchmesser der übrigen Tröpfehen, die durch die Instabilität der Oberfläche entstanden sind, um eine Größenordnung! ZELENY hat diese Erscheinung in einer fortlaufenden Bilderfolge photographiert (Zerstäubung von Methanol bei 5 kV und $p=3\,\mathrm{cm}$ Flüssigkeitssäule) [5]. Diese Tatsache gibt bei der Zerstäubung von Wasser leicht zu Täuschungen Anlaß. Bei wenig erhöhtem Druck (10 mm H₂O) bekommt man nämlich an Stelle des runden, stabilen Wassertropfens mit einer Entladung eine sehr grobe "Zerstäubung". Es handelt sich hier aber nicht um eine Zerstäubung, sondern nur um ein schnell aufeinanderfolgendes Abtropfen. Der Tropfen verlängert sich regelmäßig zu einem langen Stift, bis er in der Mitte auseinanderbricht (s. Abb. 5c). Es tritt aber keine Zuspitzung des Tropfens, keine Oberflächeninstabilität auf. Die Entladung beginnt nach wie vor an der Spitze des Tropfens und verhindert seine

Instabilität. Man kann diese Erscheinung an Glycerin leichter beobachten als an Wasser.

In Abb. 10 ist die Druckabhängigkeit der Ausflußmenge bei der Zerstäubung von Aceton aufgetragen.

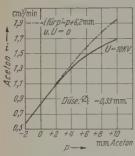


Abb. 10. Druckabhängigkeit der Ausflußmenge (U=10 kV)

Man sieht daraus zunächst, daß die Druckeinstellung während einer Messung sehr genau eingehalten werden muß. Denn bei p=0 hat eine Erhöhung oder Erniedrigung des Druckes um +1 mm eine Änderung der Ausflußmenge um 20% zur Folge! An Abb. 10 sieht man, daß die Erhöhung des Drukkes über das Nullniveau sich im Rahmen der Meßgenauigkeit nur auf den

Durchfluß durch die Düse auswirkt: Die unterbrochene Kurve stellt die Ausflußmenge dar, die durch

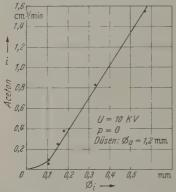


Abb. 11. Ausflußmenge als Funktion des Öffnungsdurchmessers

die Düse bei einem Druck von p' = p + 6,2 mm in ein Flüssigkeitsbad fließt (U=0). Durch den Druck von 6,2 mm wird gerade die Flüssigkeitsmenge durch die Düse gedrückt, die während der Zerstäubung (U =10 kV, p=0) gemessen wird. Man sieht an Abb. 10,

daß diese beiden Kurven für kleine Druckänderunger übereinstimmen. Bei großen Druckänderungen ist das nicht mehr der Fall. Das liegt daran, daß bei größeren Ausflußmengen (d.h. größerer Raumladung) die Feldstärke an der Tropfenspitze absinkt.

Die Ausflußmenge kann man auch durch die Weite der Düsenöffnung bestimmen (Abb. 11). Für die in Abb. 11 eingetragenen Meßwerte wurden Düsen ver schiedenen Innendurchmessers aber gleichen Außen durchmessers verwendet.

Zusammenfassung

Es ist nicht möglich, eine Formel anzugeben, die es gestattet, die Ausflußmenge für eine beliebig Flüssigkeit aus den Konstanten der Flüssigkeit und den äußeren Bedingungen zu berechnen. Das liegt daran, daß die Ausflußmenge weder eine stetige noch eine eindeutige Funktion der Spannung ist. Es ist aber möglich, die Flüssigkeiten nach der Größe ihrer Leitfähigkeit in Gruppen einzuteilen. In einer Gruppe sind dann Flüssigkeiten gleichen äußeren Verhalten (Größenordnung der Ausflußmenge, Feinheit der Nebels) zusammengefaßt.

Diese Arbeit wurde im Physikalischen Institut de Friedrich-Schiller-Universität Jena (Institutsdirektor Prof. Dr. W. Schütz) durchgeführt. Für die Anregung zu diesem Thema sowie für die immer hilfsbereite Beratung während der Arbeit möchte ich Herre Prof. Dr. HARALD STRAUBEL besonders herzliel danken.

Literatur: [1] STRAUBEL, H.: Z. angew. Phys. 6, 26 (1954). — [2] STRAUBEL, H.: Exp. techn. Phys. 3, 89 (1955). [3] Zeleny, J.: Phys. Rev. 3, 69 (1914). — [4] ENGLISH, W.N. Phys. Rev. 74, 179 (1948). — [5] Zeleny, J.: Phys. Rev. 18 (1917). — [6] Gänger, B.: Der elektrische Durchschla von Gasen. Berlin 1953. — [7] Zeleny, J.: Proc. Cambi Phil. Soc. 18, 71 (1915). — [8] RAYLEIGH: Phil. Mag. 14, 184 (1882). — [9] PAUTHENIER, M., u. G. DUHAUT: Resgén. Elektr. 58, 35 (1949); 59, 133 (1950). — [10] DROZIN V. G.: J. Coll. Sci. 10, 158 (1955). — [11] GEMANT, A.: Wiss Veröff. Siemenskonzern 6, 58 (1928); [12] SCHULTZE, K.: Diplomarbeit, Jena 1957.

> Dipl.-Phys. KLAUS SCHULTZE, Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, München 23

Einfluß von Oberflächenströmen auf die Charakteristik formierter Spitzengleichrichter

Von R. EBHARDT, E. HOFMEISTER und E. GROSCHWITZ

Mit 13 Textabbildungen

(Eingegangen am 7. Oktober 1959)

Einleitung

Die vorliegende Untersuchung schließt sich an eine Reihe früherer Arbeiten der Verfasser an [1] bis [5]. Es werden im folgenden Meßergebnisse über die Strom-Spannungsabhängigkeit von formierten Spitzengleichrichtern mitgeteilt und diskutiert. Die physikalische Interpretation dieser Messungen stützt sich auf ausgewertete analytische Ergebnisse, die in den Arbeiten [1] bis [5] ermittelt worden sind. Die hierbei als Leitmotiv der Untersuchung verwendet Konzeption geht von der Vorstellung aus, daß di elektrischen Eigenschaften von Halbleiterkontakte nicht unerheblich von Oberflächenströmen bestimm werden. Dieser Sachverhalt liegt ganz besonder stark bei Spitzengleichrichtern vor. Die experimer tellen Erfahrungen bei der physikalisch-technische Entwicklung und industriellen Fertigung von Die den und Transistoren zeigen, daß charakteristisch eliche Veränderungen der Strom-Spannungskennren durch Leckströme auftreten, die an Halbleiterctakten parallel zur Oberfläche in Oberflächenversionsschichten fließen. Eine Reihe von Autoren
üten deshalb Messungen der Leitfähigkeit in solchen
vallen durch [6] bis [12]. In der bisherigen Fachtatur ist jedoch, soweit den Verfassern zur Zeit beint, das Problem der Oberflächenströme im Zumenhang mit der Physik der Spitzenkristallgleichiter noch nicht ausführlich theoretisch und experitell behandelt worden.

Die im folgenden durchgeführte vergleichende rlyse der berechneten und der gemessenen Charaktiken zeigt einen bemerkenswerten Einfluß der oleiteroberfläche auf den Mechanismus des Gleichbereffektes von Spitzenkristallgleichrichtern. Bei icksichtigung des Oberflächenstromes lassen sich gemessenen Kurven befriedigend durch die Theorie hreiben. Die konventionelle Theorie des pntrganges für das kugelsymmetrische Problem ohne rag des Oberflächenstromes leistet diese Übereinmung nicht in gleicher Weise. Die in den Arbeiten und [4] durchgeführte analytische Beschreibung *Oberflächenstromes stützt sich auf eine in [3] mitilte Untersuchung über den inneren Aufbau von b flächeninversionsschichten. Wesentlich ist hierlie Herstellung des Zusammenhanges, auf welche Be die physikalische Beschaffenheit der Kristallofläche und die Größen des Halbleiterkörpers die ktur und die elektrischen Eigenschaften der Oberineninversionsschicht bestimmen. Das verwendete bell des Oberflächenstromes [4] stellt eine schemase Vereinfachung des in Wirklichkeit sehr kompligen Potential- und Stromlinienverlaufes dar; es shreibt jedoch die wesentlichen physikalischen Vore in einer geschlossenen mathematischen Form, # für die Auswertung der analytischen Ergebnisse die Diskussion des experimentellen Sachverhaltes *Vorteil ist.

Gei der Analyse der gemessenen Strom-Spannungsschungen zeigt sich, daß der Anteil des Oberflächenmes den Verlauf des Gesamtstromes in charaktesteher Weise bestimmt und insbesondere von iher Größenordnung ist wie der gemessene Gesetstrom. Ein Vergleich zwischen dem Volumentund dem Oberflächenstrom im Zusammenhang it dem experimentell bestimmten Gesamtstrom gestet quantitative Aussagen über die Beschaffenheit "Halbleiteroberfläche und über den Einfluß der **ktur der Oberflächeninversionsschicht auf die **isakteristik.

ie in [2], [3] und [4] ausgearbeitete theoretische peption der Oberflächenströme ist so allgemein gelin, daß sie grundsätzlich nicht nur auf Spitzenoen, sondern auch auf andere Halbleiterbaueleite angewendet werden kann. Ein entsprechendes biel für Oberflächenströme am Kollektor eines itten Transistors ist in [4] behandelt worden. Bei diendioden ist jedoch das Problem der Oberflächenströme im Prinzip viel gravierender als bei rasistoren, weil bei Spitzendioden die Ausdehnung urch die Feder gebildeten Kontaktfläche außerlitlich viel kleiner ist als die geometrische Größe hysikalisch wirksamen Halbleiteroberfläche [5]. Irimentell läßt sich leicht zeigen, wie empfindlich leichrichtereigenschaften bei einer Veränderung

der physikalischen Bedingungen an der Halbleiteroberfläche reagieren. Die Vorbehandlung der Kristalloberfläche, z.B. durch Ätzen, Bestrahlen, Tempern,
aber auch der Einfluß der Gasatmosphäre oder die
Art der Oberflächenbelegung bei fertigen Spitzendioden
demonstrieren die Größenordnung und Bedeutung der
physikalischen Eigenschaften der Oberfläche für den
Gleichrichtereffekt des Bauelements. Im Rahmen der
in [2] und [3] durchgeführten Beschreibung der Oberflächeninversionsschichten wird dieser Sachverhalt
verständlich, weil hierbei gezeigt wird, wie die Eigenschaften der Oberfläche die Struktur der Inversionsschicht bestimmen.

Das in [2] bis [4] ausgeführte Modell des Oberflächenstromes enthält die Vorstellung einer spannungsabhängigen effektiven Kontaktfläche, die in [5] auch quantitativ diskutiert worden ist. Diese effektive Kontaktfläche beschreibt jenen Oberflächenbereich in der Umgebung der Metallspitze, der durch die Existenz des Oberflächenstromes in den Gleichrichtereffekt einbezogen wird. Von W. Schottk wurde bereits vor Jahren die Vermutung geäußert¹, daß der Strom von Spitzendioden durch eine spannungsabhängige effektive Kontaktfläche über die Oberflächeninversionsschicht fließt, wobei die Verhältnisse an der Kristalloberfläche jeweils eine modifizierende Rolle spielen.

Die Beschaffenheit der Halbleiteroberfläche wird durch die elektrische Oberflächenladung charakterisiert, die summarisch die Gesamtwirkung der Adsorptionsschicht und der Oberflächenzustände auf die Struktur der Oberflächeninversionsschicht inhaltet. Durch die elektrische Flächenladungsdichte an der Kristalloberfläche ist die Randfeldstärke der Oberflächeninversionsschicht bestimmt, die für den inneren Aufbau und das elektrische Verhalten dieser gesamten Inversionsschicht von Bedeutung ist. Eventuell vorhandene Transportvorgänge innerhalb der adsorbierten Fremdschicht auf der Kristalloberfläche werden im Rahmen dieser Untersuchung nicht in Betracht gezogen. Diese Konzeption, die den Oberflächenstrom in erster Linie als einen Vorgang innerhalb der oberflächennahen Zone der Inversionsschicht betrachtet, ist im Sinne einer guten Approximation durch naheliegende physikalische Gründe gerechtfertigt. Es ist anzunehmen, daß die Leitfähigkeit innerhalb des Kristallgitters wesentlich größer ist als in der allgemeinen stark gestörten und inhomogenen Oxydschicht oder in anderen Adsorptionsschichten. Außerdem ist die Dicke der Anreicherungsschicht im allgemeinen ein bis zwei Größenordnungen größer als die hiergegen sehr dünne molekulare Adsorptionsschicht, so daß ein möglicherweise in der äußeren Fremdschicht stattfindender Transport von Ladungsträgern einen Strombeitrag liefern würde, der gegenüber dem Oberflächenstrom innerhalb der Anreicherungszone der Oberflächeninversionsschicht vernachlässigt werden kann. Dies gilt jedoch nur bei zeitlich stationären Vorgängen, also bei einer äußeren Belastung der Oberflächeninversionsschicht mit einem zeitlich konstanten Potential. Bei zeitlich periodischen

¹ Briefliche Diskussionsbemerkungen von W. Schottky im Jahre 1952 zu einer nicht veröffentlichten Arbeit von E. Groschwitz über den Einfluß von UV-Bestrahlung der Halbleiteroberfläche auf den Gleichrichtereffekt bei Spitzendioden.

Vorgängen oder Impulsbelastungen kann die Strukturänderung der adsorbierten Fremdschicht an der Kristalloberfläche durchaus den Oberflächenstrom beeinflussen. Bei Wechselstromvorgängen spielen sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht die Prozesse der Störstellenreaktionen nicht nur am Kristallrand, sondern insbesondere auch in der adsorbierten Fremdschicht eine Rolle. Auch statistische Fluktuationsprozesse an der Halbleiteroberfläche, z. B. Rauscheffekte, werden zum Teil durch Schwankungserscheinungen des Adsorptionsgleichgewichtes be-

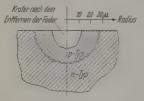


Abb. 1. Schnitt durch einen Formierkontakt nach R. THEDIECK [Z. angew Phys. 5, 165 (1953)]

stimmt. Bei den in der vorliegenden Arbeit zu erörternden Fragen handelt es sich grundsätzlich um Gleichstromeffekte und demzufolge um stationäre Strom-Spannungsbeziehungen.

Anschließend soll zunächst der experimentelle Sachverhalt mitgeteilt werden. Dann

werden aus den theoretischen Ergebnissen von [2] bis [5] berechnete Charakteristiken diskutiert, wobei insbesondere die Stromanteile des Volumenstromes und

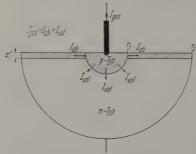


Abb. 2. Schema eines formierten Spitzengleichrichters mit ausgeprägter Modell-Oberflächen-Inversionsschicht

des Oberflächenstromes unterschieden werden. Hierauf folgt der Vergleich zwischen experimentellen und theoretischen Kurven mit einer Diskussion der hierbei durchführbaren Analyse der Gesamtcharakteristik. Schließlich werden in einem Anhang die analytischen Ergebnisse aus [1] bis [5] zusammengestellt, mit deren Hilfe die experimentellen Kurven verglichen wurden.

Experimentelle Untersuchung

Die Kennlinienmessungen wurden mit einer Kompensationsmethode durchgeführt, die einerseits eine genaue Bestimmung von Meßwerten auch bei kleinen Strömen erlaubt und andererseits Fehler durch Innenwiderstände der Meßinstrumente zu eleminieren gestattet. Für die Dioden wurden Germanium-Plättchen verwendet, die mit Arsen dotiert waren. Als Ausgangsmaterial diente ein aus der Schmelze gezogener Germanium-Einkristallstab. Die Störstellendichte betrug $n_D=0.8 \cdot 10^{15}~{\rm cm}^{-3}$, was einem spezifischen Widerstand von 2 Ω em entspricht. Als Federmaterial wurde Molybdän gewählt. Der Krümmungsradius der Molybdänspitze schwankte bei den einzelnen Dioden zwischen 3 und 5 μ . Bei der Formierung wurde die Federkraft der Metallspitze mit Hilfe eines Dyna-

mometers für alle Dioden gleich groß eingestellt. I Formierstromimpuls betrug 0,6 A und 0,75 see w war für sämtliche Exemplare gleich.

Um die gemessenen Kurvenverläufe mit den the retischen Kurven vergleichen zu können, ist die Kem nis einer Reihe von Parametern erforderlich: I Radius r, der Formierhalbkugel, die Diffusionsläng im Kristall L_{vol} und in der Anreicherungsschicht ϵ Oberflächeninversionsschicht L_{ob} , die elektrische F chenladungsdichte auf der Kristalloberfläche. I Radius r₁ variiert mit den Formierbedingungen u repräsentiert somit das effektive Ergebnis einer h stimmten Formiervorschrift. Die Diffusionslänge I charakterisiert den Leitungsmechanismus im Inner des Kristalls, sie bestimmt somit den über die Formie halbkugel fließenden Volumenanteil des Diodenstr mes. Die Größe L_{vol} wird durch Messung am Ai gangskristall bestimmt, der zur Herstellung der Diod verwendet wurde. Durch die elektrische Fläche ladungsdichte an der Kristalloberfläche ist die ele trische Randfeldstärke und somit der Aufbau der I versionsschicht, z.B. die Dicke der Anreicherung schicht, bei vorgegebener Dotierung festgelegt. I elektrische Flächenladungsdichte kann durch die Vo geschichte des Kristalls, durch Oberflächenbehanlung, durch die an den Kristall anschließende Gaphase und durch technologische Bedingungen t der Herstellung der Spitzendioden verändert werde Für die fertige Diode stellt die elektrische Fläche ladungsdichte eine charakteristische effektive Grö dar, durch welche die physikalische Beschaffenho der Kristalloberfläche und ihre Wirkung auf d Gleichrichtereffekt zum Ausdruck kommt. Desgle chen ist die Diffusionslänge L_{ab} in der an den Krista rand anschließenden Anreicherungsschicht als ein effektive phänomenologische Kenngröße des Obe flächenstromes der Spitzendiode anzusehen.

R. THEDIECK [13] hat den Einfluß und die phys kalischen Verhältnisse der Formierung von Spitze kontakten an Germaniumoberflächen eingehend e perimentell untersucht. Durch ein stufenweises At und Meßverfahren wurde von Thedieck die Tiefensu dehnung desjenigen Halbleitergebietes bestimmt, de durch die Formierung gegenüber dem Grundmateri den Leitungstypus geändert hat. Die Dicke der Sper schicht wird mit weniger als 2 μ angegeben. Bei TH DIECK betrug der Formierstromimpuls etwa 1 A un 1 sec. Nach dem Formierprozeß hat der gesamt Radius r_1 der Halbkugel vom p-Typ eine Größ zwischen 24 und 34 µ. In Abb. 1 ist der Schnitt durc das beschriebene Formiergebiet nach Thedieck da gestellt. Bei den Spitzendioden, die von uns zu de Messungen herangezogen wurden, war der Formie stromstoß geringer, so daß sich etwas kleinere Radio ergaben.

Auswertung und Diskussion der analytischen Ergebnisse

Zur Erleichterung des Verständnisses ist es zwechmäßig, die gewonnenen analytischen Ergebnisse, di im letzten Abschnitt dieser Arbeit zusammengestell sind, an Hand berechneter Beispiele zu diskutierer Abb. 2 zeigt das Modell eines Spitzenkontaktgleichrichters. Die halbkugelförmige Zone vom Radius stellt das durch den Formierprozeß entstandene leitende Gebiet hoher Leitfähigkeit dar. An diesen

bkugelförmigen Gebiet existiert somit ein echter Übergang infolge von zwei aneinandergrenzenden stallbereichen, deren Leitungstypus durch die Ansenheit entsprechender Donatoren- bzw. Akzepcenkonzentrationen bestimmt wird. Beim Formieren d die auf den Halbleiterkristall aufgesetzte Metallitze durch einen kurzen Formier-Stromstoß stark fitzt, wodurch das Germanium in einem kleinen eich in der Umgebung der Spitze schmilzt. Durch das flüssige Halbleitermaterial eindiffundierende brstellen und durch eine hohe Konzentration von terbaufehlern mit Akzeptorencharakter entsteht Machine Abkühlen der Schmelzzone im n-leitenden Gerrnium ein nahezu halbkugelförmiges p-leitendes miergebiet. Über diesen halbkugelförmigen pnlergang fließt der Volumenanteil des Diodenstromes. H. BENEKING [14] sowie HOFMEISTER und GROSCHvrz [1] haben den Einfluß der geometrischen Vertnisse, die bei der Spitzendiode im Gegensatz zum llnen pn-Übergang vorliegen, berücksichtigt und rielten dadurch eine bedeutend bessere Übereintnmung der theoretischen und experimentellen Eronisse. In der Arbeit [1] wurde die Strom-Spaningsgleichung durch Formfaktoren verbessert, die in für das kugel- und zylindersymmetrische Problem der Analysis ergeben. Beneking berücksichtigt Berdem noch die spannungsabhängige Variation Sperrschichtdicke und erhält dadurch eine Errung für den mit wachsender Sperrspannung steiaden Sättigungsstrom.

In Abb. 2 ist ferner schematisch zwischen den dien r_1 und r_2 die den Oberflächenstrom leitende reicherungsschicht dargestellt. Die senkrecht zur erfläche gemittelte Konzentration der Defektktronen sowie die Dicke der Anreicherungsschicht wieren mit dem sich an der Oberfläche zwischen r_1 r_2 einstellenden Potentialverlauf. Feld- und Ohteverteilung stehen in einem sich gegenseitig beigenden ursächlichen Zusammenhang. Der zylindermmetrische Potentialgradient bewirkt einerseits eine rriation der mittleren Trägerdichte an jeder Stelle r, man sich durch homogen in der Anreicherungsticht verteilte fiktive Quellen und Senken erzeugt oken kann, und andererseits die Bewegung der Laingsträger in der idealisierten Modellinversionsschicht vallel zur Oberfläche. Dieser Mechanismus ist ein adellmäßiger Ersatz für die in Wirklichkeit komplite Stromverteilung innerhalb der Oberflächeninverusschicht [4]. Am Rande r_1 werden beim Übergang sschen der spannungsabhängigen Leitfähigkeit der vitenden Anreicherungsschicht und der von der Spanng nicht abhängigen halbkugelförmigen p-Zone des miergebietes keine zusätzlichen Bedingungen angemmen. An der äußeren Elektrode wird die Spannung Ill festgehalten, so daß hier die Verhältnisse in der reicherungsschicht nicht durch eine an den Spitzenutakt angelegte Spannung modifiziert werden.

In Abb. 3 sind Strom-Spannungskennlinien des itzenkontaktgleichrichters dargestellt, die nach den letzten Abschnitt der vorliegenden Arbeit zumengestellten theoretischen Ergebnissen [1] bis 5 berechnet wurden. Als Beispiel wurde n-leitendes bleitermaterial als Grundsubstanz mit einer Dougskonzentration $n_D=10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$ gewählt, was im spezifischen Widerstand von $\varrho=1,5\,\Omega\mathrm{cm}$ entocht. Der Radius r_1 der formierten, p-leitenden

halbkugelförmigen Zone in der Umgebung der Metallspitze beträgt 25 μ und der Radius r_2 des äußeren Kristallrandes nach üblichen Richtleiterabmessungen 800 μ . Für die Berechnung des Volumenstromes I_{vol} kann in der Formel (2), s. Anhang, der Anteil des Diffusionsstromes der Elektronen im p-leitenden halbkugelförmigen Gebiet gegenüber dem Löcherstrom im n-leitenden Kristallgebiet des Halbleiterinneren vernachlässigt werden. Diese Näherung setzt voraus, daß die Dichte der Defektelektronen in der formierten Halbkugelzone groß ist gegen die Konzentration der

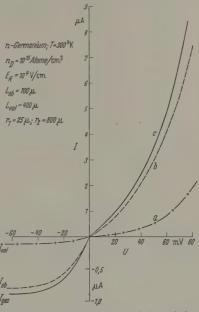


Abb. 3. Berechneter Volumen-Oberflächen- und Gesamtdiodenstrom in Abhängigkeit von der angelegten Spannung eines Spitzengleichrichters

Leitungselektronen im n-leitenden Halbleiterkristall. Die Diffusionskonstante D_p der Löcher beträgt in Germanium $44~{\rm cm^2/sec}$; für die zugehörige Diffusionslänge L_p wurde ein gebräuchlicher, mittlerer Wert von $400~\mu$ angenommen. Mit den obigen Werten erhält man bei den vorliegenden geometrischen Abmessungen einen Volumensättigungsstrom von $I_{s\,vol}=0.08~\mu{\rm A}.$ Die mit diesem Sättigungsstrom berechnete Diodenkennlinie des Volumenstromes ist in Abb. $3~{\rm mit}~a$ bezeichnet.

Zur Berechnung des Oberflächenstromes ist neben den bereits erwähnten Bestimmungsgrößen noch die Wahl der elektrischen Flächenladungsdichte an der Kristalloberfläche oder der entsprechenden Randfeldstärke E_R notwendig. In [3] ist mit der Ungleichung (15a) ein Kriterium für E_R angegeben, das für die Ausbildung einer ausgeprägten Anreicherungsschicht (starke Inversion) erfüllt sein muß. Für Germanium mit einer Dotierung von 1015 Atomen/cm3 liegt die untere Grenze der erforderlichen Randfeldstärke nach Maßgabe des Kriteriums bei etwa 6 · 103 V/cm. Die obere Grenze ist durch die Durchbruchsfeldstärke beschränkt, die mehr als 105 V/cm beträgt. Für unser Beispiel haben wir $E_R = 10^4 \, \text{V/cm}$ gewählt. Dieser Randfeldstärke entsprechen etwa 10¹¹ Elementarladungen pro cm² der Oberfläche. Wenn man annimmt, daß diese Elementarladungen von ionisierten Atomen oder Molekülen herrühren, so ist bei einer Flächenladungsdichte von 10¹¹ cm⁻² der gegenseitige Abstand der elektrisch wirksamen Zentren etwa 1000 bis 10000 Moleküldurchmesser.

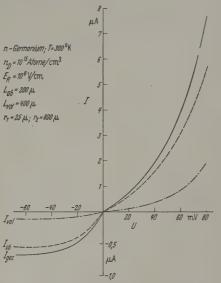


Abb. 4. Berechneter Volumen-Oberflächen- und Gesamtdiodenstrom in Abhängigkeit von der angelegten Spannung eines Spitzengleichrichters

Bei Diffusionsvorgängen in randnahen Gebieten sind die kennzeichnenden Größen gegenüber den entsprechenden Volumenparametern mehr oder weniger

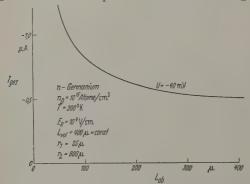


Abb. 5. Berechneter Gesamtdiodenstrom in Abhängigkeit von der effektiven Diffusionslänge der Anreicherungsschicht an der Halbleiteroberfläche

zu modifizieren. Durch Reflexion der beweglichen Ladungsträger an der Kristalloberfläche sowie durch vergrößerte Anzahl der Rekombinationszentren ist eine kleinere Diffusionslänge gegenüber dem Kristallinneren zu erwarten. Aus den gleichen Gründen ist auch die Beweglichkeit der Ladungsträger im allgemeinen etwas verkleinert [15].

Um diese randnahen Verhältnisse zu berücksichtigen, ist in dem Rechenbeispiel der Abb. 3 für die Berechnung des Oberflächenstromes die Diffusionslänge $L_{ob}=100~\mu$ in der Anreicherungsschicht der Oberfläche gewählt worden, während für den Volumenanteil des Stromes über das formierte Halbkugelgebiet $L_{vol}=400~\mu$ angenommen wurde. Die mit diesen Para-

metern berechnete Kennlinie des Oberflächenstrome. [s. Anhang Formel (11)], ist ebenfalls in Abb. 3 dar gestellt (Kurve b). Der Gesamtstrom, der sich au der Summe des Volumenstromes und des Oberflächen stromes zusammensetzt, ist in Kurve c veranschaulicht

Das Zustandekommen eines Gleichrichtereffekte des Oberflächenstromes wurde in [4] im einzelner auseinandergesetzt. In physikalischer Hinsicht re sultiert die Kennlinie des Oberflächenstromes auf den Zusammenwirken bestimmter spannungsabhängige Größen der Anreicherungsschicht gemäß Formel (11) Insbesondere beruht die Unipolarität des Oberflächenstromes auf dem in Fluß- und Sperrichtung unsymmetrischen Verlauf der Variation der mittleren Träger dichte sowie der Dicke der Anreicherungsschicht in Abhängigkeit von der angelegten Spannung.

Es sei hierbei bemerkt, daß die zum Rechenbeispie nötige Wahl bestimmter physikalischer Größen viel leicht als willkürlich erscheinen könnte. Ein solche Argument ist jedoch nicht gerechtfertigt, weil die Be deutung des Beispiels gerade in der Demonstrationeines empirischen Sachverhaltes besteht, der sich aus einer Reihe verschiedener Ursachen von physikalisch gut begründeter Größenordnung zusammensetzt. In sofern erweist sich das Studium eines berechnete Modells als ein wirksames Hilfsmittel zur Analyster einzelnen physikalischen Ursachen eines komplizierten zusammengesetzten Effektes wie beispielsweist der gemessenen Strom-Spannungskennlinie.

Aus den in Abb. 3 dargestellten Kurvenverläufer ist ersichtlich, daß sowohl im Sperr- als auch in Durchlaßbereich der Oberflächenstrom den größter Anteil am Gesamtstrom liefert. Um zu verdeutlichen welchen Einfluß die den Leitungsmechanismus in der Modellanreicherungsschicht charakterisierende Dif fusionslänge L_{ab} nimmt, sind in Abb. 4 die Strom Spannungskennlinien für eine doppelt so große Dif fusionslänge $L_{ob} = 200 \,\mu$ dargestellt worden. Alle anderen physikalischen Bestimmungsgrößen wurder hierbei festgehalten. Physikalisch entspricht einer größeren Diffusionslänge eine geringere Rekombination in der Modellanreicherungsschicht. Die Rekombinationsfähigkeit der Oberfläche kann durch verschiedene Oberflächenbehandlung in definierter Weise beeinflußt werden. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Oberflächeneinflüsse auf den Dioden strom ist in Abb. 5 der gesamte Sperrstrom in Ab hängigkeit von der Diffusionslänge L_{ob} der Anreiche rungsschicht aufgetragen. Die Kurve zeigt den Verlauf bei einer willkürlich herausgegriffenen Sperrspannung von $U = -40 \,\mathrm{mV}$. Alle übrigen Bestimmungsgrößen sind die gleichen wie in Abb. 3 und 4 Mit zunehmender Diffusionslänge des Oberflächenstromes wird der Betrag des Sperrstromes kleiner Dieser Sachverhalt steht in Analogie zur konventio nellen Theorie des pn-Überganges. Von praktischer physikalischer Bedeutung ist jedoch, daß sich der Sperrstrom außerordentlich vergrößert, wenn die effektive Diffusionslänge in der Anreicherungsschicht wesentlich kleiner als im Kristallinneren wird. Es läßt sich also bei sonst gleichbleibenden Bedingungen ein möglichst kleiner Sperrstrom erzielen, indem man durch entsprechende Oberflächenbehandlung die Rekombinationsfähigkeit der Oberfläche wirksam herabsetzt und hierdurch die Diffusionslänge L_{ab} hinreichend groß macht.

Einfluß der Formierung auf den Diodenstrom

Bei der Herstellung von Spitzenkontaktgleichitern aus n-leitendem Germanium spielt während Formierens die Stärke und Zeitdauer des Stromnoulses eine wichtige Rolle. Der Einfluß des Formierrzesses auf die Struktur des Halbleiters in der Nähe Metallspitze hat verschiedene physikalische Fol-Von all diesen Effekten sind jedoch zwei hinitlich ihrer Wirkung auf die Diodenkennlinie von märer Bedeutung, nämlich die Erzeugung einer etiv hohen Leitfähigkeit vom p-Typ innerhalb der okugelförmigen Zone und die geometrische Größe es formierten Bereiches. Eine Änderung des dius r₁ durch verschieden starke Formierung belußt sowohl den Volumen- als auch den Oberhenstrom der Diode entsprechend der Zunahme der reiligen Austrittsflächen. In Abb. 6 ist der Oberihen-, Volumen- und Gesamtstrom für einen ver-Gerten Radius $r_1 = 50 \,\mu$ gegenüber $r_1 = 25 \,\mu$ in b. 3 dargestellt. Alle anderen Bestimmungsgrößen den nicht verändert. Der Volumensättigungsstrom a im Beispiel der Abb. 6 den Wert $I_{svol} = 0.16 \,\mu\text{A}$. der graphischen Darstellung ist beim Vergleich Abb. 3 ersichtlich, wie die beiden Stromanteile wachsendem r_1 zunehmen, so daß auch der Getstrom mit r_1 wächst. Wesentlicher noch als die erung der Größe des Diodenstromes ist jedoch, aus Abb. 3 und Abb. 6 zu ersehen, die Änderung Gestalt der Strom-Spannungskennlinie durch den Ifluß der Formierung auf die geometrische Struki des Spitzenkontaktes.

Analyse experimenteller Kurven

An Hand theoretisch ermittelter Strom-Spannungseilinien sollen jetzt experimentelle Kurven unternt werden, die an Spitzendioden gemessen wurden. Die standen die experimentellen Voraussetzungen linklang mit den Grundannahmen der in den Arein [1] bis [5] ausgeführten theoretischen Kon-

in Abb. 7 sind zunächst zwei gemessene Stromnnungskennlinien durch Meßpunkte dargestellt. berechnete Kurve für den Gesamtstrom I_{ges} ist ausgezogene Linie aufgetragen. Hierzu wurden ende Modellannahmen im Einklang mit den exmentell bekannten Daten gemacht: Dotierung ,=0,8 · 10¹⁵ cm⁻³, Diffusionslänge für den Volumennanteil $L_{vol} = 400 \,\mu$, äußerer Radius des n-leiren Kristalls $r_2 = 800 \,\mu$. Außerdem wurden zur nassung der theoretischen Kurve an die gemessenen efolgenden Bestimmungsgrößen für das Modell tihlt: Randfeldstärke $E_R = 0.8 \cdot 10^4 \text{ V/cm}$, diesem et entspricht bei Germanium eine elektrische ähenladungsdichte an der Kristalloberfläche von 10¹¹ Elementarladungen pro cm², was größendungsmäßig auch von anderen Autoren ermittelt ule [16]. Für die Anpassung der theoretischen onlinie an die gemessene wurde als effektive Difsnslänge des Oberflächenstromes in der Anreichepsschicht der Wert $L_{ob} = 320 \,\mu$ benutzt; dieser et ist kleiner als im Inneren des Kristalls, um den Tits erwähnten randnahen Verhältnissen Rechnung agen. Die Beweglichkeit der Ladungsträger in der wicherungsschicht wurde entsprechend den Schrief-Then Untersuchungen gegenüber dem Inneren um

 2 /₃ verringert [15]. Als Radius der Formierhalbkugel wurde $r_1 = 20 \,\mu$ angenommen. Dies stimmt mit den Ergebnissen von Thedieck [13] überein und ist außer-

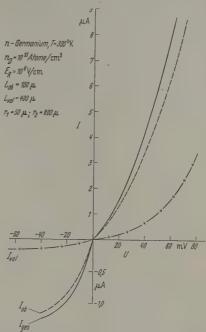


Abb. 6. Berechneter Volumen-Oberflächen- und Gesamtdiodenstrom in Abhängigkeit von der angelegten Spannung eines Spitzengleichrichters

dem durch unveröffentlichtes Erfahrungsmaterial, das den Verfassern freundlichst aus dem engeren Kollegenkreis zur Verfügung gestellt wurde, in befriedigender

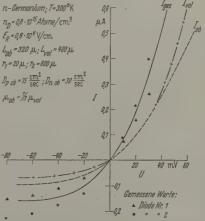
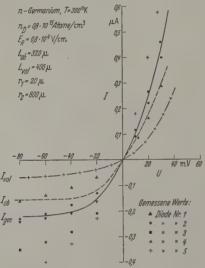


Abb. 7. Berechneter Volumen-Oberflächen- und Gesamtdiodenstrom in Abhängigkeit von der angelegten Spannung im Vergleich zu gemessenen Spitzengleichrichterkennlinien

Weise belegt. Außer der theoretischen Kurve für den Gesamtstrom sind in Abb. 7 die berechneten Kennlinien des zugehörigen Volumen- und Oberflächenstromes dargestellt.

Wie aus der graphischen Darstellung hervorgeht, ergibt sich im Durchlaßbereich, soweit die Messung durchgeführt wurde, und im Sperrbereich bis etwa 50 mV, eine befriedigende Übereinstimmung der theoretischen mit den gemessenen Kurven. Für größere Sperrspannungen weichen die theoretischen und experimentellen Kurven etwas voneinander ab. Der gemessene Strom nimmt dann stärker zu als der theoretisch ermittelte. Beneking [14] hat nachgewiesen, daß bei Berücksichtigung der Spannungsabhängigkeit der Sperrschichtdicke des halbkugelförmigen pn-Überganges der Sperrstrom mit wachsender Spannung steigt. In den der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden Berechnungen ist dieser Effekt des Volumenstromes aus Gründen der Vereinfachung des Modells nicht berücksichtigt worden. Es liegt



o. S. Berechneter Volumen-, Oberflächen- und Gesamtdiodenstrom in Abhängigkeit von der angelegten Spannung im Vergleich zu einem experimentellen Kennlinienfeld

jedoch nahe, für den zunehmenden Anstieg des Sperrstromes noch eine Reihe anderer physikalischer Gründe in Betracht zu ziehen. Beispielsweise ist es denkbar, daß die zunehmende äußere Sperrspannung die wirklichen Bedingungen an der Kristalloberfläche stärker modifiziert als es den verwendeten theoretischen Voraussetzungen des Modells entspricht und dadurch den Oberflächenstrom beeinflußt.

Es soll noch bemerkt werden, daß zur Angleichung der berechneten an die gemessenen Kurven bereits ein relativ kleiner Radius $r_1 = 20~\mu$ des formierten Halbkugelgebietes ausreicht. Würde man den gemessenen Gesamtstrom allein durch den Volumenstrom beschreiben, so müßten hierbei Werte r_1 von etwa 50 μ bis 100 μ verwendet werden.

Durch Berücksichtigung des Oberflächenstromes wird außerdem noch eine Schwierigkeit hinsichtlich der Temperatur des Spitzenkontaktes beseitigt. Die gemessenen Kurven liefern bei einer Beschreibung durch den Volumenstrom im Rahmen der Shockleyschen Theorie des pn-Überganges [s. Anhang Formel (7)], auch bei Berücksichtigung der Formfaktoren in der Arbeit [1] häufig einen zu kleinen Parameter $\alpha = q/kT$. Für die in Abb. 7 gemessenen Kurven 1 und 2 ergibt sich ohne Berücksichtigung des Oberflächenstromes ein Wert von $\alpha = 35$ bzw. 32 V⁻¹. Dies würde Temperaturen vortäuschen, die weit über

der Zimmertemperatur liegen. Bei 300 °K beträgt jedoch der Parameter α = 38.6 V⁻¹. Durch die Exi stenz des Oberflächenstromes werden diese physikalischen Schwierigkeiten beseitigt. In Abb. 7 wurde bei der Angleichung an die gemessenen Kurven für den Volumenstrom der Wert $\alpha = 38,6 \text{ V}^{-1}$ verwende entsprechend der wirklichen Temperatur (300°K des pn-Überganges. Eine den Werten $\alpha = 35$ bzw 32 V⁻¹ entsprechende Temperaturüberhöhung ist be den voriegenden physikalischen Verhältnissen im ge gebenen Spannungsbereich unmöglich.

Dieser gesamte Sachverhalt darf als ein entschei dendes Argument für die Existenz und den Einflu! des Oberflächenstromes auf die Strom-Spannungsver hältnisse formierter Spitzenkontaktgleichrichter an gesehen werden.

Vergleich der theoretischen Ergebnisse mit einer gemessenen Kennlinienschar

Bei dem bisherigen Vergleich zwischen theoreti schen und experimentellen Ergebnissen sind zur De monstration des Oberflächeneinflusses nur zwei ge messene Diodenkennlinien betrachtet worden. Jetz soll eine gemessene Kennlinienschar zur Analys herangezogen werden. Die hierbei verwendeten Spit zenkontaktgleichrichter sind alle aus dem gleiche Kristall mit einer Donatorenkonzentration von $0.8 \cdot 10^{15} \, \text{Atome/cm}^3 \, \text{hergestellt} \, (L_{vol} = 400 \, \mu)$, und si wurden von der Herstellung bis zur Messung in je der Hinsicht streng den gleichen äußeren Bedingunge ausgesetzt. Die Daten für den bei allen Exemplare unter gleichen Bedingungen ablaufenden Formier prozeß sind bereits oben mitgeteilt worden. Bemei kenswert ist, daß trotz dieser sorgfältig beachtete Gleichheit der äußeren Bedingungen keine der ge messenen Kennlinien in Strenge einer anderen gleich Dieser Sachverhalt demonstriert ein bekanntes Pha nomen, das für die Produktion von Halbleiterbauele menten von großer Bedeutung ist. Sowohl die phäne menologischen Zustandsgrößen, die den Herstellung prozeß des Bauelements kennzeichnen, als auch di physikalischen Bestimmungsgrößen des fertigen Exen plars reichen nicht aus, um die elektrischen Eiger schaften eindeutig zu definieren. Jeder Kristall un insbesondere jedes Halbleiterbauelement besitzt ein gewisse Individualität, die für differenziertere Zweck erst genau bestimmt werden muß und die vor aller durch Oberflächeneinflüsse hervorgerufen wird. Dies Einflüsse werden sich bei einem Exemplar um so stäl ker bemerkbar machen, je mehr der Mechanismus de Oberflächenstromes an der gesamten Strombilanz b teiligt ist. Bei Spitzenkontaktgleichrichtern spiel wie eingangs schon ausgeführt, infolge der geometr schen Anordnung der Oberflächenstrom im Vergleic zu anderen Arten von Bauelementen eine besonde entscheidende Rolle. Die Analyse der Kennlinie durch Vergleiche mit berechneten Strom-Spannung kurven läßt eine planmäßige Beeinflussung der Ken linienform durch entsprechende Wahl der wesentliche Bestimmungsgrößen in den Bereich der Möglichkeite

In Abb. 8 ist die gemessene Kennlinienschar da gestellt. Die Kurven sind nach den verwendete Dioden numeriert. Daß hier nur fünf Kennlinien au gezeichnet sind, hat nur den Grund besserer Ube sichtlichkeit. Die gewählten Kurven repräsentiere II. Band

ne größere Anzahl ähnlicher Kurven innerhalb des eichen Streubereiches. Zum Vergleich ist in die geessene Kurvenschar eine berechnete Kennlinie von eigneter Form aufgenommen worden, deren Bemmungsgrößen im Sinne einer Approximation ttelwerte der entsprechenden Parameter der geessenen Dioden darstellen. Diese theoretische Kennie wurde mit Ausnahme der Beweglichkeit der Langsträger mit den gleichen Daten wie in Abb. 7 Die Beweglichkeit der Ladungsträger rechnet. urde in Abb. 8 im Vergleich zu den Werten im Halbterinneren nicht geändert. Der Wert der Randfeldirke ist etwas kleiner als in den theoretischen Beiielen. Die Bedingungen der starken Inversion [3] ad jedoch erfüllt.

Aus dem Vergleich mit den oben bereits diskutiern theoretischen Kurven ist zu ersehen, daß der olumenstrom in Abb. 8 jetzt relativ mehr zum Gemtstrom beiträgt. Der Grund hierfür ist, daß inge der kleiner gewordenen elektrischen Flächenlungsdichte an der Halbleiteroberfläche der Beitrag s Oberflächenstromes in der Strombilanz geringer worden ist. Außerdem wächst der Volumenstrom t zunehmendem Radius r_1 stärker als der Oberchenstrom. Bemerkenswert ist ein charakteristiner Unterschied der Kennliniengestalt zwischen den eoretischen und gemessenen Kurven im Sperrbech. Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich darin, ß die elektrische Flächenladungsdichte auf der Halbteroberfläche in der Umgebung der Metallspitze rch die angelegte Spannung kontinuierlich modiiert wird. In der Arbeit [4] wurde gezeigt, daß eine erkliche Veränderung der elektrischen Oberflächenlegung erst bei Sperrspannungen größer als 50 mV erwarten ist. Die vorliegenden experimentellen ırven scheinen zu zeigen, daß die Steuerung des erflächenstromes im Sperrbereich durch Variation r Oberflächeneigenschaften bereits bei kleineren annungen einsetzt und kontinuierlich zunimmt, was rmutlich als eine wesentliche Ursache für das chasteristische Anwachsen des Sperrstromes anzunen ist. Der theoretische Kurvenverlauf wurde zuichst unter der Voraussetzung ermittelt, daß bei n hier vorliegenden äußeren Belastungen eine Modiation der Oberflächenverhältnisse infolge der anegten Spannung vernachlässigt werden kann. Der n Beneking [14] diskutierte Einfluß der spannungshängigen Ausdehnung der Inversionszone des forerten Halbkugelgebietes tendiert ebenfalls im Sinne s gemessenen Kurvenverlaufes. Ein möglicher Einß auf den Kennlinienverlauf durch eine Modifikation s Bahnwiderstandes des Volumenstromes infolge rker Trägerinjektion kommt in dem vorliegenden rom-Spannungsbereich im Vergleich zu den erhnten Oberflächeneffekten kaum in Betracht.

In Abb. 9 sind in das durch Meßpunkte angezeigte Innlinienfeld vier theoretische Strom-Spannungstinlinien des Gesamtstromes eingetragen. Der Verzich zwischen den theoretischen und gemessenen Grven zeigt, in welcher Weise die Streuung der gesenen Kennlinien durch Variation der verfügsen Parameter beispielsweise zustande kommen kann. Bi den gemessenen Kurven sind folgende Parameter cannt: n-Germanium mit einer Dotierung $n_D = 1.10^{15}$ Atome/cm³, $T = 300^{\circ}$ K, $L_{vol} = 400$ μ , $r_2 = 30$ μ . Diese Werte wurden auch in den theoretischen

Kennlinien zugrunde gelegt. Für die noch verfügbaren Parameter wurden die in Abb. 9 angegebenen, im Bereich der Erfahrung liegenden Annahmen gemacht.

Bei Kurve d wurde die Beweglichkeit der Ladungsträger in der Anreicherungsschicht der Oberfläche gegenüber a, b und c um $^2/_3$ des konventionellen Wertes bei Germanium vermindert. In den Kurven a, b und c wurde für die Beweglichkeit in der Anreicherungsschicht näherungsweise der konventionelle Wert des Halbleiterinneren verwendet. Eine Modifikation der Beweglichkeit bei gleichbleibender Diffusionslänge entspricht einer Änderung der mittleren Lebensdauer der Ladungsträger. Da in der Anreicherungsschicht

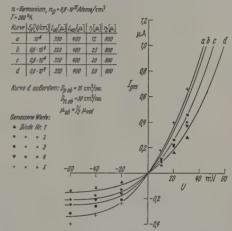


Abb. 9. Theoretische Kennlinien mit verschiedenen Parametern im Vergleich zu einem durch Meßpunkte dargestellten experimentellen Kennlinienfeld

gemäß Formel (11) des Anhanges neben dem Diffusionseffekt des Stromes auch ein Feldanteil eine wesentliche Rolle spielt, ist in dem betrachteten Beispiel der Einfluß der Beweglichkeit von Interesse.

Hinsichtlich des Einflusses der physikalischen Parameter auf die Kennlinien lassen sich allgemein folgende Gesetzmäßigkeiten erkennen. Der Oberflächenstrom und damit auch der Gesamtstrom wächst im Fluß- und Sperrgebiet, wenn die Randfeldstärke E_R bzw. die elektrische Flächenladungsdichte im unbelasteten Gleichgewichtszustand an der Oberfläche erhöht, oder der Radius r₁ vergrößert, oder die Oberflächendiffusionslänge in der Anreicherungsschicht L_{ob} verringert wird. Die übrigen Parameter sind hierbei festzuhalten. Eine Vergrößerung des Radius r_1 bedeutet gleichzeitig eine Zunahme des Volumenstromanteils. Eine Verringerung der Beweglichkeit in der Anreicherungsschicht der Oberfläche hat außerdem eine Verkleinerung der Oberflächenleitfähigkeit und somit auch des Oberflächenstromes zur Folge. Man sieht hieraus deutlich, wie sich der Einfluß der Oberflächenverhältnisse auf das gesamte elektrische Verhalten der Spitzenkristallgleichrichter bemerkbar macht.

In den vorliegenden Beispielen sind nur Oberflächenströme betrachtet worden, die sich auf Grund starker Inversion [3] ergeben. Entsprechende Betrachtungen lassen sich aber auch für den Fall schwacher Inversion [3] durchführen. Es ist sogar wahrscheinlich, daß bei Spitzendioden, die unter gleichen äußeren Bedingungen hergestellt wurden, beide Fälle und dazwischenliegende Übergänge vorkommen. So kann man beispielsweise in Abb. 9 die durch dreieckige Meßpunkte (Diode Nr. 1) angedeutete experi-

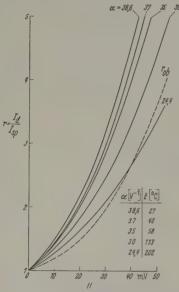


Abb. 10. Theoretische Richtverhältnisse als Funktion der Spannung bei verschiedenen Temperaturen. Ausgezogene Kurven für Volumenstrom, gestrichelte Kurven für Oberflächenstrom

mentelle Kurve unter Beibehaltung aller übrigen Halbleiterparameter durch die Existenz schwacher Inversion der Oberflächeninversionsschicht erklären.

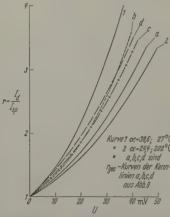


Abb. 11. Richtverhältnis in Abhängigkeit von der Spannung. Kurve 1 und 2 ohne, Kurve a, b, c und d mit Berücksichtigung des Oberflächenstromes

Zur Frage des Richtverhältnisses

Wird die Kennlinie eines Spitzenkristallgleichrichters ohne Berücksichtigung des Oberflächenstromes nur durch den über das formierte Halbkugelgebiet fließenden Volumenstrom erzeugt, so ist das von der Spannung U abhängige Richtverhältnis rim Rahmen der Shockleyschen Theorie durch den Parameter $\alpha = q/kT$ eindeutig bestimmt

$$r_{vol} = \frac{I_{dvol}}{I_{sp\ vol}} = e^{\alpha U}. \tag{1}$$

Im Anhang sind in Formel (7) bis (10) die hier einzu setzenden analytischen Ausdrücke für den Volumen Durchlaßstrom $I_{d\,vol}$ und den Volumen-Sperrstron $I_{sp\,vol}$ angegeben. Das Richtverhältnis variiert dem zufolge bei vorgegebener Spannung nur mit der Tem peratur. Dieser Sachverhalt ist in Abb. 10 dargestellt In Abhängigkeit von der Spannung U ist hier da Richtverhältnis bei verschiedenen a-Werten aufge tragen. Die den Parameterwerten a zugehörige Temperaturen sind jeweils bei den einzelnen Kurvel eingetragen. Mit abnehmendem a wächst die Tem peratur. Bei einer Zimmertemperatur von 27°C ha α den Wert 38,6. Die zugehörige Richtverhältnis kurve hat in diesem Fall, wo die Temperatur de Diode mit der Umgebungstemperatur übereinstimmt unter gewöhnlichen experimentellen Umständen der größten α-Wert und demzufolge die günstigste Richtverhältniswerte. Diese der Zimmertemperatu entsprechende Kurve begrenzt die Kurvenschar de Abb. 10 nach oben. Ermittelt man aus experimen tellen Kennlinien von Spitzenkristallgleichrichtern di zugehörigen Kurven des Richtverhältnisses und träg diese in die Kurvenschar der Abb. 10 ein, so zeig sich, daß die gemessenen Kennlinien α-Werte auf weisen, die zum Teil beträchtlich kleiner sind als 38,6 Den experimentellen Kennlinien müßten demzufolg Diodentemperaturen zugeordnet werden, die im all gemeinen wesentlich höher sind als die in Wirklich keit existierende Temperatur.

Bei den in der vorliegenden Arbeit verwendeter experimentellen Kurven sind die aus den abgelesener α-Werten entnommenen relativ hohen Temperature mit Sicherheit nicht mit den vorherrschenden Ver hältnissen geringer Belastungen zu vereinbaren H.A. Bethe erklärte die kleinen experimentellen a Werte durch eine Superposition von Kennlinien ein zelner Gleichrichterelemente [17]. Die den gemesse nen Kurven zugeordneten niederen α-Werte bzw. die entsprechenden Übertemperaturen werden offensicht lich durch einen zusätzlichen Effekt vorgetäuscht, de im Rahmen der für den Volumenstrom gültiger Theorie des pn-Überganges nicht explizit enthalten ist

Es läßt sich zeigen, daß sich bei Berücksichtigun des Oberflächenstromes diese Schwierigkeiten grund sätzlich nicht ergeben. Der in (1) nicht erfaßte Effek kann durch den Oberflächenstrom eine befriedigend Erklärung finden. In Abb. 10 ist in die Kurvenscha eine gestrichelte Kurve eingezeichnet. Diese kan näherungsweise mit einer Kurve der Schar verglicher werden, der gemäß (1) eine Temperatur von 202° (zugeordnet werden müßte. Diese gestrichelte Kurv beschreibt den Verlauf des Richtverhältnisses eine Kennlinie des Oberflächenstromes, die mit plausible physikalischen Größen nach der im Anhang angege benen Formel (11) der Kennlinie des Oberflächen stromes berechnet wurde. Wesentlich hierbei ist, dal dieser gestichelten Kurve nicht eine scheinbare Tem peratur von 202° C, sondern eine den wirklichen Ver hältnissen entsprechende von 27°C zuzuschreiben ist Dieses Beispiel zeigt wieder, das experimentelle Strom-Spannungskennlinien sich grundsätzlich durch einen Beitrag des Oberflächenstromes zum Gesamt strom der Spitzendiode beschreiben lassen.

In Abb. 11 wird nunmehr gezeigt, daß der Verlau empirischer Kennlinien in Wirklichkeit nicht au einer Übertemperatur, sondern auf einer Gesamthei iglicher Mischungen von Volumen- und Oberchenströmen beruht. Die Kurven 1 und 2 stellen n Verlauf von Richtverhältnissen mit der Spannung mäß Formel (1) dar. Die Kurve 1 hat einen α-Wert n 38,6, was einer Temperatur von 300° K entspricht. hrend bei Kurve 2 der Parameter a den Wert 24.4 sitzt. (Dies würde eine scheinbare Diodentemperavon 474° K bedeuten.) Zwischen diesen beiden rven 1 und 2 sind Richtverhältniskurven a. b. c d d aufgetragen, die den entsprechend bezeichneten nnlinien der Abb. 9 zugehörig sind. Hierbei hant es sich um theoretisch berechnete Kennlinien mit er Diodentemperatur T=300° K, die gemäß dem en erläuterten Modell aus Volumen- und Oberchenstromanteilen resultieren. Nach Abb. 9 bereiben diese theoretischen Kennlinien in befriedinder Weise eine Schar von gemessenen Stromannungscharakteristiken. Wenn die theoretischen nnlinien mit bestimmten physikalischen Bestimngsgrößen, die weitgehend mit der Erfahrung über

Halbleiteroberfläche in Einklang sind, eine gute passung an den gemessenen Kennlinienverlauf ersen, so darf man annehmen, daß diese Bestimmungsßen den wirklichen Verhältnissen in ausreichender herung entsprechen werden. In diesem Sinne resentieren die theoretischen Kurven a, b, c und d vohl in Abb. 9 als auch in Abb. 11 einen realen wiskalischen Sachverhalt, der mit dem Experiment tgehend übereinstimmt.

Es sei an dieser Stelle bemerkt, daß der über den bkugelförmigen pn-Übergang fließende Volumenom bei Berücksichtigung der Rekombination und arbildung im Inneren der raumladungsbehafteten ergangszone durch einen Rekombinationsstrom größert wird. Bei dem von uns zugrunde gelegten dell gemäß Abb. 2 wurde dieser möglicherweise voredene Anteil des Volumenstromes in Gestalt eines tätzlichen Rekombinationsstromes absichtlich nicht Betracht gezogen. Hierfür waren mehrere Gründe schlaggebend. Erstens ist die durch einen Renbinationsstromanteil bedingte Vergrößerung des umenstromes relativ klein und erreicht den Fak-2 im allgemeinen nicht, während der Oberflächenpmanteil jedoch, wie Abb. 3, 4 und 6 zeigen, ein ar- oder Vielfaches des mit r_1 bestimmten Volumenmes sein kann. Zweitens sind praktisch die Paraer des Rekombinationsmechanismus in der Übergszone des halbkugelförmigen pn-Überganges bei klichen Dioden nicht bekannt, so daß man die I freier, unbekannter Parameter des Modells hierch vergrößern würde. Der entscheidende Grund die Vernachlässigung modifizierender Nebenkte ist jedoch die Tatsache, daß insbesondere bei zenkontaktgleichrichtern der Oberflächenstrom experimentell bewiesene Realität besitzt und die dichen physikalischen Verhältnisse in den wesenten Grundzügen richtig beschreibt.

Es ist im Prinzip möglich, bei einer gemessenen mu-Spannungskennlinie den Anteil des Oberieenstromes vom Volumenstrom zu separieren das Verhältnis dieser beiden Anteile zu bestimet. Eine Kenntnis der die Struktur der Oberieninversionsschicht bestimmenden Parameter ist bei allerdings erforderlich. Zum Verständnis der ilieser Frage wesentlichen Gesetzmäßigkeiten gehen rlavon aus, daß der in Abhängigkeit von der Span-

nung gemessene Gesamtstrom der Spitzendiode aus einer Superposition von Volumen- und Oberflächenstrom resultiert. Für den Durchlaß- und Sperrfall gilt somit

$$I_{dges} = I_{dvol} + I_{dob},$$
 (2a)

$$I_{sp \, ges} = I_{sp \, vol} + I_{sp \, ob}$$
. (2b)

Hieraus ergibt sich das Richtverhältnis des Gesamtstromes

$$r_{ges} = \frac{I_{dges}}{I_{spges}} = \frac{I_{dvol}}{I_{spges}} + \frac{I_{dob}}{I_{spges}}.$$
 (3)

Führt man auf der rechten Seite der Gl. (3) im Nenner den Ausdruck (2b) ein, so kann man (3) auch in der Form schreiben

$$r_{ges} = a \, r_{vol} + (1 - a) \, r_{ob},$$
 (4)

wobei r_{vol} und r_{ob} jeweils die Richtverhältnisse des Volumenstromes und des Oberflächenstromes sind

$$r_{vol} = \frac{I_{dvol}}{I_{sp\ vol}}; \quad r_{ob} = \frac{I_{dob}}{I_{sp\ ob}} \tag{5}$$

und sich der Faktor a bzw. (1-a) wie folgt berechnet

$$a = \frac{1}{1 + \frac{I_{sp ob}}{I_{sp vol}}}; \quad (1 - a) = \frac{1}{1 + \frac{I_{sp vol}}{I_{sp ob}}}. \quad (6)$$

Das Richtverhältnis des Gesamtstromes ergibt sich demzufolge gemäß (4) aus den beiden Richtverhältnissen des Volumenstromes r_{vol} und des Oberflächenstromes r_{ob} sowie aus dem Mischfaktor a, der eine Funktion (6) des Quotienten des Oberflächenstromes zum Volumenstrom im Sperrbereich ist. Nach unserem Modell des Spitzenkontaktgleichrichters Abb. 2 fließt der Volumenstrom über den halbkugelförmigen pn-Übergang. Das Richtverhältnis r_{vol} des Volumenstromes ist deshalb gemäß Formel (1) durch den Parameter α bzw. durch die Temperatur eindeutig bestimmt und hängt nicht von den physikalischen Bestimmungsgrößen des halbkugelförmigen pn-Überganges ab. Bei dem Richtverhältnis rob des Oberflächenstromes ist dies jedoch anders. Der Kürze halber sei hier lediglich als Ergebnis mitgeteilt, was sich an den berechneten Kennlinien des Oberflächenstromes verifizieren läßt. Das Richtverhältnis r_{ob} wird von dem Verhältnis r_1/L des Radius r_1 zur effektiven Diffusionslänge L in der Anreicherungsschicht der Oberfläche nur schwach modifiziert. Das Richtverhältnis r_{ob} wird jedoch bestimmt durch die Temperatur T, durch die Dotierung des Halbleiters n_D , die elektrische Oberflächenbelegung, d.h. durch die Randfeldstärke \boldsymbol{E}_R und durch die effektive Beweglichkeit in der Anreicherungsschicht.

Wenn die elektrische Oberflächenladungsdichte für die Halbleiteroberfläche des verwendeten Materials bekannt ist, so läßt sich bei vorgegebener Temperatur und Dotierung sowie bei Veranschlagung einer effektiven Beweglichkeit gemäß Gl. (4) das Richtverhältnis des Gesamtstromes in die Richtverhältnisanteile des Volumen- und Oberflächenstromes zerlegen und als Funktion der Spannung angeben. Als charakteristischer Parameter tritt hierbei der Mischfaktor a in (4) auf, der durch (6) definiert ist. Dieser Sachverhalt ist in Abb. 12 demonstriert. Es wurden als Beispiel folgende, im Bereich der Erfahrung konventionelle

Bestimmungsgrößen gewählt: n-leitendes Germanium mit einer Dotierungskonzentration $n_D=10^{15}$ Atome/cm³, Randfeldstärke $E_R=10^4$ V/cm entsprechend einer

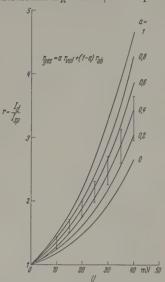


Abb. 12. Richtverhältnisse in Abhängigkeit von der Spannung für verschiedengroße Anteile des Oberflächenstromes am Gesamtdiodenstrom

Oberflächenladungsdichte von 10¹¹ Elementarladungen pro cm², die effektive Beweglichkeit der Ladungsträger in der Anreicherungsschicht näherungsweise



Abb. 13. Mischfaktor a in Abhängigkeit vom Verhältnis des Oberflächen- zum Volumenstrom

von gleicher Größe wie im Inneren des Germaniums, Temperatur $T = 300^{\circ}$ K. Die beispielsweise mit diesen Werten bestimmten Richtverhältnisse r_{vol} und r_{ob} wurden in Abb. 12 gemäß (4) zur Konstruktion des Gesamtrichtverhältnisses als Funktion der Spannung bei verschiedenen Mischfaktoren a als Scharparameter verwendet. Aus dem Diagramm der Abb. 13 kann nach (6) für jeden vorkommenden Wert a das entsprechende Verhältnis zwischen Oberflächen- und Volumenstrom abgelesen werden. Die in die Kurvenschar der Abb. 12 eingezeichneten senkrechten Striche kennzeichnen einen Bereich, der den Verlauf der Richtver-

hältniskurven beinhaltet, die den in Abb. 9 dargestellten, gemessenen sowie theoretisch beschriebenen Kennlinien entsprechen. Die der Kurvenschar der Abb. 12 zugrunde liegenden physikalischen Bestimmungsgrößen sind zahlenmäßig in Einklang mit den physikalischen Verhältnissen der Kennlinien in Abb. 9. Deshalb lassen sich mit Hilfe des Diagramms der Abb. 13 die Mischverhältnisse der Stromanteile für diese empirischen Kennlinien ablesen, nachdem aus Abb. 12 die a-Werte ermittelt wurden. Aus der Abb. 12

läßt sich erkennen, daß für die empirischen Kurve der Abb. 9 der mittlere Wert des Mischfaktors a m wachsender Spannung abnimmt. Bei relativ kleine Spannungen des Diagramms (10 mV) liegt der We von a zwischen 0,2 und 0,8, während er bei 40 m zwischen 0,2 und 0,4 liegt. Wenn diesen Zahlenwerte auch keine allgemeine Bedeutung zukommt, so i doch der hierin zum Ausdruck kommende Sachverha von grundsätzlichem Interesse, daß bei einer wirkliche Diode das Mischverhältnis zwischen Oberflächen- ur Volumenstrom mit der Spannung veränderlich se kann. Diese Änderung deutet darauf hin, daß m der Spannung unabhängig vorgegebene Parameter d Kristalls oder der Oberfläche modifiziert werden, w in der theoretischen Konzeption in erster Näherung vernachlässigt wurde. Die Richtverhältniskurve stel definitionsgemäß eine reduzierte Kennlinie dar. Ein Variation des Parameters a mit der Spannung b deutet, daß der physikalische Einfluß des Oberfläche stromes auf die elektrischen Eigenschaften der Dioc in Fluß- und Sperrichtung unterschiedlich ist. De Beispiel zeigt, daß sich die Bestimmungsgrößen d Oberflächeninversionsschicht im Fluß-und Sperrbereic im allgemeinen verschieden auf die Gestalt der Ken linie auswirken können.

Bei den hier verwendeten gemessenen Kennlinie der Abb. 9 haben wir das Verhältnis zwischen Obe flächen- und Volumenstrom bereits weiter oben b der Anpassung der berechneten Kennlinien an d empirischen festgestellt. In Abb. 12 und 13 wird j doch unabhängig von diesem Umstand in Allgemei heit eine Methode gezeigt, nach der im Prinzip ein Analyse empirischer Kennlinien durchgeführt werde kann, wenn die notwendigen oben angegebenen B stimmungsgrößen des Halbleiters und seiner Obe fläche bekannt sind. In Verbindung mit einer B stimmung dieser physikalischen Parameter durch andere Meßmethoden könnte im Prinzip auf eine solc Weise umgekehrt aus dem Verhältnis zwischen Obe flächen- und Volumenstrom der Einfluß eines b stimmten Oberflächenparameters auf das elektrisch Verhalten der Diode ermittelt werden.

Anhang

Die in der vorliegenden Untersuchung verwendete theoretischen Ergebnisse sind in den Arbeiten [1] b [5] ausführlich mitgeteilt und diskutiert worden. Zu Zwecke einer besseren Übersicht soll im folgenden ein kurze Zusammenstellung der in der vorliegenden A beit benötigten Formeln gegeben werden.

Volumenstrom [1]:

$$I_{vol} = 2 \pi r_1^2 i_{s \, vol} (e^{\frac{q}{kT} U} - 1)$$

mit der Sättigungsstromdichte:

$$i_{s\,vol} = q\left(rac{D_n\,n_p}{L_{n\,vol}}\,K_n + rac{D_p\,p_n}{L_{p\,vol}}\,K_p
ight)$$

und mit den Formfaktoren [1]:

$$\begin{split} K_n = \frac{1}{r_1/L_{nvol}} \cdot \frac{\left(\frac{r_1}{L_{nvol}} - 1\right) \exp\left[\frac{r_1}{L_{nvol}} \left(1 - \frac{2r_0}{r_1}\right)\right] +}{\exp\left[\frac{r_1}{L_{nvol}} \left(1 - \frac{2r_0}{r_1}\right)\right] -}\\ + \left(\frac{r_1}{L_{nvol}} + 1\right) \exp\left[-\frac{r_1}{L_{nvol}}\right]\\ - \exp\left[-\frac{r_1}{L_{nvol}}\right] \end{split}, \end{split}$$

Oberflächenstrom [2] und [4]: (Der Index (1) berutet Abhängigkeit vom äußeren Potential $\varphi_{(1)} = \frac{qU}{kT}$ n der Stelle $r = r_1$)*.

$$\lambda_{b} = 2\pi q \, x_{(1)}^{**} \left(\frac{\partial \delta \overline{p}}{\partial r} \, r \right)_{(1)} \times \left\{ \left[\mu_{p} \overline{p}_{0} + (\mu_{n} + \mu_{p}) \, \delta \overline{p}_{(1)} \right] \left(-\frac{\partial U}{\partial \delta \overline{p}} \right)_{(1)} + \right. \\
\left. + (D_{n} - D_{p}) \right\}. \tag{11}$$

1 (11) ist die Dicke der Anreicherungsschicht [3]:

$$x_{(1)}^{*'} = \frac{1}{\sqrt{K_{1(1)}^{*}}} \ln \left[\frac{1}{Y_{(1)}} \left\{ (1 + K_{1(1)}^{*} L_{D_{n}}^{2}) + + L_{D_{n}} \sqrt{K_{1(1)}^{*} L_{D_{n}}^{2} + 2 K_{1(1)}^{*}} \right\} \right]$$
(12)

it den Strukturparametern [3]:

$$K_{1(1)}^* = \frac{2}{L_{D_-}^2} \left(2 \ln \frac{n_D}{n_{(1)}^*} - 1 \right),$$
 (13)

$$K_{2(1)}^* = Y_{(1)} = \frac{\left(\frac{du}{dx}\right)_{R(1)}^* L_{D_n} + \sqrt{2} \sqrt{2 \ln \frac{n_D}{n_{(1)}^*} - 1}}{\left(\frac{du}{dx}\right)_{R(1)}^* L_{D_n} - \sqrt{2} \sqrt{2 \ln \frac{n_D}{n_{(1)}^*} - 1}} \cdot (14)$$

ler Einfluß des äußeren Potentials $\varphi_{(1)} = \frac{qU}{kT}$ geht urch die Transformation [3]

$$n_{(1)}^* = n_i \exp\left[-\frac{\varphi_{(1)}}{2}\right]$$
 (15)

die Formeln (12) bis (14) und (16) bis (22) ein. In (1) ist ferner, [2] und [4]:

$$= \frac{r_{1}}{L_{ob}} \left\{ \Phi_{1} \frac{\left(-iI_{1}\left(i\frac{r_{1}}{L_{ob}}\right)\right)}{I_{0}\left(i\frac{r_{1}}{L_{ob}}\right)} + \Phi_{2} \frac{H_{1}^{(1)}\left(i\frac{r_{1}}{L_{ob}}\right)}{iH_{0}^{(1)}\left(i\frac{r_{1}}{L_{ob}}\right)} \right\} \right\}$$
(16)

rit den Formfaktoren [2] und [4]:

$$\begin{split} \varPhi_{1} = & \frac{\delta \, \overline{p}_{(1)}}{1 - \frac{I_{0} \left(i \, \frac{r_{2}}{L_{0b}} \right) \, i \, H_{0}^{(1)} \left(i \, \frac{r_{1}}{L_{0b}} \right)}{I_{0} \left(i \, \frac{r_{1}}{L_{0b}} \right) \, i \, H_{0}^{(1)} \left(i \, \frac{r_{2}}{L_{0b}} \right)}} \,, \end{split} \tag{17}$$

$$\Phi_{2} = \frac{\delta \overline{p}_{(1)}}{1 - \frac{I_{0} \left(i \frac{r_{1}}{L_{0b}}\right) i H_{0}^{(1)} \left(i \frac{r_{2}}{L_{0b}}\right)}{I_{0} \left(i \frac{r_{2}}{L_{0b}}\right) i H_{0}^{(1)} \left(i \frac{r_{1}}{L_{0b}}\right)}}$$
(18)

und dem spannungsabhängigen Randwert der Variation der mittleren Trägerdichte der Anreicherungsschicht bei $r = r_1$ [3]:

$$\delta \bar{p}_{(1)} = n_D L_{Dn}^2 \{ K_{1(1)}^* B_{(1)}^* - K_1 B \}. \tag{19}$$

Außerdem gilt in (11) für den positiven reziproken Wert der Ableitung der Variation der mittleren Trägerdichte nach der Spannung [3]:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial \delta \overline{p}}\right)_{(1)} = \frac{1}{n_D L_{Dn}^2} \left\{ K_{1(1)}^{**} B_{(1)}^* + K_{1(1)}^* B_{(1)}^{**}' \right\}^{-1}. (20)$$

In (20) bedeuten die gestrichenen Größen in der geschweiften Klammer Ableitungen nach der Spannung gemäß Formel (15). Es ist [3]:

$$B_{(1)}^* = \frac{\coth\left(\frac{1}{8}\ln Y_{(1)}\right) - \coth\left(\frac{1}{2}\ln A_{(1)}^* + \frac{1}{2}\ln Y_{(1)}\right)}{\ln A_{(1)}^*}\,, \tag{21}$$

$$A_{(1)}^* = \frac{1}{Y_{(1)}} \left\{ (1 + K_{1(1)}^* L_{D_n}^2) + L_{D_n} \sqrt{K_{1(1)}^* L_{D_n}^2 + 2 K_{1(1)}^*} \right\}. (22)$$

Der Aufbau der Kennlinien des Oberflächenstromes und die hierbei zugrunde liegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten wurden in den beiden Arbeiten [4] ausführlich diskutiert.

Zusammenfassung

Es werden experimentelle Ergebnisse über die elektrischen Eigenschaften von formierten Spitzenkontaktgleichrichtern mitgeteilt, die unter genau definierten Bedingungen hergestellt und gemessen worden sind. An Hand der theoretischen Ergebnisse in vorausgegangenen Arbeiten [1] bis [5] lassen sich die gemessenen Strom-Spannungskennlinien analysieren. Hierdurch konnte insbesondere der Einfluß der Halbleiteroberfläche und der Geometrie des formierten Bereiches auf den Gleichrichtereffekt quantitativ untersucht werden. Es zeigt sich, daß bei Spitzenkontaktgleichrichtern der Oberflächenstrom eine dominierende Rolle spielt und sowohl die Größe des Diodenstromes als auch die Gestalt der Kennlinien entscheidend bestimmt. Bei Berücksichtigung des Oberflächenstromes werden die gemessenen Kurven befriedigend durch die Theorie beschrieben. Man erhält aus dem Vergleich zwischen den experimentellen und den theoretischen Kennlinien eine genauere Kenntnis des vielschichtigen Problemkreises der physikalischen Verhältnisse bei Spitzenkontaktgleichrichtern. In der vorliegenden Arbeit werden zunächst nur die Verhältnisse bei relativ kleinen Gleichspannungen untersucht, damit der Einfluß der Oberflächeneffekte nicht durch Nebenerscheinungen überdeckt wird.

Wir danken Herrn Dipl.-Phys. H. EGER für seine wertvolle Mitarbeit bei den experimentellen Vorbereitungen und bei der Durchführung zahlreicher Messungen.

Literatur: [1] Hofmeister, E., u. E. Groschwitz: Z. angew. Phys. 10, 109 (1958). — [2] Groschwitz, E.: Solid State Physics in Electronics a. Telecommunications published by Academic Press Inc. (London) Ltd. S. 575 (1960). — [3] Groschwitz, E., u. R. Ebhardt: Z. angew. Phys. 11, 99 (1959). — [4] Groschwitz, E., u. R. Ebhardt: Z. angew. Phys. 11, 296 (1959). — Groschwitz, E., E. Hofmeister u. R. Ebhardt: Z. angew. Phys. 12, 544 (1960). — [5] Groschwitz, E., u. R. Ebhardt: Z. angew. Phys. 11,342 (1959). — Groschwitz, E., E. Hofmeister u. R. Ebhardt: Zur Physik der Spitzenkontaktgleichrichter. Vortrag auf der Physikertag. in Berlin, 29. Sept. bis 3. Okt. 1959. — [6] Bardeen,

^{*} In der Arbeit [4] ist in Formel (12) bei der Korrektur er Schreibfehler unbemerkt geblieben. Im zweiten Glied 1:6 in der Klammer vor $1/\tau_p$ an Stelle des positiven ein zatives Vorzeichen stehen.

J., and W.H. Brattain: Phys. Rev.75, 1208 (1949). — [7] AIGRAIN, P.: Ann. Phys. 7, 140 (1952). — [8] Brown, W. L.: Phys. Rev. 91, 518 (1953). — [9] Christensen, H.: Phys. Rev. 98, 1766 (1955). — [10] McWhorter, A. L., and R. H. Kingston: Proc. Inst. Radio Engrs., N.Y. 42, 1376 (1954). — [11] De Mars, G. A., H. Statz and I. Davis: Phys. Rev. 98, 539 (1955). — [12] Cutler, M., and H. M. Bath: Proc. Inst. Radio Engrs., N.Y. 45, 39 (1957). — [13] Thedieck, R.: Z. angew. Phys. 5, 163 (1953); 5, 165 (1953). — [14] Beneking, H.: Z. angew. Phys. 9, 626 (1957);

10, 216 (1958). - [15] SCHRIEFFER, J.R.: Phys. Rev. 97, (1955). - [16] STATZ, H., G.A. DE MARS jr. and A. ADAMS j Reitrag in Semiconductor Surface Physics, edit. by R.H. Kingston. Philadelphia: University Pennsylvania Pres 1957. — [17] Bethe, H.A.: RL Report No. 43—12, Nov. 23, 1942.

Dipl.-Ing. R. EBHARDT, Dr. E. HOFMEISTER und Dr. E. GROSCHWITZ. Wernerwerk für Bauelemente der Siemens & Halske AG., München

Die ideale Magnetisierungskurve von Ferriten mit unterschiedlicher Magnetisierungsschleife

Von M. Kornetzki und E. Röss

Mit 11 Textabbildungen

(Eingegangen am 19. August 1960)

Überlagert man beim Messen der Magnetisierungskurve dem jeweils eingestellten Gleichfeld ein Wechselfeld, dessen Amplitude von einem großen Anfangswert stetig auf Null abnimmt, so stellt die sich ergebende Induktion als Funktion des Gleichfeldes die ideale Magnetisierungskurve [1] des betreffenden Stoffes dar. Sie ist hysteresefrei und daher unabhängig von der magnetischen Vorgeschichte des Stoffes. Früher wurde angenommen, daß die ideale Kurve ungescherter Stoffe bei der Gleichfeldstärke Null senkrecht verläuft [2], [3]. Allerdings wurden auch endliche Steigungen beobachtet [3], [4]. Diese hat man — soweit sie gedeutet wurden - einer inneren Scherung des betreffenden Stoffes zugeschrieben. Im folgenden wird die ideale Kurve aus dem Preisach-Diagramm abgeleitet und gezeigt,

daß die Kurve auch ohne vorhandene Scherung normalerweise eine endliche Steigung hat. Die Preisach-Diagramme und die idealen Kurven einiger Ferrite mit Rechteck-, Normal-, Isoperm- und Perminvarschleife werden mitgeteilt.

A Hm Abb. 1. Vereinfachtes Schema einer Preisach-Ebene

Verlauf der idealen Kurve

Die Besetzungsdichte eines Preisach-Diagrammes [5], [6] sei $\gamma(H_b, H_m)$, wobei H_b die Koerzitivfeldstärke, H_m die Vormagnetisierung der Elementarschleifen bezeichnet (Abb. 1). Die (zur H_h -Achse symmetrische) Grenze der besetzten Fläche sei ACD. Die

Induktion B bei einer kleinen Feldstärke H besteht aus dem reversiblen¹ und dem irreversiblen Anteil; letzterer wird beschrieben durch das Umklappen der in dem Dreieck OEF enthaltenen Magnetisierung².

Somit gilt für die Neukurve

$$egin{aligned} B_{ ext{Neu}} &= \mu_a H + \iint\limits_{ ext{OEF}} \gamma \, dH_b \, dH_m \ &= \mu_a H + 2 \nu H^2 \end{aligned}
brace$$

 $(\mu_a$ Anfangspermeabilität, ν Rayleighsche Konstante). ν ist unabhängig von H, solange γ konstant ist oder wenigstens das Flächenintegral quadratisch mit H steigt.

Überlagert man nun dem Gleichfeld ein großes Wechselfeld und läßt die Amplitude stetig gegen Null gehen, so verbleibt der (nahezu rechteckförmige Streifen OEGC ummagnetisiert [6]. Die reversible Magnetisierung wird bei kleiner Feldstärke näherungs weise unabhängig von der magnetischen Vorgeschichte sein. Also beträgt die ideale Induktion

$$B_{
m Ideal} pprox \mu_a H + \iint\limits_{
m OEGC} \gamma \, dH_b \, dH_m \ pprox \mu_a H + i H,$$
 (2)

Da die Fläche OEGC bei kleiner Feldstärke etwa linear mit H wächst, ist i nahezu eine Konstante, wenn γ konstant ist oder in erster Näherung nur von H_b abhängt oder wenigstens das Flächenintegral linear mit H steigt. Dann wächst die ideale Induktion näherungsweise linear mit H, während die Neukurve [nach Gl. (1)] von Anfang an ein quadratisches Glied enthält.

Im einfachsten Fall konstanter Besetzungsdichte y (innerhalb der Randlinie) verlaufen die ideale und die Neukurve etwa wie in Abb. 2 (Anfangssteigung µldeal bzw. μ_a). Das Verhältnis zwischen dem irreversiblen Anteil AD auf der idealen Kurve und dem auf der Neukurve AC ist dann gleich dem Verhältnis der Fläche des (angenäherten) Rechtecks OEGC zur Fläche des Dreiecks OEF. Je geringer die irreversible Induktion im Verhältnis zur reversiblen Induktion ist, um so mehr nähert sich die ideale Kurve der Neukurve (s. die Abschätzung von $B_{\text{ideal}}/B_{\text{Neu}}$ im Anhang).

Da die Ummagnetisierungsfront EG mit wachsender Feldstärke H eher die gesamte Fläche innerhalb der Randlinie ACD überstreicht als die Front EF, mündet die ideale Kurve eher in die Sättigung ein als die Neukurve.

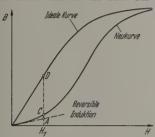
Nach den Untersuchungen von H. WILDE und H. GIRKE [7] ist die Preisach-Ebene nicht gleichförmig besetzt. Die Besetzungsdichte ist aber normalerweise endlich, und deshalb kann die ideale Kurve

¹ Siehe dazu die Untersuchungen von H. WILDE [6].

² Unter dem folgenden Integral [Gl. (1)] müßte an sich 2γ stehen, um den Richtungswechsel der Magnetisierung von – nach + zu berücksichtigen. In den folgenden Preisach-Diagrammen ist aber γ bereits so definiert, daß eine Integration über die gesamte Fläche des Diagramms die doppelte irreversible Induktion liefert. Auch eine Multiplikation mit $2B_8$, wie sie bei den von WILDE und GIRKE [7] mitgeteilten Diagrammen erforderlich ist, fällt hier weg.

eht unendlich steil ansteigen. Nur Stoffe, deren gnetisierungsschleife große Barkhausen-Sprünge thält, können in gleichem Ausmaß unendlich steile ücke der idealen Magnetisierungskurve aufweisen. diesem Fall ist die Preiach-Ebene nicht stetig bezt, sondern enthält diskrete Punkte. Dasselbe gilt sehr kleine Kerne, die nur noch wenige Weißsche zirke enthalten.

Eine endliche Anfangssteigung der idealen Kurve nn daher nicht einfach als Maß für eine innere

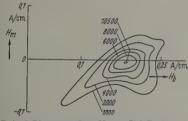


2. Verlauf der idealen Magnetisierungskurve und der Neukurve (schematisch)

herung des betreffenden Stoffes gelten. Sofern aber e (innere oder äußere) Scherung vorliegt, wird die gliche Steigung auf den Wert 1/N begrenzt (N =herungsfaktor)1.

Meßergebnisse

Die im folgenden gezeigten idealen Magnetisiengskurven wurden an Ringkernen mittels eines exmeters gemessen; für die Idealisierung wurde ein



Preisach-Diagramm eines Mangan-Zink-Ferrits mit rechteckger Magnetisierungsschleife ($\mu_a=1500$). Parameter ist die Besetzungsdichte in $10^{-6}~{\rm Vs/A^2}$

echselstrom von 1 Hz verwendet. Die Preisachagramme wurden freundlicherweise von den Herren GIRKE und D. STOLL im Institut für Nachrichtenhnik der Technischen Hochschule Stuttgart auf-

Je ein Mangan-Zink-Ferrit mit Rechteck-, Normald Isopermschleife, jedoch mit etwa gleicher Koervfeldstärke [8], wurde untersucht, ferner ein kobalttiges Nickel-Zink-Ferrit² mit Perminvarschleife [9]. Stoffe mit Rechteckschleife sind stark hystereseaftet, und das Preisach-Diagramm (Abb. 3) ist ne der H_h -Achse bei Feldstärken etwa vom Betrage Koerzitivfeldstärke sehr dicht besetzt³. Deshalb

ymmetrie s. H. WILDE und H. GIRKE [7].

steigt die ideale Kurve (Abb. 4) viel steiler an als die Neukurve ($\mu_{\text{ideal}} = 55000, \mu_a = 1500, \mu_{\text{ideal}} / \mu_a = 37$); sie erreicht auch wesentlich früher die Sättigung. Anisotrope Ferrite mit (induzierter) Rechteckschleife, z.B. feldgetemperte Perminvare, deren Schleife viel schärfere Ecken aufweist, werden sicher ein noch wesentlich größeres Verhältnis μ_{ideal}/μ_{α} haben.

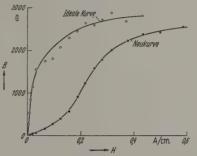


Abb. 4. Ideale Magnetisierungskurve und Neukurve des Ferrits nach

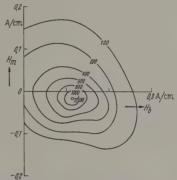


Abb. 5. Preisach-Diagramm eines Mangan-Zink-Ferrits mit normaler Magnetisierungsschleife ($\mu_a=2800$). Parameter wie in Abb. 3

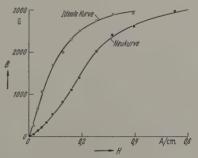


Abb. 6. Ideale Magnetisierungskurve und Neukurve des Ferrits nach Abb. 5

Die Preisach-Ebene von Ferriten mit normaler Schleife ist viel gleichförmiger besetzt (Abb. 5). Daher liegt die ideale Kurve näher an der Neukurve (μ_{ideal} = 17000, $\mu_a = 2800$, $\mu_{\text{ideal}}/\mu_a = 6.1$) (Abb. 6).

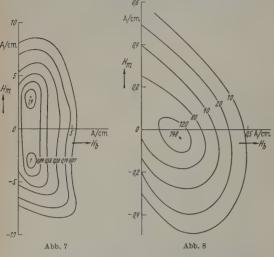
So wie es Ferrite mit induzierter und mit spontaner Rechteckschleife gibt, kennt man auch Ferrite mit induzierter und mit spontaner Isopermschleife. Im ersten Fall handelt es sich um Kerne mit eingeprägter Anisotropie, z.B. im Querfeld getemperte Perminvare [9], im zweiten Fall um hochpermeable Mangan-Zink-Ferrite mit bestimmter Zusammensetzung [8]. Beide

¹ In kleinen Stufen kann allerdings die Steigung auch hier rschritten werden, nämlich wenn einmal gestartete Barksen-Sprünge bei verminderter Feldstärke weiterlaufen. ² Die Perminvarschleife der kobalthaltigen Ni-Zn-Ferrite

stabiler als die der Mn-Zn-Ferrite und wird deshalb durch hier notwendigen großen Felder weniger gestört [10]. ³ Über die Ursache der in den Diagrammen auffallenden

Stoffe sind verhältnismäßig hysteresearm, haben aber verschiedenartige Preisach-Diagramme. Induziertes Isoperm zeigt eine in Richtung der $\pm H_m$ -Achse langgezogene Besetzung ohne Häufungsstelle auf der H_b -Achse (Abb. 7)¹, während das spontane Isoperm eine

 $\mu_{\rm ideal}/\mu_a$ auf weniger als 1,7 abgesunken ($\mu_{\rm ideal}=56$, $\mu_a=34$). Die Häufungsstellen haben zur Folge, daß die ideale Kurve einer normalen Magnetisierungskurve ähnelt; sie krümmt sich nämlich zunächst nach oben und wird dann wieder flacher.



Abb, 7. Preisach-Diagramm eines im Querfeld getemperten kobalthaltigen Nickel-Zink-Ferrits mit (induzierter) Isopernschleife $(\mu_a=12)$. Parameter wie in Abb.3

Abb. 8. Preisach-Diagramm eines Mangan-Zink-Ferrits mit spontaner Isopermschleife ($\mu_a=3500$). Parameter wie in Abb. 3

dem normalen Ferrit ähnliche, nur viel schwächere Besetzung mit geringerer Häufung aufweist (Abb. 8). In beiden Fällen steigt die ideale Kurve nur wenig

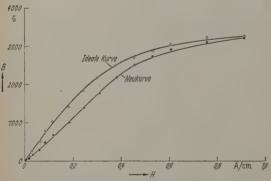


Abb. 9. Ideale Magnetisierungskurve und Neukurve des Ferrits nach Abb. 8

steiler an als die Neukurve. Aus den in Abb. 9 dargestellten Kurven eines spontanen Isoperms folgt $\mu_{\rm ideal}=7400,~\mu_a=3500,~\mu_{\rm ideal}/\mu_a=2,1.$

Das bei geringer Feldstärke besonders hysteresearme Perminvarferrit 2 weist in der Preisach-Ebene zwei kräftige Häufungsstellen oberhalb und unterhalb der H_b -Achse auf (Abb. 10 [7]). Infolge der geringen Hysteresedichte nahe der H_b -Achse ist der Quotient

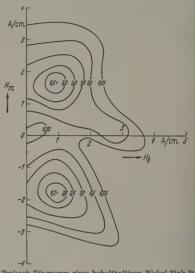


Abb. 10. Preisach-Diagramm eines kobalthaltigen Nickel-Zink-Perminvar ferrits ($\mu_{\alpha} = 130$). Parameter wie in Abb. 3

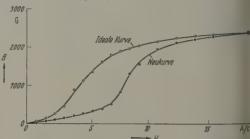


Abb. 11. Ideale Magnetisierungskurve und Neukurve eines kobalthaltigen Nickel-Zink-Perminvarferrits ($\mu_a=34$)

Diskussion der Ergebnisse

Die hier mitgeteilten Ergebnisse bestätigen die oben gezogenen Schlüsse. In keinem Fall wurde ein unendlich steiler Anstieg der idealen Kurve beobachtet. Zwar konnte nicht geprüft werden, ob die an dem Rechteckferrit gefundene Anfangssteigung der idealen Kurve von $55\,000\,\mu_0$ durch innere Scherung des Ferritkerns bestimmt wird. In einer an anderer Stelle veröffentlichten Untersuchung [8] wird aber nachgewiesen, daß die geringe ideale Anfangspermeabilität des Isopermkerns nicht durch eine innere Scherung hervorgerufen wird; ferner ist die mit wachsender Feldstärke zunehmende Steigung der idealen Kurve des Perminvars nicht mit einer Scherung vereinbar.

Den Herren H. GIRKE und D. STOLL danken wir für die Aufnahmen der Preisach-Diagramme.

Anhang

Abschätzung des Verhältnisses µ_{ideal}/µ_a

Ist die Besetzungsdichte γ der Preisach-Ebene wenigstens nahe der H_b -Achse näherungsweise konstant, so kann man in Gl. (1) das Integral gleich $\gamma H^2/2$ setzen. Hieraus folgt

Die schwachen Häufungsstellen oberhalb und unterhalb der H_b-Achse stellen offenbar Reste der Perminvarschleife dar.
² Aus meßtechnischen Gründen wurde für die Aufnahme der idealen Kurve nicht das gleiche, sondern ein ähnliches Ferrit gewählt wie für die Aufnahme des Preisach-Diagramms.

 $=4\nu$. Ferner ist die Strecke OC dann etwa gleich der doppelten oerzitivfeldstärke H_c ; daher hat das Integral in Gl. (2) wa den Wert 2ν H_c H. Somit folgt (für geringe Feldstärke)

$$i \approx 8 \nu H_c$$
. (3)

er Quotient aus idealer Induktion und der Induktion auf er Neukurve ist also [bei Vernachlässigung des quadratichen Gliedes in Gl. (1)]

$$\frac{B_{\rm ideal}}{B_{\rm Neu}} \approx \frac{\mu_{\rm ideal}}{\mu_a} \approx \frac{\mu_a + 8\nu H_c}{\mu_a} = 1 + 8\frac{\nu}{\mu_a} H_c. \tag{4}$$

ührt man den Jordanschen Hysteresebeiwert [11]

$$h \approx \frac{16\sqrt{2}}{3} \frac{\nu}{\mu_a} \tag{5}$$

n, so folgt

$$\frac{\mu_{\rm ideal}}{\mu_a} \approx 1 + \frac{3}{2 \cdot \sqrt{2}} h H_c \approx 1 + h H_c. \tag{6}$$

ach früheren Untersuchungen [12] hat $h\,H_c$ bei Ferriten wa den Wert 0,5 bis 3, so daß für $\mu_{
m ideal}/\mu_a$ etwa 1,5 bis 4 zu

warten ist. Daß der am Isopermferrit gemessene Wert von 2,1 tatchlich in diesen Bereich fällt, erklärt sich aus der wenigstens herungsweise gleichförmigen Besetzungsdichte der Preisachene nahe der H_b -Achse. Die ungleichförmigere Besetzungschte des Normalferrits und die sehr starke Häufung auf der Achse des Rechteckferrits verursachen den gegenüber dem geschätzten Wert wesentlich höheren Quotienten $\mu_{\rm ideal}/\mu_a$. an erkennt, daß $\mu_{\rm ideal}$ — wie es BOZORTH [4] angibt — hierigrößenordnungsmäßig gleich der größten differentiellen rmeabilität der Magnetisierungsschleife sein sollte [8], rminvarferrite sollten einen sehr geringen Quotienten $|\mu_{\rm ideal}/\mu_a\rangle$ von 1,5 bis unter 1,1 aufweisen; diese Vermutung 3t sich aber nicht prüfen, da infolge der zum Idealisieren twendigen großen Feldstärke stets nur der gestörte Permzarzustand beobachtet werden kann [10].

Zusammenfassung

Die ideale Magnetisierungskurve wird aus dem Preisach-Diagramm abgeleitet. Sie beginnt mit endlicher Steigung (ideale Anfangspermeabilität $\mu_{\rm ideal}$): Bei Ferriten mit Rechteck-, Normal- oder Isopermschleife nimmt die Steigung mit wachsender Feldstärke ab, bei Perminvaren zunächst zu und dann ab. Stark hysteresebehaftete Stoffe (Rechteckferrite) haben ein großes, hysteresearme Stoffe (Isoperme, Perminvare) ein kleines Verhältnis von $\mu_{\rm ideal}$ zur Anfangspermeabilität.

Literatur: [1] Maurain, Ch.: C. R. Acad. Sci., Paris 134, 914 (1903). — Gumlich, W., u. E. Steinhaus: Verh. dtsch. phys. Ges. 17, 369 (1915). — [2] Gans, R.: Ann. Phys., Lpz. 61, 379 (1920). — [3] Gerlach, W., u. A. Temesvary: Z. Physik 124, 570 (1948). — [4] Snoek, J. L.: Physica, Haag 3, 463 (1936). — Bozorth, R. M.: Ferromagnetism, S. 9, Fig. 1—8, S. 548/49. Toronto-New York-London 1951. — Smit, J., u. H. P. J. Wijn: Ferrites, S. 122 u. 223. Eindhoven 1959. — [5] Preisach, F.: Z. Physik 94, 277 (1935). — [6] Wilde, H.: Nachr.-techn. Z. 10, 497 (1957), Abb. 7c. — [7] Wilde, H., u. H. Girke: Z. angew. Phys. 11, 339 (1959). — [8] Kornetzki, M., E. Moser u. E. Röss: Naturwissenschaften 47, 274 (1960). — Z. angew. Phys. 13, 31 (1961). — [9] Kornetzki, M., J. Brackmann u. J. Frey: Naturwissenschaften 42, 482 (1955). — Siemens-Z. 29, 434 (1955); 32, 412 (1958). — [10] Kornetzki, M.: Elektrotechn. Z. A 80, 605 (1959). — [11] Jordan, H.: Elektr. Nachr.-Techn. I, 7 (1924). — Kornetzki, M.: Z. angew. Phys. 8, 127, 536 (1956).

Dr. Max Kornetzki, Dr. Erich Röss Wernerwerk für Bauelemente der Siemens & Halske AG, München

Mangan-Zink-Ferrite mit verschiedenartigen Magnetisierungsschleifen

Von M. Kornetzki, E. Moser und E. Röss

Mit 5 Textabbildungen

(Eingegangen am 19. August 1960)

Neben der normalen Magnetisierungsschleife kennt un noch die anomalen Formen, nämlich die Rechtsschleife, die eingeschnürte oder Perminvarschleife d die schrägliegende, rhomboidförmige Isopermdeife¹. Die Rechteck- und die Isopermschleife wurn zunächst nur an magnetisch anisotropen Kernen blachtet, z.B. an Metallen mit eingewalzter Vorgerichtung, an feldgetemperten Perminvaren, an

¹ Der Name Isoperm bezeichnet einen Stoff, dessen Perubilität wenig von der Feldstärke abhängt. Er wurde geliet für Eisen-Nickel· oder Eisen-Nickel· Kupfer-Legierung, denen durch Walz- und Glühbehandlung eine magnetische sotropie derart eingeprägt wurde, daß die Magnetisierungsleife schräg zur Induktionsachse verläuft [1]. Kennzeicht für die Isopermschleife ist nicht allein eine geringe Reienz, sondern auch eine angenäherte Linearität der Flanße einem Isoperm steigt die Permeabilität mit zunehuder Feldstärke etwa linear bis zur Maximalpermeabilität dabei ist die Maximalpermeabilität nur wenig größer als Anfangspermeabilität (μ_{\max}/μ_a etwa 1,1 bis 1,3). Ein Permarhat bis zu einer gewissen Feldstärke (Öffnungsfeldstärke) praktisch konstante Permeabilität; diese steigt dann steil Maximalpermeabilität an. μ_{\max}/μ_a beträgt etwa 2 bis 4. me, deren Schleife durch scherende Luftspalte geneigt i, wie z. B. Pulverkerne, rechnen nicht zu den Isopermen.

hexagonalen Einkristallen in der Richtung leichtester bzw. schwerster Magnetisierbarkeit und an Kernen, die unter äußerer mechanischer Zug- oder Druckspannung stehen. Später fand man zunächst die Rechteck-, dann auch die Isopermschleife an polykristallinen, magnetisch isotropen² Kernen, erstere z.B. an geglühtem Elektrolyteisen [2] und an den für Speicherzwecke verwendeten Ferritkernen [3], letztere an Ferriten mit hexagonaler Kristallstruktur [4] und an kubischen Mangan-Zink-Ferriten [5, 6]. Die Perminvarschleife [7] setzt keine Anisotropie des gesamten Kerns voraus, sondern nur eine bei erhöhter Temperatur einstellbare, uniaxiale Anisotropie in den einzelnen Weißschen Bezirken [8]. Im folgenden wird gezeigt, daß im System der Mangan-Zink-Ferrite alle

² Magnetisch isotrop ist ein Stoff, der in jeder Meßrichtung die gleichen magnetischen Eigenschaften hat. Einkristalle sind stets magnetisch anisotrop; im polykristallinen Kern mit regellos orientierten Kristalliten fällt die Anisotropie durch Mittelbildung fort. Kerne, die unter äußerer Zug- oder Druckspannung stehen, sind infolge der Magnetostriktion magnetisch anisotrop. Allseitig gleicher (hydrostatischer) Druck erzeugt keine Anisotropie.

bekannten Schleifenformen bei verschiedenen, aber dicht benachbarten Zusammensetzungen auftreten, und es wird versucht, die Ursache für den Isopermeffekt zu deuten.

Verschiedene Magnetisierungsschleifen der Mangan-Zink-Ferrite

Da die magnetischen Werte von Mangan-Zink-Ferriten stark von der Reinheit der Ausgangsstoffe und von der Sinterbehandlung abhängen, wurden die

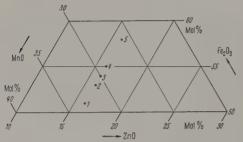


Abb. 1. Zusammensetzung der untersuchten Ferrite

Ferrite aus sehr reinen Oxyden hergestellt, gleichartig bei etwa 1300° C gesintert und in reinem Stickstoff abgekühlt. Auf einem Schnitt durch das System.

entwickelten Ferriten; dafür ist die remanente Induktion höher¹. Es handelt sich — wie bei den speziellen Rechteckferriten - um eine Pseudo-Rechteckschleife [9], deren relative Remanenz nur hoch ist. wenn man sie auf eine bei geringer Feldstärke (z.B. bei einigen Örsted) gemessene Induktion bezieht. Die auf die wahre Sättigungsmagnetisierung bezogene Remanenz eines polykristallinen isotropen ferromagnetischen Stoffes mit kubischer Gittersymmetrie kann nur etwas mehr als 80% betragen, wenn die spontane Magnetisierung nach dem Abschalten des sättigenden Magnetfeldes in den feldnächsten Richtungen leichtester Magnetisierbarkeit liegt [2], [10]. Vorbedingung hierfür ist, daß entweder vorhandene, sehr kleine Ummagnetisierungskeime erst nach Umkehr des Feldes (negative Feldstärke) wesentlich zu wachsen beginnen oder daß sich Ummagnetisierungskeine überhaupt erst bei negativer Feldstärke² bilden. GOODENOUGH [11] gibt hierfür die Bedingung an

$$LI_s^2 (\overline{\cos \Theta_1 - \cos \Theta_2})^2 < 60 \, \sigma_w \approx 240 \, \sqrt{A(K + \lambda \sigma_i)}$$

(L Korngröße des betreffenden Stoffes; I_s Sättigungsmagnetisierung; Θ_1 und Θ_2 Winkel der spontanen Magnetisierung in zwei benachbarten Kristalliten gegen die Normale der Korngrenze; σ_w spezifische Energie der Blochwand; A Austauschenergie; K Kristallanisotropie; λ Magnetostriktion; σ_i innere Spannungen). Hinreichend große Bildungsenergie der



Abb. 2a bis e. Magnetisierungsschleifen der untersuchten Ferrite 1 bis 5. Die Spitzenfeldstärke beträgt für die Schleifen a bis d 1,4 Oe, für die Schleife e 2,8 (bzw. 0,9) Oe; die Spitzeninduktion beträgt in der Reihenfolge a bis e 3170, 3520, 3130, 3000, 3000 (bzw. 1400) G

welcher von der Zusammensetzung 51 Fe₂O₃: 33MnO: 16 ZnO (Mol-%) bis zur Zusammensetzung 58 Fe₂O₃: 26 MnO: 16 ZnO reicht (Abb. 1), zeigen sich an Kernen, deren Zusammensetzungen den Punkten 1, 2, 3, 4 und 5 entsprechen, die in Abb. 2a bis e dargestellten Magnetisierungsschleifen. Wenn also der Gehalt an Eisenoxyd nur um 7% erhöht wird, durchläuft die Schleife alle bekannten Formen, nämlich die Rechteck-, Normal-, Isoperm- und Perminvarschleife. Die Rechteckschleife tritt auch auf, wenn man von Punkt 1 aus zu tieferem Eisenoxydgehalt übergeht, die Perminvarschleife auch, wenn man von Punkt 5 aus zu höherem Eisenoxydgehalt übergeht.

Legt man den Schnitt an anderer Stelle durch das System, so verschieben sich die Grenzen für die einzelnen Schleifen zu etwas anderem Eisenoxydgehalt. Da die Formen stetig ineinander übergehen, lassen sich scharfe Grenzen nicht angeben.

Die magnetischen Werte der oben genannten Ferrite sind in der Tabelle zusammengestellt.

Die Rechteckschleife in Punkt 1

Die hier auftretende rechteckförmige Schleife ist nicht so gut ausgeprägt wie bei den für Speicherkerne

Bloch-Wände kann man also als Ursache für die rechteckförmige Schleife ansehen. Die Bloch-Wände haben eine hohe Energiedichte, wenn die magnetische Kristallanisotropie oder die Magnetostriktion groß ist (leider liegen für das System der Mangan-Zink-Ferrite nicht genügend Meßwerte der Kristallanisotropie vor³). In beiden Fällen ist mit relativ geringer Anfangspermeabilität zu rechnen⁴. Der Quotient $\mu_{\rm max}/\mu_a$ aus Maximal- und Anfangspermeabilität und der Quotient aus dem Jordanschen Hysteresebeiwert \hbar und der Anfangspermeabilität sind bei Stoffen mit Rechteckschleife immer hoch [12] (s. Tabelle).

Die normale Magnetisierungsschleife in Punkt 2

Mit zunehmendem Gehalt an Eisenoxyd nimmt die Magnetostriktion der Mangan-Zink-Ferrite ab [13]; deshalb kann man nach der Formel von GOODENOUGH

 $^{^1}$ Magnesium-Mangan-Ferrite haben eine remanente Induktion von etwa 2 bis 2,5 kG.

² GOODENOUGH definiert die Feldstärke mit umgekehrtem Vorzeichen.

Meßwerte für Mangan-Ferrite s. bei Pearson [22].
 Diese Aussage gilt sowohl für den durch reversible

⁴ Diese Aussage gilt sowohl für den durch reversibte Wandverschiebungen als auch für den durch Drehprozesse der spontanen Magnetisierung verursachten Anteil der Anfangspermeabilität.

Tabelle. Magnetische Werte der untersuchten Ferrite

usammensetzung	μ_{α}	$\mu_{ ext{max}}$	$\mu_{\rm max}/\mu_a$	h cm/kA	h/μ_a cm/kA	<i>H_c</i> * Oe	\hat{B}^* Gauß	B_R/\widehat{B}^* %	$\mu_{ ext{ideal}}$	₽di#
Rechteck Normal Isoperm Normal Perminvar	1200 2500 3100 2800 770	5200 6100 3800 4100 2500	4,3 2,4 1,2 1,5 3,2	8800 8400 4000 10600 85	7,4 3,3 1,3 3,8 0,11	0,28 0,18 0,15 0,21	3950 4200 4600 4500 4300	80 50 18 35	50000 15000 6500 9500	36000 14000 6200 9900

^{*} $\hat{H} = 10 \text{ Oe}$

n (mit zunehmendem Eisenoxydgehalt stattfindenn) Übergang von der Rechteck- zur Normalschleife Folge eines verminderten σ_w -Wertes deuten. In sind bei verschwindender Feldstärke schon so del Ummagnetisierungskeime vorhanden, daß die manenz merklich vermindert wird. Aus den oben wähnten Gründen ist jetzt mit höherer Anfangsmeabilität zu rechnen, während μ_{\max}/μ_a und \hbar/μ_a windere (normale) Werte annehmen (s. Tabelle).

Die Isopermschleife in Punkt 3

Über die vermutliche Ursache der Isopermschleife l erst weiter unten ausführlicher gesprochen wer-1. Hier sei nur erwähnt, daß nach der Formel von ODENOUGH möglicherweise bei geringer, vielleicht ar bei noch positiver Feldstärke zahlreiche Umgnetisierungskeime entstehen, wenn σ_{m} hinreichend in wird. Tatsächlich geht die Magnetostriktion einem Eisenoxydgehalt von 53 bis 54% durch Null], so daß wahrscheinlich die Bloch-Wände hier die ingste Energie enthalten. Dann steht eine große ndfläche zur Verfügung, wodurch sowohl die Perabilität erhöht als auch der h/\mu_a\delta\text{Wert verringert}^1 d (s. Tabelle). Unabhängig davon wirkt sich natürdie geringe Magnetostriktion allein schon im ne einer gesteigerten Permeabilität aus. Ob ein ßer Anteil von Drehprozessen an der Anfangsmeabilität zu einem geringen h/μ_a -Wert führt, ist ht bekannt.

Die normale Magnetisierungsschleife in Punkt 4

Die für die Ausbildung der Isopermschleife günen Bedingungen sind nur in einem schmalen Beh des Mangan-Zink-Ferritsystems vorhanden. rhalb dieses Gebietes treten etwa normale Magnerungsschleifen auf, möglicherweise allein deshalb, I hier die Magnetostriktion wieder anwächst [13].

Die Perminvarschleife in Punkt 5

An Mangan-Zink-Ferriten mit mehr als etwa b Eisenoxyd entsteht bei geeigneter Sinterbehandg die eingeschnürte Schleife [14]. Sie läßt sich at aus obigen Gedankengängen über den Einfluß Wandenergie verstehen, sondern hat zur Vorausung, daß die Bloch-Wände in Energiemulden en, die beim langsamen Abkühlen unterhalb der ie-Temperatur durch eine uniaxiale magnetische sotropieenergie in den Kristalliten gebildet wert [8]. Hierdurch werden die Anfangspermeabilität der h/μ_a -Wert vermindert (s. Tabelle). Jedoch en die Perminvare nur bei geringer Aussteuerung

Es läßt sich zeigen, daß unter sonst gleichen Bedingungen Quotient h/μ_a umgekehrt proportional der in einem vorbenen Volumen vorhandenen Bloch-Wandfläche ist.

bis zu einigen hundert Gauß die eingeschnürte Schleife und den sehr geringen Hysteresebeiwert. Mit wachsender Aussteuerung verschwindet die Einschnürung; die Schleife nimmt dann eine isopermartige Form und schließlich meist eine normale Form an. Die isopermartigen Zwischenschleifen ([15], s. auch Abb. 2e) können von einer wahren Isopermschleife unterschieden werden, weil die Schleife eines Perminvarferrits durch Tempern im Magnetfeld verändert wird, nicht jedoch die eines Isopermferrits. Es ist wenig wahrscheinlich, daß diese isopermartigen Zwischen- oder Grenzschleifen auf die gleiche Ursache zurückzuführen sind wie die Schleifen der Isopermferrite. Vielmehr ist anzunehmen, daß die Energiemulden des Perminvars beim Durchlaufen der Grenzschleife noch eine gewisse Fangwirkung auf die Bloch-Wände ausüben.

Die Perminvarschleife der Mangan-Zink-Ferrite ist nicht so stabil wie die der kobalthaltigen Perminvare¹; sie wird durch ein wesentlich über die Koerzitivfeldstärke hinausgehendes Magnetfeld stark "gestört" [8], und es entsteht dann eine auch bei geringer Feldstärke mehr oder minder normal erscheinende Schleife. Bis zu welchem Eisenoxydgehalt herab sich noch Reste des Perminvareffektes bemerkbar machen, ist nicht bekannt. Vielleicht ist die in Punkt 4 beobachtete Schleife hierdurch noch beinflußt.

Magnetische Eigenschaften der Isopermferrite

Da die Eigenschaften von Ferriten mit Rechteckoder Perminvarschleife bereits weitgehend bekannt sind, sollen hier nur die Isopermferrite näher besprochen werden. Wie schon oben erwähnt, haben die Mangan-Zink-Ferrit-Isoperme eine sehr hohe Anfangspermeabilität 2 von etwa 3000 bis über 7000, ein niedriges Verhältnis von Maximal- zu Anfangspermeabilität (etwa 1,2; s. Tabelle) und geringe Hystereseverluste. Der Quotient \hbar/μ_a liegt anomal niedrig [12]; auch die Verluste bei großer Induktion von einigen Kilogauß sind klein.

Die Isopermferrite unterscheiden sich von den Perminvaren des Mangan-Zink-Ferritsystems noch durch folgende Eigenschaften:

- 1. Die Magnetisierungsschleife öffnet sich normal als (sehr schmale) Rayleigh-Lanzette.
- 2. Die magnetische Stabilität ist wie bei den metallischen Isopermen groß; die nach starker Vormagnetisierung gemessene reversible Permeabilität im Remanenzpunkt liegt nur etwa 5 bis $10\,\%$ unter der

Die kobalthaltigen Perminvarferrite haben allerdings eine wesentlich geringere Anfangspermeabilität (bis zu etwa 150 (161)

² Die metallischen, durch Walzen hergestellten Isoperme und die durch Tempern im Magnetfeld aus Perminvarferrit hergestellten Isoperme haben eine Anfangspermeabilität unter 150 [1], [16].

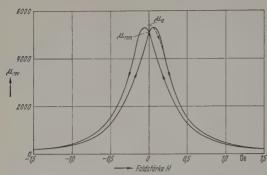


Abb. 3. Abhängigkeit der reversiblen Permeabilität von der Vormagnetisierung bei einem Isopermferrit

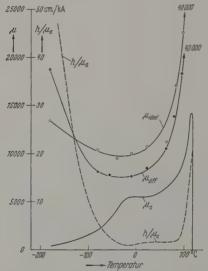


Abb. 4. Abhängigkeit der Anfangspermeabilität μ_a , der differentiellen Permeabilität auf den Flanken der Magnetisierungsschleite $\mu_{\rm diff}$, der idealen Anfangspermeabilität $\mu_{\rm ideal}$ und des bezogenen Hysteresebeiwerts h/μ_a eines Isopermferrits von der Temperatur

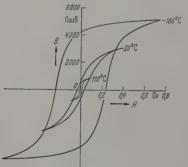


Abb. 5. Magnetisierungsschleifen eines Isopermferrits bei -186, 20 und $110^{\circ}\,\mathrm{C}$

Anfangspermeabilität (Abb. 3), und die Verluste werden nicht nennenswert geändert.

- 3. Die zeitliche Änderung der Permeabilität, z.B. nach einer Abmagnetisierung (Desakkommodation), ist gering.
- 4. Die Magnetisierungsschleife ändert sich nicht, wenn die Isopermkerne im Magnetfeld getempert werden.

Temperaturabhängigkeit der magnetischen Eigenschaften

Die Anfangspermeabilität der meisten Isoperm ferrite hat in Abhängigkeit von der Temperatur der von vielen Mangan-Zink-Ferriten bekannten Verlau mit mindestens einem sekundären Maximum, dessei Lage von der Zusammensetzung des Ferrits abhäng (Abb. 4). Die Isopermschleife ist im großen und ganze in dem Temperaturbereich am besten ausgeprägt, i dem dieses Maximum liegt1; in dem hier dargestellte Fall findet sich die Isopermschleife etwa zwische. 80 und +90° C. Nach tieferer Temperatur hin wir die Schleife normal und dann rechteckähnlich, nac höherer Temperatur hin normal (Abb. 5). Der relativ Hysteresebeiwert ist im Isopermbereich am geringste (Abb. 4). Es gibt aber auch Isoperme, die kein erkenn bares sekundäres Maximum aufweisen. Dieser Fal scheint aufzutreten, wenn die Curie-Temperatur tie liegt und die Permeabilität zur Curie-Temperatur hir steil ansteigt; dann wird vielleicht das sekundär Maximum durch den Steilanstieg verdeckt.

Die Ursache der Isopermschleife

Eine geringe Remanenz kann in einem magnetischanisotropen oder in einem isotropen Kern entstehen Im ersten Fall muß eine magnetische Vorzugslage que zur Meßrichtung vorhanden sein; im zweiten Falmüssen Gründe dafür vorliegen, daß ein wesentliche Teil der spontanen Magnetisierung nach dem Abschalten eines sättigenden Feldes in Richtungen übergeht die mit der Richtung des gewesenen Feldes eine Winkel über 90° bilden.

Zunächst wurde geprüft, ob der Kern eine z.E. während des Pressens entstandene Anisotropie auf weist. Zu diesem Zweck wurden aus einem große ringförmigen Isopermkern kleine Ringe herausge schliffen, derart, daß deren Achse durch den Mittel punkt des ursprünglichen Kerns oder in tangentiale Richtung verlief². Die kleinen Kerne zeigten di gleiche Schleifenform. Der Isopermkern ist als magnetisch isotrop; er kann keine gerichteten Kristallite oder Spannungen enthalten.

Daß die Schleife nicht durch seherende unmagneti sche Einschlüsse oder Poren beeinflußt ist, kann au folgenden Ergebnissen geschlossen werden:

1. Die Isopermschleife bildet sich anscheinend was besser aus, je dichter man das Ferrit sintert, jenehr man also eine vermutete Scherung herabsetzt Die hier beschriebenen Kerne haben eine Dichte vol 4,7 bis 4,9 g/cm³. Bei niedriger Temperatur gesinterte porige Ferrite mit einer Dichte von 4,1 g/cm³ haber zwar eine geringere Anfangspermeabilität, aber kein so gut ausgeprägte Isopermschleife.

2. Gibt man dem Ferrit geringe (unmagnetischt Zusätze, die sich (nach Guillaud [17]) an den Kongrenzen ablagern, z.B. Kalziumoxyd, so wird di Schleife nicht flacher, sondern man findet eine steiler Schleife normaler Form.

3. Wie bereits erwähnt, geht die Isopermschleif bei hoher Temperatur in eine normale, bei tiefe

¹ Im Gegensatz dazu tritt ein Perminvareffekt nur ober

halb eines Permeabilitätsmaximums auf [8], [16].

² Mit diesem Verfahren wurde bereits früher die Isotropi der Rechteckschleife von Magnesium-Mangan-Ferriten nach gewiesen [9]. mperatur in eine rechteckähnliche Schleife über bb. 5). Die Flanken dieser Schleifen haben eine ßere Steilheit (μ_{diff} etwa 40000 bzw. 19000 bei dem r untersuchten Kern) als die bei Zimmertemperatur nessene Isopermschleife (μ_{diff} etwa 7000). Ferner igt die Anfangspermeabilität mit wachsender mperatur bis auf etwa 14000 (Abb. 4). Ein evenler Scherungsfaktor kann nicht diese Temperaturnängigkeit haben.

4. Die Anfangsneigung μ_{ideal} der idealen Magnerungskurve¹, welche nicht steiler ansteigen kann, es ein vorliegender Scherungsfaktor zuläßt [18], ist bestimmten Temperaturbereichen wesentlich größer die Anfangspermeabilität der Isopermferrite bb. 4). Bei Zimmertemperatur ist zwar die ideale meabilität nur etwa doppelt so groß wie die Angspermeabilität, so daß man hieraus zunächst chlicherweise auf eine Scherung schließen könnte².

ideale Permeabilität steigt aber sowohl nach er als auch nach hoher Temperatur erheblich an, zwar bei dem untersuchten Kern auf 13000 bzw.

000 (Abb. 4).

5. Die Isopermferrite haben nicht nur einen gegen h/μ_a -Wert, sondern auch einen — für die befende Anfangspermeabilität — anomal kleinen bienten h/μ_a^2 . Wäre die Isopermschleife durch erung aus einer normalen Schleife entstanden, so nte h/μ_a^2 nicht anomal klein sein, weil h/μ_a^2 bei erung konstant bleibt.

Aus diesen Ergebnissen folgt, daß die Isopermite keine wesentlich scherenden unmagnetischen

schlüsse oder Poren enthalten.

SMIT und WIJN [5] stellten an polykristallinen fen mit hexagonaler Kristallstruktur und großer stallanisotropie, z.B. an hochgesintertem Bariumit, eine starke Scherung durch querliegende Kriste fest; diese Scherung muß offenbar von der aperatur abhängen. Es liegt nahe, einen gleichgen, wenn auch wesentlich schwächeren Effekt bei kubischen Isopermferriten anzunehmen. Dagegen icht jedoch ein Meßergebnis von Gieseke und Ger³; sie fanden an Einkristallen aus Manganit eine Isopermschleife in der Richtung leichtester netisierbarkeit, obgleich hier keine querliegenden tallite vorhanden sind.

BOZORTH [19] deutet eine anomal kleine Remanenz ⁴ ch das Vorhandensein vieler Schließungsbezirke, ² zwar als Folge einer sehr geringen Energie der ih-Wände. Die gleiche Voraussetzung führt auch eine Deutung durch die Goodenoughsche Formel, ⁴ welcher sich die ummagnetisierten Bezirke im infeld der Korngrenzen ausbilden sollen. Beide tungen haben jedoch den Nachteil, daß ihre Vorsetzungen für jeden hochpermeablen Stoff zu-

Die ideale Magnetisierungskurve eines magnetischen es entsteht, wenn man an den entmagnetisierten Kern Heichfeld anlegt und einen Abmagnetisierungsvorgang hselfeld mit stetig bis auf Null abnehmender Amplitude) agert. Die verbleibende Induktion wird in Abhängigkeit Gleichfeld aufgetragen.

An anderer Stelle [18] wird nachgewiesen, daß eine he Steilheit der idealen Magnetisierungskurve kein unlbares Maß für eine innere Scherung darstellt.

Wird an anderer Stelle veröffentlicht.

Bei den von Bozorth angeführten Beispielen, nämlich alloy mit 65% Nickel und Eisen mit 6,5% Silizium, itt es sich aber (mindestens im ersten Fall) um Zwischen-Grenzschleifen von Perminvaren [23]. treffen, daß aber im allgemeinen diese Stoffe keine besonders geringe Remanenz haben.

Grundsätzlich ist es nicht notwendig, daß ein Stoff mit geringer Remanenz zahlreiche Bloch-Wände enthält, denn auch wenige, aber große Schließungsbezirke können die Remanenz vermindern. Für eine große Zahl von Wänden spricht jedoch neben dem geringen Hysteresewert h/μ_a (s. oben) noch eine Auswertung des von Metzdorf angegebenen Zusammenhanges zwischen Hysterese- und Nachwirkungsverlust [20]. Hieraus folgt für die Isopermferrite eine besonders große Zahl von Sprüngen der Bloch-Wände, die man am einfachsten durch eine vergrößerte Zahl von Wänden deuten kann. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß — wie Bozortн schon erwähnt — Stoffe mit geringer Wandenergie sehr dicke Bloch-Wände haben; möglicherweise wird die Hysterese gesenkt, weil die dieken Wände gegenseitig ihre Bewegung behindern.

Die naheliegende Deutung der Isopermschleife allein durch reversible Drehprozesse scheitert an der fehlenden Quervorzugslage.

Aus einer geringen Remanenz folgt noch nichts über die Form der Schleife. Tatsächlich treten neben schrägliegenden rhomboidförmigen Schleifen auch stark gekrümmte Schleifen auf. Hierüber wird an anderer Stelle berichtet.

Eigenartigerweise haben die isotropen Isopermferrite ein Preisach-Diagramm, welches mehr dem eines normalen Ferrits ähnelt als dem eines anisotropen Isopermferrits [18]. Die Besetzungsdichte ist natürlich relativ gering. Die Linien konstanter Besetzungsdichte verlaufen schräg, was nach den Überlegungen von WILDE und GIRKE [21] darauf hindeutet, daß die Elementarvorgänge miteinander verkoppelt sind, und zwar — im Gegensatz zu den Stoffen mit Rechteckschleife — im Sinne einer Gegenkopplung. Vielleicht ist dies der Ausdruck für die oben angedeutete gegenseitige Behinderung der Bloch-Wände.

Zusammentassung

Verändert man den Eisenoxydgehalt von Mangan-Zink-Ferriten von etwa 51 bis zu etwa 58 Mol-%, so treten alle bekannten Formen von Magnetisierungsschleifen auf: Rechteckschleife, normale Schleife, Isopermschleife und Perminvarschleife. Die Anfangspermeabilität hat ihren höchsten Wert im Isopermgebiet, der relative Hysteresebeiwert h/μ_a nimmt in obiger Reihenfolge ab. Die Isopermferrite sind besonders stabil gegen ein vorübergehend wirkendes Magnetfeld. Soweit die Permeabilitäts-Temperatur-Kurve der Isopermferrite ein sekundäres Maximum aufweist, ist der Isopermeffekt in der Umgebung dieses Maximums besonders gut ausgeprägt. Bei tiefer Temperatur, z.B. unter - 80° C, geht die Isopermschleife in eine rechteckähnliche Schleife, bei hoher Temperatur, z.B. bei + 100° C, in eine normale Schleife über.

Die Isopermschleife entsteht spontan, ohne daß die Kerne im Magnetfeld getempert werden müssen; sie wird weder durch eine Anisotropie des Kerns noch durch eine Scherung verursacht, sondern möglicherweise durch eine große Zahl von Bloch-Wänden.

Das Preisach-Diagramm dieser isotropen Isopermferrite ähnelt mehr dem eines normalen Ferrits als dem eines anisotropen Isoperms. Aus der Verzerrung der Linien konstanter Besetzungsdichte kann man auf eine Verkopplung der Elementarvorgänge schließen, welche das Vorzeichen einer Gegenkopplung hat.

Literatur: [1] Bozorth, R. M.: Ferromagnetism, S. 125 u. 157. Toronto-New York-London 1951. — Pawler, F.: Magnetische Werkstoffe, S. 242. Berlin-Göttingen-Heidelberg 1952. — [2] Kornftzkt, M.: Ann. Phys., Lpz. 5. F. 43, 203 (1943), Abb. 1. — [3] Albers-Schoemberg, E.: J. Appl. Phys. 25, 152 (1954). — [4] Smit, J., u. H. P. J. Vijn: Ferrites, Fig. 43.6, 43.7 u. 60.2. Eindhoven 1959. — [5] Bauformblatt B 60 151, Blatt 2, der Siemens & Halske AG, Ausgabe 4. 1958 (Werkstoff 2000 N 28). — Albers-Schoemberg, E.: J. Amer. Ceram. Soc. 41, 484 (1958), Fig. 1. — [6] Kornftzki, M., E. Moser u. E. Röss: Naturwissenschaften 47, 274 (1960). — [7] Bozorth, R. M.: Ferromagnetism, S. 121 u. 170. Toronto-New York-London 1951. — [8] Zusammenstellung siehe Kornftzki, M.: Elektrotechn. Z. A 80, 605 (1959). — [9] Kornftzki, M.: Frequenz 9, 81 (1955). — [10] Bozorth, R. M.: Ferromagnetism, S. 502. Toronto-New York-London 1951. — [11] Goodbinough, J. B.: Phys. Rev. 95, 917 (1954). — 12] Kornftzki, M.: Z. angew. Phys. 8, 127 (1956); 10, 368

(1958). — [13] SMIT, J., n. H. P. J. WIJN: Ferrites, Fig. 48.2 Eindhoven 1959. — [14] ENZ, U.: Physica, Haag 24, 60 (1958). — Röss, E.: Naturwissenschaften 46, 65 (1959). — [15] Siehe z. B. Kornstzki, M., J. Brackmann u. J. Frey Siemens-Z. 29, 434 (1955), Bild 2. — SMIT, J., u. H. P. J. WIJN: Ferrites, Fig. 58.1. Eindhoven 1959. — [16] Kornstzki, M., J. Brackmann u. J. Frey: Naturwissenschaftet 42, 482 (1955). — Siemens-Z. 29, 434 (1955); 32, 412 (1958). — [17] Guillaud, C.: Proc. Inst. Electr. Engrs. B 104 Suppl. 5, 165 (1957). — [18] Kornstzki, M., u. E. Röss: Z. angew. Phys. 13, 28 (1961). — [19] Bozorth, R. M.: Z. Physin 124, 519 (1947/48). — [20] Metzdorf, W.: Z. angew. Phys. 11, 339 (1959). — [21] WILDE, H., u. H. Girke: Z. angew. Phys. 11, 339 (1959). — Girke, H.: Z. angew. Phys. 12, 11, 339 (1959). — Girke, H.: Z. angew. Phys. 12, 11, 339 (1959). — [22] Pearson, R. F.: J. Appl. Phys. 12, 20 (1960). — [22] Pearson, R. F.: J. Appl. Phys. 12, 20 (1960). — [23] Lee, E. W. and A. C. Lynch: Phil. Mag. Suppl. 8, No. 31, 292 (1959), 5.4.

Dr. Max Kornetzki, Dr. Erich Moser, Dr. Erich Röss Wernerwerk für Bauelemente der Siemens & Halske AG, München

Ladungstransport mit Kunststoffäden im Bandgenerator

Von Eduards Bailitis

Mit 7 Textabbildungen (Eingegangen am 28. Juli 1960)

1. Einführung

Zur Erzeugung von hoher Gleichspannung bis zu einigen Megavolt wird oft der Bandgenerator angewendet. Das Prinzip der Maschine ist zuerst durch VAN DE GRAAFF [1] bekannt geworden. Durch die Verwendung eines Bandes zu dem Transport der elektrischen Ladungen konnte man eine Ausführung eines statischen Generators realisieren, indem die Wirkung des Faradayschen Käfigs, im Gegensatz zu den ersten Maschinen von Holz, Töpler und Wimshurst, voll ausgenutzt wird. Die Elektroden zwischen denen das Hauptfeld entsteht, erhalten Hohlräume. Das Transportband wird über zwei Walzen, die in den Hohlräumen lagern, geführt. In einem Hohlraum werden die elektrischen Ladungen durch eine Hilfsspannung getrennt und das Band mit Ladungen gleicher Polarität belegt. Durch eine mechanische Vorrichtung wird das Band in Bewegung gehalten. Die elektrischen Ladungen werden durch mechanische Arbeit zu dem gegenüberliegenden Hohlraum in die zweite Elektrode gebracht, worin sie zu der Oberfläche der Elektrode restlos abfließen. Ist die Ladungsabnahme so ausgeführt, daß vor dem Abfluß der Ladungen nach der Oberfläche der Elektrode zusätzlich ein Nebenfeld entsteht, so kann man die in der entgegengesetzten Richtung sich bewegende Bandhälfte mit Ladungen entgegengesetzter Polarität belegen. Sind beide Ladevorrichtungen so ausgelegt, daß ein Nebenfeld zur Ladungstrennung entsteht, so kann man die Maschine ohne eine fremde Hilfsspannung erregen. Die Beladung, die Entladung und die Umladung der Transportfläche ist bei einem Bandgenerator von der Hauptfeldstärke unabhängig. Die Stromstärke des Gerätes ist allein durch die mittlere Ladungsdichte auf dem Transportband und der Flächengeschwindigkeit bedingt.

Zum Transport der elektrischen Ladungen Bandgeneratoren sind bis heute ausschließlich ein ode mehrere Bänder benutzt worden. Nicht jeder Isolie stoff ist zur Anfertigung des Bandes geeignet. Di mechanische Beanspruchung, besonders bei eine höheren Geschwindigkeit, ist sehr groß. Als geeignett Material zur Anfertigung des Bandes haben sich einig besonders hergestellte und bearbeitete Gummimasse bewährt. Um die notwendige mechanische Stabilitä zu erreichen, wird das Band oft aus einem Seiden- ode Baumwollgewebe hergestellt und mit einer synthet schen oder Natur-Gummimasse überzogen. D Gummimassen sind bei der Herstellung des Bande so beliebt geworden, daß man sogar Gewebe aus eine Kunststoff mit ausgezeichneten elektrischen un mechanischen Eigenschaften wie z.B. Perlongeweb mit einem Gummibelag versieht [5].

Die Bandgeschwindigkeit bei technischen Geräte dieser Art liegt zwischen 10 bis 25 m/sec. Die Lebendauer des Bandes beträgt etwa 400 bis 600 Betriebstunden

Die Geschwindigkeit ist durch die Eigenschwingun des Bandes begrenzt. Bei einer höheren Geschwindigkeit wird das Band durch Luftwirbel oder ander mechanische Vorgänge zu Schwingungen angereg Im Resonanzfall werden die Schwingungsamplitude so groß, daß ein Betrieb nicht mehr möglich ist.

Die mechanischen Schwierigkeiten treten mit zunehmender Bandbreite bereits bei geringeren Geschwidigkeiten auf. Die Flächengeschwindigkeit kann mabei einem Band durch vergrößern der Breite nich wesentlich steigern. Die technisch erreichte Flächet geschwindigkeit liegt zwischen $60\cdot 10^3~{\rm cm}^2/{\rm sec}$ b $100\cdot 10^3~{\rm cm}^2/{\rm sec}$.

Auf dem Gebiet der Kunststoffe liegt eine groß Auswahl an Isoliermaterialien vor, die ausgezeichnet ktrische und mechanische Eigenschaften haben. Es d Materialien mit einer hohen mechanischen Zugtigkeit und einer hohen Abriebfestigkeit bekannt. haben oft eine hohe elektrische Durchschlagfestigit und ebenfalls eine hohe elektrische Überschlagtigkeit.

Ein besonders geeignetes Material zur Herstellung des Transportsystems der elektrischen Ladungen in ktrostatischen Maschinen scheinen runde Kunstfischnüre zu sein. Eine Transportfläche aus einnen runden Fäden verhält sich ähnlich wie ein stem aus parallel gespannten Saiten. Die Schwingsformen einer Fadenwand sind erheblich einfacher die eines Bandes. Die Eigenfrequenz liegt viel höher bei einem Band und kann durch Zugkraft leicht Berhalb der Eigenresonanz des Gesamtsystems vertt werden.

Die Stromstärke in elektrostatischen Maschinen

$$I = v_F \cdot \sigma \tag{1}$$

an durch eine Steigerung der Flächengeschwindigte v_F und eine Erhöhung der Ladungsdichte σ versößert werden. Die Ladungsdichte steigt mit einem nehmenden Druck der Umgebungsatmosphäre an. beträgt in technischen Geräten bei einem Druck Tank von 10 bis 20 atm etwa $8 \cdot 10^{-9} \, \mathrm{Asec/cm^2}$. Bei einem atmosphärischen Druck kann man die Stromirke durch eine Erhöhung der Geschwindigkeit des ansportsystems steigern.

Die Geschwindigkeit eines aus den Fäden bestenden Transportsystems läßt sich bei einer breiteren iche wesentlich über die Geschwindigkeit eines lichbreiten Bandes steigern. In dieser Arbeit ist der ansport der elektrischen Ladungen durch runde enststoffschnüre aus Polyamid (Perlon) untersucht.

2. Abschätzung der zu erwartenden Beladungsdichte

Aus dem Gaußschen Satz in der Elektrostatik ist 'Maximalwert der Ladungsdichte für ein ebenes nd von Kossel [2] abgeleitet worden. Die Ergebse von Kossel sind nochmals von Kessel [3] kutiert worden. Über die Ergebnisse in bezug auf sog, doppelte Bandbeladung ist in diesen Arbeiten ne Übereinstimmung erzielt worden. Nach Aufsung von Kossel könnte man auf die Transportche eine Ladungsdichte von $2 \cdot 2,65 \cdot 10^{-9} \, \mathrm{Asec/cm^2}$ eichen, wobei dieser Betrag die maximale Ladungshte auf ebene Flächen bei einem atmosphärischen uck darstellt. Nach Interpretation von Kessler in man bei gleichen Verhältnissen nur einen halben trag erreichen.

Zur Abschätzung der Ladungsdichte kann man ch aus der Energiegleichung des elektrostatischen des ausgehen. Die Energie eines elektrostatischen des ist durch die Beziehung

$$P = \int_{V} \frac{\varepsilon \, \varepsilon_0}{2} \, E^2 \, dV \tag{2}$$

geben, worin P die Energie, E die Feldstärke, $= \frac{1}{4\pi\,9\cdot 10^{11}}\,\frac{\text{Asec}}{\text{Vem}} \quad \text{die absolute und } \varepsilon \,\, \text{die relative}$ elektrizitätskonstante und dV das Volumenelement leuten.

Sind zwei ebene Flächen mit elektrischen Ladun-1 entgegengesetzter Polarität belegt und liegen die Flächen parallel, so ist das Feld homogen. Der Energieinhalt eines Zylinders mit der Grundfläche F, dessen Mantelfläche mit den Kraftlinien parallel liegt, beträgt

$$P = \frac{\varepsilon \, \varepsilon_0}{2} \, E^2 \, F \, d, \tag{3}$$

worin d die Länge des Zylinders bedeutet. Liegt auf der Fläche eine Ladungsmenge Q und beträgt die Potentialdifferenz U, so besteht die Beziehung

$$\varepsilon \, \varepsilon_0 \, E^2 F d = Q \, U \,. \tag{4}$$

Berücksichtigt man, daß $U=E\cdot d$ ist, so folgt für die Ladungsdichte $\sigma=Q/F$ die bekannte Beziehung

$$\sigma = \varepsilon \varepsilon_0 E. \tag{5}$$

Die elektrische Durchschlagfestigkeit der Luft beträgt etwa $30~\mathrm{kV/cm}$. Setzt man diesen Wert in (5) ein, so ergibt sich für die maximale Beladungsdichte der Betrag von

$$\sigma = 2.65 \cdot 10^{-9} \,\text{Asec/cm}^2$$
. (5a)

Die Anordnung kann man spiegelsymmetrisch erweitern. Die Gesamtanordnung ähnelt einem Doppelkondensator. Die mittlere Fläche kann eine doppelte Ladungsmenge erhalten. Die maximale Ladungsdichte beträgt $\sigma=2\cdot 2,65\cdot 10^{-9}\,\mathrm{Asec/cm^2}$ bzw. 16 egs-Einheiten pro em². Nur dann wenn das Band in einem Generator von der Beladung bis zu der Entladung in dem Hochspannungshohlraum so geführt wird, daß es auf der Mittelebene eines Doppelkondensators bleibt, kann man die Ladungsdichte bis zu diesem doppelten Betrag steigern.

In keinen experimentellen Arbeiten ist dieser Betrag erreicht worden. Die Ladungsdichten auf dem Band, die durch eine einfache Beladevorrichtung erreicht worden sind, betragen etwa $1.4 \cdot 10^{-9}$ bis $1.6 \cdot 10^{-9}$ Asec/cm². Durch eine sorgfältig überlegte Elektrodenführung in der Beladevorrichtung, wie das von A. Flammersfeld und G. Weber [4] beschrieben worden ist, kann man die Ladungsdichte bis zu einem Betrag von $2.6 \cdot 10^{-9}$ Asec/cm² steigern.

Nach der erfolgten Beladung ist es nicht von Bedeutung zu wissen, ob sich die Ladungen auf der einen oder der anderen Seite des Bandes befinden, wie das von Kessler angeführt ist. Bestimmend ist das von dem Band entspringende Feld. Ist das Feld spiegelsymmetrisch, so kann man bei der Abschätzung der Ladungsdichte für die Feldstärke den Durchbruchswert einsetzen, was zu dem Ergebnis von Kosselführt. Die Annahme von Kessler, daß die Hälfte von den Ladungen auf dem Band eigene Influenzladungen sind, die zum Stromtransport keinen Beitrag liefern, scheint nicht zutreffend zu sein.

Die Beladungsdichte ist durch das resultierende Feld auf der Fläche des Ladungsträgers bedingt. Benutzt man runde Isolierschnüre aus Kunststoff, so kann man die erreichbare Ladungsdichte wie folgt abschätzen. Auf einem runden Isolierstab mit dem Radius r und der Länge l ist eine Ladungsmenge Q homogen auf der gesamten Mantelfläche verteilt. Das resultierende Feld ist achsial symmetrisch. Die radiale Feldstärke beträgt

$$E_r = \frac{Q}{2\pi r l \, \varepsilon_1 \, \varepsilon_0} \,, \tag{6}$$

worin ε_1 die Dielektrizitätskonstante der Umgebungsatmosphäre bedeutet. Bei einer radialen Feldstärke

von 30 kV/cm ergibt sich eine Ladungsdichte von

$$\sigma = \frac{Q}{2rl} = \frac{30 \cdot 10^3}{4 \cdot 9 \cdot 10^{11}} = 8.3 \cdot 10^{-9} \,\text{Asec/cm}^2.$$
 (7)

Der Diametralquerschnitt ist hierbei als Bezugsfläche gewählt. Diese Beladungsdichte ist auch dann zu erwarten, wenn die Feldlinien auf zwei parallelen Ebenen sich gleichmäßig verteilen. Enden die Feldlinien nur auf eine Ebene, so ist nur mit einem halben Betrag $\sigma=4\cdot 10^{-9}$ Asec/cm² zu rechnen.

Nach den Messungen von Petersen und W.O. Schumann [6] ist die Durchschlagfestigkeit bei einer zylindrischen Elektrodenanordnung nicht auf 30 kV/cm

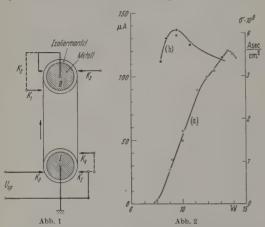


Abb. 1. Versuchsanordnung. Die Fadenwand ist über zwei rotierende Rollen I und II aufgespannt. Der Pfeil gibt die Bewegungsrichtung der Wand an. Die Beladung, Entladung und die Umladung erfolgt mit Hilfe der Kämme K_0 bis K_2 . Die Erregungsspannung ist zwischen K_0 und der Erdklemme angeschlossen

Abb. 2a.u.b. Der von der Fadenwand transportierte Strom und die Beladungsdichte. a) Strom von der unteren zu der oberen Rolle; b) Strom von der oberen zu der unteren Rolle

beschränkt. Bei einem Innenradius von 1 cm und einem Druck von 760 Torr und 20° C beträgt die Durchschlagfeldstärke in der Luft 40,2 kV/cm. Sie steigt mit einem abnehmenden Radius noch an. Die ermittelte Ladungsdichte von $\sigma=4\cdot 10^{-9}\,\mathrm{Asec/cm^2}$ auf runden Isolierfäden stellt keinen Höchstwert dar. Auf dünnen Fäden kann die Ladungsdichte einen höheren Betrag erreichen.

3. Versuchsanordnung und Meßergebnisse

In Abb. 1 ist die Versuchsanordnung schematisch wiedergegeben. Über zwei Rollen, die isoliert voneinander angeordnet sind, ist eine Perlonschnur mit einem Durchmesser von 1 mm in mehreren nebeneinanderliegenden Lagen aufgespannt. Die beiden Rollen aus Aluminium sind mit einer Isolierschicht überzogen. Die Isolierschicht ist mit nebeneinanderliegenden Rillen versehen, in denen die Schnur gelagert wird. Über eine Umlenkvorrichtung sind die beiden Schnürenden endlos verbunden. Die eine Rolle wurde mit einem Motor angetrieben. Bei einem sauberen mechanischen Aufbau konnte man die Fadenwand auch bei größeren Geschwindigkeiten schwingungsfrei laufen lassen.

Zur Beladung der Fadenwand ist ein Sprühkamm K_0 angebracht. Die Hochspannung wird zwischen dem Sprühkamm und dem inneren Rollenbelag

angeschlossen. Bei einer genügend hohen Spannung fließen die Ladungen von der Sprühspitze auf die Isolierschicht der Rolle, und auf die in die Rille gelegte Schnur. Die Ladungen, die auf der Fadenfläche liegen, werden zu der zweiten Rolle transportiert und in der Nähe derselben mit einem Abnahmekamm K, abgenommen. Die auf der Isolierschicht der Rolle verbleibende Ladung wird an irgendeiner anderen Stelle mit einem weiteren Kamm K_5 entfernt, so daß in der Umgebung der Beladung dauernd der gleiche Zustand herrscht. Wird die auf der Rolle verbleibende Ladung nicht abgenommen, so entsteht nach einigen Umdrehungen der Rolle ein Potentialausgleich, so daß die Sprühung bei dem Beladungskamm aussetzt. Die Fadenwand erhält keine Ladungen und der Ladungstransport wird unterbrochen.

Die Fadenwand wurde mit einer Geschwindigkeit von 40 m/sec angetrieben. Die Sprühspannung wurde langsam gesteigert und der von der Fadenwand transportierte Strom gemessen. Die Ergebnisse sind in Abb. 2 graphisch aufgetragen. Der Strom steigt linear mit der Sprühspannung an, erreicht einen Maximalwert und nimmt ab. Kurz vor dem Maximalwert ist eine Neigungsänderung der Kurve zu sehen. Hier dürfte es sich um einen Nebenschluß handeln, da die eine Neigungskurve auf der Sprühstromkurve (Abb. 4) zu erkennen ist.

Der von der Fadenwand transportierte maximale Strom beträgt 120 µA. Die Fadenwand bestand aus 84 Fäden mit einem Durchmesser von 1 mm.

Der gesamte Diametralschnitt beträgt 8,4 cm. Die Flächengeschwindigkeit des Diametralquerschnitts beträgt $v_F=33,6\cdot 10^3~{\rm cm^2/sec}$. Für die auf dem Diametralquerschnitt bezogene maximale Beladungsdichte findet man den Betrag von

$$\sigma = rac{I_F}{v_F} = 3.6 \cdot 10^{-9} \, \mathrm{Asec/cm^2}.$$

Die Kurve (b) in Abb. 2 gibt den Strom auf der ablaufenden Fadenwand wieder. Die Kämme K_1 und K_2 an der zweiten Rolle sind mit dem Innenbelag, der Kamm K_3 mit der Grundplatte, die auf dem Erdpotential liegt, verbunden. Die ursprünglich aufgesprühten Ladungen fließen auf den Innenbelag der zweiten Rolle. Zwischen dem geerdeten äußeren Kamm K_3 und der Innenfläche der Rolle entsteht en elektrisches Feld, dem zufolge die Fadenwand mit Ladungen entgegengesetzter Polarität belegt wird. Die abwärtstransportierten Ladungen wurden durch den Kamm K_4 an der ersten Rolle abgenommen und der Strom gemessen.

Der abwärtstransportierte Strom steigt steil zu dem Maximalwert an und nimmt dann mit einer steigenden Sprühspannung allmählich ab. Der maximale Strom beträgt 137 μ A, was eine Beladungsdichte von 4,1 · 10⁻⁹ Asec/cm² ergibt.

Die Ergebnisse stimmen gut mit der zu erwartenden Beladungsdichte laut durchgeführter Abschätzung überein. Die Breite der Fadenwand betrug 14 cm. Betrachtet man als Träger ein Band von dieser Breite so beträgt die Flächengeschwindigkeit $v_F=56\cdot 10^3$ cm²/sec. Die mittlere Beladungsdichte wäre demnach $\sigma=2,45\cdot 10^{-9}$ Asec/cm², was gut mit der zu erwartenden Ladungsdichte auf einem Band übereinstimmt.

4. Versuchsmaschine

Die Versuchsanordnung war ein Teil der späteren ersuchsmaschine. Die Maschine ist von K. WIL-TZKI konstruiert und sorgfältig aufgebaut worden. n Teilausschnitt ist in Abb. 3 abgebildet. Auf eine undplatte aus Metall ist die untere Rolle mit dem itriebsmechanismus und dem Umlenksystem für den dlosen Fadenlauf montiert. Ein besonders geform-Profil aus Plexiglas, welches aus mehreren, teilise geformten Einzelteilen zusammengekittet worn war, ist auf der Grundplatte befestigt. Die zweite, f der Hochspannungsseite liegende Rolle ist auf m Plexiglasprofil montiert. Durch eine Vorrichtung nnte man den Abstand der Rollen auf eine Weite n etwa 5 cm verstellen und damit die notwendige chanische Vorspannung der Fadenwand geben. er das Transportsystem wurde ein viereckig geimtes Plexiglasgehäuse gestülpt. Dadurch wurde notwendige Stabilität erreicht. Das Gehäuse des rätes konnte man dicht durch einen Deckel abließen, so daß es möglich war den Ladungstransport einer getrennten für sich abgeschlossenen Atmonäre vorzunehmen. Die Rollen waren sorgfältig sgewuchtet, so daß man die Geschwindigkeit der denwand in dem Generator auf 50 m/sec erhöhen nnte. Über die Grundplatte und der oberen Rolle rden Elektroden mit einem großen Krümmungslius angeordnet.

Der Generator wurde mit einer Fremderregung beben. Die Hochspannung wurde mit einer Kugelakenstrecke gemessen. Die maximale Spannung rug 500 kV. Bei einer vergrößerten Funkenstrecke olgten Durchschläge von der oberen zu der unteren aktrode. Bei einer Spannung von 450 kV betrug mittlere Entladungsstrom über eine Funkenscke 0,25 mA. Eine kleine Zugabe von CCl₄-Dampf wirkte einen Stromanstieg bis 0,3 mA. Die Eignung runden Kunststoffschnüre für den Transport der ktrischen Ladungen in Bandgeneratoren dürfte man erwiesen betrachten können.

Die Stromverteilung auf der laufenden Fadenwand und der rotierenden Rolle

Von dem Sprühkamm K_0 fließt auf die erste Rolle Strom I_{sp} . Ein Teil von den Ladungen werden ich die laufende Fadenwand nach der zweiten Rolle nsportiert, der Rest fließt durch den Abnahmenm K_5 ab.

Bei einer glatten Rolle ohne Fadenwand fließen r den Kamm K_5 soviel Ladungen ab wie auf die ntelfläche von dem Kamm K_0 gelangen. Ist der omkreis bei K_5 unterbrochen, so fließen die Langen von K_0 nur so lange, bis die Spannungserenz zwischen dem Sprühgerät und der Mantelbe gleich der Löschspannung der Sprühstrecke $-U_M = U_{L\bar{o}}$ ist. Auf dem Außenmantel befindet eine Ladungsmenge

$$Q = U_M \cdot \frac{\varepsilon_2 \varepsilon_0 2\pi l}{\ln r_1/r_0}, \tag{9}$$

m l die Länge der Rolle, ε_2 die Dielektrizitätsstante des Isoliermaterials der Mantelfläche, ler Außen- und r_0 der Innenradius bedeuten. Ist Isolierschicht $r_1-r_0=a$ dünn, bzw. das Verhältnis

 $a/r_0 \ll 1$, so kann man auch schreiben

$$Q = U_M \frac{\varepsilon_2 \varepsilon_0 2\pi r_1 l}{a}. \tag{10}$$

Die Ladungsdichte auf dem Außenmantel ist

$$\sigma_M = U_M \cdot \frac{\varepsilon_2 \, \varepsilon_0}{a} \tag{11}$$

der Spannung proportional. Bei einer konstanten Umlauffrequenz ist der über die Rolle fließende Strom

$$I = U_{M} \cdot \frac{\varepsilon_{2} \varepsilon_{0} 2\pi \nu lr}{a}$$
 (12)





Abb. 3a u. b. a Versuchsmaschine; b Teilausschnitt aus dem Transportsystem

der Spannung $U_{M}=U_{sp}-U_{L\bar{o}}$ proportional. Den Faktor

$$R = \frac{U_M}{I} = \frac{a}{\varepsilon_2 \, \varepsilon_0 \, 2 \, \pi \, \nu \, l \, r} \tag{13}$$

kann man auch als Ohmschen Widerstand auffassen, deren Wert durch Veränderung der Umlaufsfrequenz bequem verändert werden kann.

In Abb. 4 ist der Sprühstrom in Abhängigkeit von der Sprühspannung aufgetragen. Von einer Spannung ab 7,6 kV steigt der Strom linear, wie zu erwarten ist, mit der Spannung an. Aus der Steilheit der Kurve ergibt sich der Widerstand der rotierenden Rolle und der Fadenwand von etwa 25 $M\Omega$.

Die Stromaufteilung ist der Abb. 5 zu entnehmen. Aufgetragen sind die Verhältnisse $I_F|I_{sp}=\alpha_F$ und $I_R|I_{sp}=\alpha_R$ als Funktion der Sprühspannung. I_F bedeutet der von der Fadenwand transportierte, I_R der über die Rolle abfließende Strom. Es ergibt sich, daß

$$\alpha_F + \alpha_R = 1 \tag{14}$$

ist, wie zu erwarten war. Die Streuung der Meßwerte scheint von der Reibungselektrizität hervorgerufen worden zu sein, deren Anteil nicht eliminiert war. Sie könnten auch durch Störungen bei der Ladungsabnahme verursucht worden sein.

Der von der Fadenwand transportierte Anteil des Sprühstromes steigt zuerst mit einer steigenden Sprühspannung an, erreicht das Maximum und fällt wieder

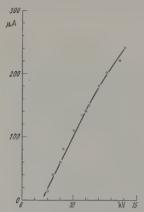
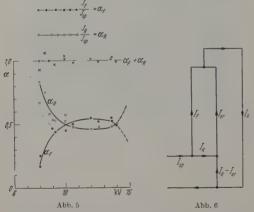


Abb. 4. Sprühstrom auf der unteren Rolle

ab. Der Durchgang durch das Maximum ist flach. Bei den vorhandenen Versuchsbedingungen ist der optimale Kurzschlußbetrieb zwischen einer Sprühspannung von 10 bis $14~\mathrm{kV}$.



Abb, 5. Die relative Stromverteilung auf der Fadenwand und der Rolle I in Abhängigkeit von der Spannung am unteren Ladekamm $K_{\mathfrak{g}}$

Abb. 6. Ersatzschema der Ströme in der Versuchsanordnung. $I_F = \alpha_F I_{sp}$; $I_R = \alpha_R I_{sp}$; $I_{er} = \gamma I_{sp}$; $I_R = \delta I_{sp}$; $I_R - I_{or} = \beta I_{sp}$; $\alpha_F + \alpha_R = 1$; $\delta + \beta = 1$

Werden die von der Fadenwand nach der zweiten Rolle transportierten Ladungen dem Innenbelag der zweiten Rolle zugeführt, so entsteht eine Spannungsdifferenz zwischen dem Innenbelag und dem Kamm K_3 . Verbindet man den Kamm K_3 mit der Grundplatte, so fließt ein Strom I_K zwischen Kamm K_3 und der Grundplatte. Die ablaufende Fadenwand wird bei dieser Schaltung mit Ladungen entgegengesetzter Polarität belegt. Demzufolge fließen die von den beiden Fadenwänden transportierten Konvektionsströme in eine Richtung. Das Ersatzschema der Ströme ist in

Abb. 6 wiedergegeben. Mit I_{er} ist der von der ablaufenden Fadenwand transportierte Strom bezeichnet, der von der Selbsterregung an der zweiten Rolle hervorgerufen wird.

Der Erregungsstrom I_{er} fließt in einer entgegengesetzten Richtung wie I_R . Sind die Abnahmekämme K_4 und K_5 durch ein Meßinstrument mit der Grundplatte verbunden, so zeigt das Instrument die Stromdifferenz $I_R - I_{er}$ an.

Auf der Ordinate in Abb. 7 sind die Größen

$$\frac{I_R-I_{er}}{I_{sp}}=\beta; \quad \frac{I_{er}}{I_{sp}}=\gamma; \quad \frac{I_k}{I_{sp}}=\delta \qquad (15)$$

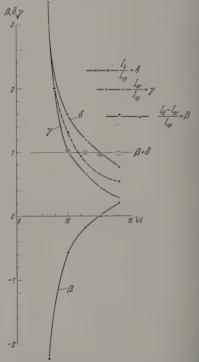


Abb. 7. Stromtransport durch auf- und ablaufende Fadenwand. Das Sprühgerät wird durch den Selbsterregungsstrom der oberen Rolle II nicht belastet

auf der Abszisse der Sprühspannung aufgetragen. Zwischen α , β γ und δ bestehen folgende Beziehungen

$$\begin{cases}
\beta = \alpha_R - \gamma \\
\delta = \alpha_F + \gamma
\end{cases}$$
(16)

Von hier folgt, daß

$$\beta + \delta = 1 \tag{17}$$

ist, was auch experimentell bestätigt wird.

Nach der Beziehung (15) beträgt der Kurzschlußstrom $I_k = I_{sp} \cdot \delta$. Der Faktor δ besteht aus zwei Summanden $\delta = \alpha_F + \gamma$. α_F ist durch die Sprühspannung festgelegt. Nimmt man an, daß der Erregungsstrom $I_{e\tau}$ in der Versuchsanordnung von sich aus auf dem maximalen Wert von etwa 130 μ A einstellt, so wären für γ die Werte zu erwarten, die in Abb. 7 durch die gestrichelt aufgetragene Kurve, gegeben sind. Die gemessenen Werte, besonders bei einer

öheren Sprühspannung sind erheblich kleiner. Das eutet darauf hin, daß bei einer höheren Sprühspanung, die auf den Innenbelag der zweiten Rolle ießenden Ladungen eine zu hohe Erregungsspannung zeugen. Die Umladung erfolgt nicht in dem optitalen Arbeitsbereich der Rolle.

Bei einer Sprühspannung von 14 kV war für γ ein setrag von etwa 0,5 zu erwarten. Da bei 14 kV auch $\gamma = 0,5$ beträgt, war für δ ein Wert von $\delta = 1$ zu erarten. Gemessen wurde $\delta = 0,8$. Statt eines Kurzhlußstromes von 0,24 mA, der zu erwarten war, urde ein Strom von 0,19 mA gemessen. Der Areitspunkt der zweiten Rolle ist besser einzustellen.

Zusammenfassung

Der Transport von elektrischen Ladungen in ektrostatischen Maschinen durch runde Kunststoffinnüre wird beschrieben. Die Stromverteilung in dem ransportsystem ist untersucht und geklärt worden. s wurde gezeigt, daß man eine Ladungsdichte von $6\cdot 10^{-9}\,\mathrm{Asec/cm^2}$ bis $4\cdot 10^{-9}\,\mathrm{Asec/cm^2}$ erreichen kann, obei der Querschnitt des Fadens als Bezugsfläche wählt ist. Dieser Wert stimmt recht gut mit dem teoretisch ermittelten Betrag überein, wenn man für ie Durchschlagfeldstärke der Luft bei einem atmobhärischen Druck den Betrag von $30\,\mathrm{kV/cm}$ einsetzt.

Eine kleine Versuchsmaschine ist beschrieben woren. Die Fadenwand, die zu dem Transport benutzt wurde, bestand aus 84 Perlonfäden mit einem Durchmesser von 1 mm. Die Geschwindigkeit der Fadenwand betrug 50 m/sec. Bei einer Spannung von 450 kV wurde ein mittlerer Entladungsstrom über eine Funkenstrecke von 0.25 mA gemessen. Bei einer geringen Zugabe von $\mathrm{CCl_4}$ -Dampf konnte man den Entladungsstrom bis 0.3 mA steigern.

Herrn Professor Dr. H. RAETHER möchte ich für das entgegengebrachte Interesse an dieser Arbeit und für die Diskussionen meinen besten Dank aussprechen. Herrn Dipl.-Ing. K. Willutzki möchte ich für den Aufbau der Versuchsanordnung und der Versuchsmaschine sowie für die geführten Diskussionen an dieser Stelle danken. Herrn W. Zwaka möchte ich für die Beschaffung der Räume zur Durchführung der Arbeiten danken. Dem Hamburger Forschungsrat sowie der Bundesstelle für zivilen Bevölkerungsschutz habe ich für die finanzielle Unterstützung der Arbeit zu danken.

Literatur: [1] Graaff, van de: Phys. Rev. (2) 38, 1919 (1931). — [2] Kossel, W.: Z. Physik 111, 264 (1938). — [3] Kessler, J.: Ann. Phys. (6) 15, 496 (1955). — [4] Flammersfeld, A., u. G. Weber: Z. Naturforsch. 7a, 161 (1952). — [5] Ardenne, M. v.: Tabellen der Elektronenphysik, Ionenphysik und Übermikroskopie, Bd. II, S. 972. Berlin: VEB-Verlag der Wissenschaft 1956. — [6] Schumann, W.O.: Elektrische Durchbruchfeldstärke von Gasen. Berlin: Springer 1928.

Dr. Eduards Bailitis, Hamburg 19, Ottersbekallee 21

Beugung elektromagnetischer Wellen an rechteckigen Öffnungen in ebenen Metallschirmen

Von Hans Severin und Klaus Körper

Mit 14 Textabbildungen
(Eingegangen am 18. Juni 1960)

Die exakten Lösungsverfahren für elektromagnesche Beugungsprobleme sind auf einige wenige beuende Objekte beschränkt: Ihre Grenzfläche muß coordinatenfläche eines Koordinatensystems sein, in em die Maxwellschen Gleichungen separierbar sind]. Bei der Mehrzahl praktisch interessierender Beuungserscheinungen ist man auf Näherungsverfahren ngewiesen. Viele Abstrahlungs- und Ausbreitungsobleme der Mikrowellentechnik werden nach der aus er Optik bekannten Kirchhoffschen Methode behanelt [2]. Ein speziell für ebene Beugungsschirme agegebenes Verfahren [3], [4] hat sich bei der kreis-Irmigen und elliptischen Öffnung und bei der Kreistheibe im Vergleich mit experimentellen Ergebnissen bis 9] und der exakten Rechnung [10] gut be-'ährt, wenn die linearen Abmessungen größer als 2 bis Wellenlängen sind.

Im folgenden soll dieselbe Näherungsrechnung auf ichteckige Öffnungen in Metallschirmen angewendet ud die Ergebnisse mit entsprechenden Messungen reglichen werden. Der Fall der rechteckigen Beutingsfläche stellt insofern eine interessante Variante (x, als hier ein Seitenpaar des Rechtecks parallel, das idere senkrecht zum elektrischen Vektor der einfallen Welle orientiert werden kann. Da die Seitenlagen unabhängig voneinander geändert werden

können, ergibt sich die Möglichkeit, den Einfluß der verschieden "beleuchteten" Kanten auf das Beugungsfeld zu untersuchen. Seine Struktur hat wegen der in der Mikrowellentechnik verwendeten Hornstrahler, Linsen und Reflektoren von rechteckigem Querschnitt auch einiges praktisches Interesse.

Den Ausgangspunkt unserer Näherungsrechnung bilden die Formeln

$$2\pi \vec{E}_{P} = \frac{1}{ik} \operatorname{rot}_{P} \operatorname{rot}_{P} \iint \vec{df}_{Q} \times \vec{H}_{Q} \frac{e^{-ikr}}{r}$$

$$2\pi \vec{H}_{P} = -\operatorname{rot}_{P} \iint \vec{df}_{Q} \times \vec{H}_{Q} \frac{e^{-ikr}}{r} .$$

$$(1)$$

Sie gestatten, das elektromagnetische Feld \overrightarrow{E}_P , \overrightarrow{H}_P im Aufpunkt P aus der Tangentialkomponente des Magnetfeldes $(\overrightarrow{df}_Q \times \overrightarrow{H}_Q)$ auf einer ebenen Randfläche zu berechnen. Dabei bedeutet $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$ die Wellenzahl, und r den Abstand des Aufpunktes P vom Flächenelement df_Q der Randfläche. Die Integration ist über die ganze Ebene zu erstrecken. Hier bilden Schirm und beugende Öffnung die Randfläche. Da die Tangentialkomponente des Magnetfeldes nicht in der ganzen Schirmebene bekannt ist, können die strengen Formeln (1) nur approximativ angewendet

werden. Zwar kennt man in der Öffnung die Tangentialkomponente des Magnetfeldes, die exakt gleich der der einfallenden Welle ist. Hinter dem Schirm ist der Randwert jedoch unbekannt, und man setzt im Kirchhoffschen Sinne $\vec{df}_Q \times \vec{H}_Q = 0$. In dieser Näherung werden die Inte-

Abb. 1. Koordinaten von Aufund Quelipunkt. Öffnung in der Ebene z=0

alą × hą = 0. In dieser Näherung werden die Integrationen in (1) also nur über die Fläche F der beugenden Öffnung ausgeführt. Der vernachlässigte Beitrag der Schirmfläche, bezogen auf den der Öffnung, und damit die Ungenauigkeit dieser Näherung nehmen erfahrungsgemäß ab, wenn bei gegebener Wellenlänge die Öffnung größer wird.

Liegt die Blende in der Ebene z=0 eines kartesischen Koordinatensystems,

so ist der Abstand r des Beobachtungspunktes P(x, y, z) von einem Punkt $Q(\xi, \eta)$ der Öffnung

$$r = \sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + z^2}.$$
 (2)

Für eine in z-Richtung einfallende ebene Welle ist die Tangentialkomponente des Magnetfeldes in der Öffnung konstant. Liegt der E-Vektor der einfallenden

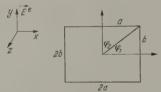


Abb. 2. Aufteilung des Integrationsbereiches für Aufpunkte längs der Mittelnormalen

Welle parallel zur y-Achse, dann bleibt von dem in (1) auftretenden Hertzschen Vektorpotential nur die y-Komponente

$$H = \frac{1}{4\pi^2} \frac{\lambda}{i} E_0 \iint\limits_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ikr}}{r} df_Q \tag{3}$$

übrig. Vom Beugungsfeld interessiert in erster Linie die Komponente, die in Richtung des *E*-Vektors der einfallenden Welle liegt. Man erhält sie nach (1) und (3) aus

$$E_y = k^2 \Pi + \frac{\partial^2 \Pi}{\partial u^2}.$$
 (4)

Nach Differentiation unter dem Integral, Einführung von Polarkoordinaten ϱ , φ und Integration über r findet man für Aufpunkte innerhalb des Zylinders mit F als Grundfläche [7]

$$\begin{split} \frac{E_{y}}{E_{0}} &= e^{-ikz} - \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} e^{-ikr_{0}} \times \\ &\times \left\{ 1 - \frac{i}{kr_{0}} + \left(3 \frac{i}{kr_{0}} - \frac{z^{2}}{r_{0}^{2}} \frac{i}{kr_{0}} - \frac{\varrho_{0}^{2}}{r_{0}^{2}} \right) \sin^{2}\varphi \right\} d\varphi, \end{split}$$
 (5)

wobei

$$r_0(\varphi) = \sqrt{\varrho_0^2(\varphi) + z^2}$$

$$= \sqrt{(x - \xi_0)^2 + (y - \eta_0)^2 + z^2}$$
(6)

und ξ_0 , η_0 die Koordinaten des Randes der Öffnung bedeuten (Abb. 1).

Bei der nun folgenden Anwendung von (5) auf eine rechteckige Öffnung mit den Seiten parallel zur x-und y-Achse beschränken wir uns auf gewisse Symmetrielinien, um den Aufwand bei der späteren numerischen Auswertung in erträglichen Grenzen zu halten. Auf der Mittelnormalen des Rechtecks haben E- und H-Feld dieselbe Richtung wie in der einfallenden Welle [11]. Daher ist in diesem Fall die Komponente E_y identisch mit dem Gesamtfeld E. Bezeichnen 2a und 2b die Längen der Rechteckseiten parallel zur x-und y-Achse (Abb. 2), so folgt aus (5) für Punkte der Mittelnormalen hinter der Öffnung (d.h. längs der Geraden x = y = 0, z > 0):

$$\begin{split} &\frac{E}{E_0} = e^{-ikz} - \\ &- \frac{1}{\pi} \int\limits_0^{\varphi_1} e^{-ikr_{01}} \left\{ 1 + \frac{z^2}{r_{01}^2} + \frac{i}{kr_{01}} \frac{\varrho_{01}^2}{r_{02}^2} \right\} d\varphi - \\ &- \frac{1}{\pi} \int\limits_0^{\varphi_2} e^{-ikr_{01}} \left\{ 1 + \frac{z^2}{r_{02}^2} + \frac{i}{kr_{02}} \frac{\varrho_{02}^2}{r_{02}^2} \right\} d\varphi + \\ &+ \frac{1}{\pi} \int\limits_0^{\varphi_1} e^{-ikr_{01}} \left\{ 3 \frac{i}{kr_{01}} - \frac{z^2}{r_{01}^2} \frac{i}{kr_{01}} - \frac{\varrho_{01}^2}{r_{01}^2} \right\} \cos 2\varphi \, d\varphi - \\ &- \frac{1}{\pi} \int\limits_0^{\varphi_2} e^{-ikr_{02}} \left\{ 3 \frac{i}{kr_{02}} - \frac{z^2}{r_{02}^2} \frac{i}{kr_{02}} - \frac{\varrho_{02}^2}{r_{02}^2} \right\} \cos 2\varphi \, d\varphi \end{split}$$

$$\begin{aligned} & \text{mit} \\ & \varrho_{01} = \frac{a}{\cos \varphi}; \ r_{01} = \sqrt{\varrho_{01}^2 + z^2}; \ \ \varphi_1 = \arctan \frac{b}{a} \\ & \varrho_{02} = \frac{b}{\cos \varphi}; \ r_{02} = \sqrt{\varrho_{02}^2 + z^2}; \ \ \varphi_2 = \arctan \frac{a}{b} = \frac{\pi}{2} - \varphi_1 \end{aligned}$$

Da Gl. (7) für beliebige Werte von a und b gilt, kann entweder die längere oder die kürzere Rechtecksette parallel zur Polarisation der einfallenden Welle, d.h. parallel zur y-Achse genommen werden. Eine Vertauschung der Zahlenwerte von a und b sowie von q_1 und φ_2 in (7) entspricht offenbar einer Drehung des Rechtecks um $\pi/2$. Daher unterscheiden sich die beiden Fälle nur durch das Vorzeichen der beiden Integrale mit $\cos 2\varphi$ im Integranden, was für die spätere numerische Auswertung günstig ist. Bei der quadratischen Öffnung (a=b); $\varphi_1=\varphi_2=\pi/4$ heben sich diese Glieder weg, und (7) vereinfacht sich zu

$$\frac{E}{E_0} = e^{-ikz} - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/4} e^{-ikr_0} \left\{ 1 + \frac{z^2}{r_0^2} + \frac{i}{kr_0} \frac{\varrho_0^2}{r_0^2} \right\} d\varphi. \quad (8)$$

Auch für den Mittelpunkt der rechteckigen Öffnung $(z=0,\,r_0=\varrho_0)$ ergibt sich aus (7) nach einigen elementaren Umformungen ein wesentlich einfacherer Ausdruck

$$\frac{E}{E_0} = 1 - \frac{2}{\pi} \int_0^{\varphi_1} e^{-i\frac{ka}{\cos\varphi}} d\varphi - \frac{2i}{\pi} \frac{1}{kb} \int_0^{\varphi_1} e^{-i\frac{kb}{\cos\varphi}} \cos\varphi \, d\varphi. \tag{9}$$

An dieses Ergebnis knüpfen wir bei der Berechnung des Feldes entlang der beiden Mittellinien des Rechtecks an. Der einzige Unterschied bei der Berechnung des Integrals (5) besteht darin, daß die rechteckige Öffnung durch die Lage des Aufpunktes jetzt nicht mehr in vier gleiche, sondern in zweimal zwei gleiche

ilrechtecke zerlegt wird (Abb. 3). Im übrigen erhält in nach ganz analoger Rechnung wie oben

tlang der x-Achse

$$\left\{ \begin{array}{l} = 1 - \\ 1 \int_{\sigma}^{\varphi_{t}} e^{-i\frac{k(a-x)}{\cos\varphi}} d\varphi - \frac{i}{\pi} \frac{1}{kb} \int_{0}^{\varphi_{z}} e^{-i\frac{kb}{\cos\varphi}} \cos\varphi d\varphi - \\ 1 \int_{\sigma}^{\psi_{t}} e^{-i\frac{k(a+x)}{\cos\varphi}} d\varphi - \frac{i}{\pi} \frac{1}{kb} \int_{0}^{\psi_{z}} e^{-i\frac{kb}{\cos\varphi}} \cos\varphi d\varphi \end{array} \right\} (10)$$

od entlang der y-Achse

$$=1-\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\varphi_{i}}e^{-i\frac{ka}{\cos\varphi}}d\varphi -$$

$$-\frac{i}{\pi}\frac{1}{k(b-y)}\int_{0}^{\varphi_{i}}e^{-i\frac{k(b-y)}{\cos\varphi}}\cos\varphi\,d\varphi -$$

$$-\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\psi_{i}}e^{-i\frac{ka}{\cos\varphi}}d\varphi -$$

$$-\frac{i}{\pi}\frac{1}{k(b+y)}\int_{0}^{\psi_{i}}e^{-i\frac{k(b+y)}{\cos\varphi}}\cos\varphi\,d\varphi.$$
(11)

As Symmetriegründen hat das E-Feld in der H-Ebene (=0) und damit längs der x-Achse nur eine y-Kompoente; in der E-Ebene (x=0) ist noch eine Kompoente $E_z \neq 0$ möglich [11], jedoch ist für alle Punkte böffnung F die Normalkomponente von E gleich der it einfallenden Welle, d.h. in unserem Fall $E_z = 0$ \mathbb{P}^p . Daher ist längs des in der Öffnung liegenden Abfirtt der y-Achse E_y ebenfalls die Gesamtfeldstärke.

Keines der in den Ergebnissen (7) bis (11) auftreden Integrale läßt sich geschlossen auswerten. Sie

den daher durch Planimetrieren gewonnen. Die der Berechnung des Feldes auf der Mittelnormalen 17) auftretenden sechs Integrale lassen sich in zwei appen zu je drei ordnen, von denen die eine aus der ^eeren durch Multiplikation der Integranden mit dem tor $\frac{\cos 2\,\varphi}{\cos 2\,\varphi}$ oder $r_0\cos 2\,\varphi$ hervorgeht. Die komken Integranden werden in Real- und Imaginärteil rgespalten, deren Verlauf für feste z-Werte als Funk- ψ von φ in dem durch die Seitenlängen des Rechtbestimmten Intervall $0 \le \varphi \le \varphi_{1,2}$ gezeichnet und Kurven planimetriert. Bei einer rechteckigen Öffug mit $2a = 6\lambda$ und $2b = 4\lambda$ erwiesen sich 25 vercledene z-Werte als ausreichend, um den Verlauf von I längs der Mittelnormalen genau genug wiederzu-Men (Abb. 4). Die Auswahl geeigneter z-Werte wurde Richtert durch den für dasselbe Rechteck von Sten-E berechneten Potentialverlauf $|\Pi|$, der den Schallrek vor einer rechteckigen Kolbenmembran im unnlichen schallharten Schirm darstellt [12]. Mit den oiegenden numerischen Ergebnissen konnte ferner a Feld auf der Mittelnormalen der quadratischen flungen mit $2a = 4\lambda$ und 6λ angegeben werden 16. 5 und 6).

3ei der Berechnung des Feldes im Mittelpunkt der teckigen Öffnung wurde für drei feste Werte der na Rechteckseite (Länge $=2\lambda, 3\lambda, 4\lambda$) die Länge underen kontinuierlich zwischen 0.4λ und 4λ varit Dies geschah mit a und b, um wieder den Einfluß

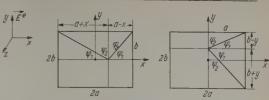


Abb. 3. Aufteilung des Integrationsbereiches durch Aufpunkte längs der z- oder y-Achse

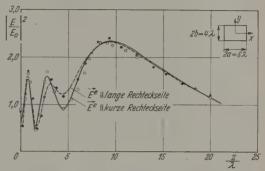


Abb. 4. Mittleres relatives Amplitudenquadrat der elektrischen Feldstärke auf der Mittelnormalen der rechteckigen Öffnung mit den Seitenlängen 6 λ und 4 λ , für beide Polarisationsrichtungen, berechnet (———, ———) und gemessen (O, •)

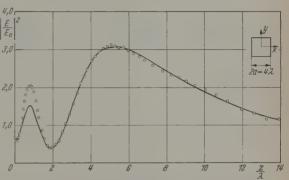


Abb. 5. Mittleres relatives Amplitudenquadrat der elektrischen Feldstärke auf der Mittelnormalen hinter einer quadratischen Öffnung der Seitenlänge $2a=4\lambda$, gerechnet (———) und gemessen (O.

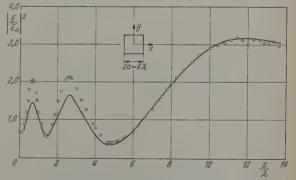
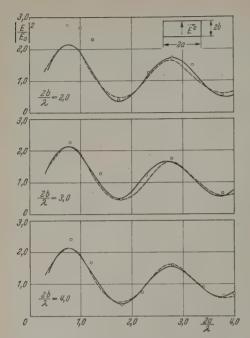


Abb. 6. Mittleres relatives Amplitudenquadrat der elektrischen Feldstärke auf der Mittelnormalen hinter einer quadratischen Öffnung der Seitenlänge $2a=6\lambda_1$ gerechnet (——) und gemessen (O)

der Polarisation untersuchen zu können. Bei der Auswertung von (9) erscheint die unabhängige Variable a oder b diesmal auch in der oberen Grenze φ_1 und φ_2 der Integrale. Daher wurden Real- und Imaginärteil



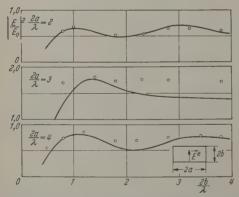


Abb. 8. Mittleres relatives Amplitudenquadrat der elektrischen Feldstärke im Mittelpunkt einer rechteckigen Öffnung in Abhängigkelt von der Länge der zum E-Vektor der einfallenden Welle senkrechten Seite, gerechnet (——) und gemessen (O). (Beachte die Unterdrückung des Ordinatennullpunktes bei der mittleren Figur!)

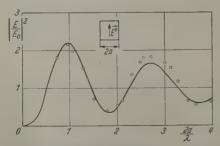


Abb. 9. Mittleres relatives Amplitudenquadrat der elektrischen Feldstärke im Mittelpunkt einer quadratischen Öffnung in Abhängigkeit von der Seitenlänge, gerechnet (———) und gemessen (○)

der beiden Integranden zunächst in einem hinreichend großen Bereich von φ für die Werte a/λ und $b/\lambda=0.1$; 0.2; 0.3... 2.0 berechnet. Dann können die Kurven für jedes gewünschte Wertepaar a,b von Null bis zu der aus (7) ersichtlichen oberen Grenze $\varphi_{1,2}$ planimetriert werden. Abb. 7 und 8 zeigen die Ergebnisse für die rechteckige, Abb. 9 für die quadratische Öffnung.

Bei der Berechnung des Feldes auf den Symmetriclinien des Rechtecks kann man im Prinzip genauso verfahren. Das geht unmittelbar aus dem Vergleich von (10) und (11) mit (7) hervor. Anstelle von zwei Integralen hat man jetzt, bedingt durch die Lage des Aufpunktes, vier mit (a+x) und (a-x) sowie (b+y) und (b-y) als unabhängige Veränderliche im Integranden und in der oberen Grenze der Integrale. Die numerischen Rechnungen wurden wieder für das Rechteck mit den Seitenlängen 6λ und 4λ ausgeführt. Die sich ergebende Feldverteilung ist in Abb. 10 und 11 dargestellt, Abb. 12 zeigt das Feld längs der Mittellinien der quadratischen Öffnung mit $2a=4\lambda$.

Frühere experimentelle Untersuchungen über Beugungserscheinungen elektromagnetischer Wellen an kreisförmigen Öffnungen [5] wurden bei einer Wellenlänge von $\lambda=10$ cm im Freien durchgeführt. In mancher Hinsicht angenehmer ist das Arbeiten mit kürzeren Wellenlängen. Dann werden die verwendeten Apparaturen (Hornantenne des Senders, Beugungsschirm) kleiner und handlicher, der Abstand zwischen Sender und beugender Öffnung geringer und das Arbeiten in geschlossenen Räumen möglich.

Mit abnehmender Wellenlänge besteht die Hauptschwierigkeit in der Verwirklichung der Forderung. daß die linearen Abmessungen des Empfängers klein zur Wellenlänge sind. Einmal muß man nämlich Verzerrungen des zu messenden Feldes durch den Meßdipol selbst vermeiden. Zum anderen zeigt der Empfänger stets nur einen integralen Mittelwert des Feldes über eine den Dipolabmessungen entsprechende Fläche an; die Ausmessung eines stark gegliederten Interferenzfeldes, wie es in der Nähe einer beugenden Öffnung zu erwarten ist, erfordert daher eine möglichst kleine Dipollänge. Frühere experimentelle Untersuchungen von Herrn Dr. H.-J. SCHMITT an verschiedenen Empfängertypen zeigen, daß bis zu einer Dipollänge von $\lambda/3$ sich keine Änderung der Meßergebnisse ergibt und daß der Empfänger bei dieser Länge eine ausreichende Anzeigeempfindlichkeit besitzt. Bei der hier benutzten Ausführungsform ist der Dipol 7,5mm lang und an eine dünne Koaxialleitung (Außendurch messer 2,5 mm) angelötet. Die Abstimmung erfolgt am anderen Ende der dort dickeren Koaxialleitung in der Nähe der Diodenhalterung.

Sämtliche Messungen wurden bei einer Wellenlänge von $\lambda=3,2$ cm im großen reflexionsfreien Raum des Instituts [13] ausgeführt. Als Sender stand ein Reflexklystron $2\,\mathrm{K}\,25\,$ zur Verfügung, das eine HF-Leistung von etwa 30 mW abgibt und mit elektronisch stabilisierter Strahl- und Reflektorspannung betrieben wurde. Die Abstrahlung erfolgte über ein an den Hohlleiter angeschlossenes Rechteckhorn. Um am Ort der beugenden Öffnung die der Rechnung zugrunde liegende ebene Welle weitgehend zu approximieren wurde der Abstand zwischen Hornöffnung und Beugungsschirm so groß gewählt, wie es Senderleistung und Empfängerempfindlichkeit zuließen, nämlich 6 m

 $(190\,\lambda)$. Der Schirm bestand aus 2 mm starkem uminiumblech und war 2×2 m² groß. In der Mitte tte er eine Öffnung von 40×40 cm², in die die zu tersuchenden Blenden, ebenfalls aus Aluminiumsch, eingefügt werden konnten. Die Verwendung

rschiedener Blechstärken (0,5 und nm) ergab keine meßbaren Unterniede im Beugungsfeld. Der Empngsdipol konnte durch eine geeignete Iterung und Führung hinter und in röffnung in x-, y-, und z-Richtung rschoben werden. Das Klystron rde durch eine rechteckförmige Rektorspannung amplitudenmoduliert, an der Diode entstehende niederquente Spannung über Resonanzstärker und Röhrenvoltmeter an- 2,000 eigt.

Die Ausmessung des Feldes erfolgte inktweise. Die Amplitude E_0 der eindenden Welle in der Öffnung wurde rter Ausnutzung des exakt bekannten ldes hinter der kreisförmigen Offing vom Durchmesser $d = 3,18 \lambda$ bemmt. Das erste Maximum des Felauf der Mittelnormalen hat den Fort $|E/E_0|^2 = 2.75$ [10]; durch Ausssung seiner Höhe findet man E_0 . gen verbleibender kleiner Unsicherten in der Justierung von Sender rl Empfangsdipol und stets vorndener geringer Störreflexionen wurh alle Messungen mehrmals für verniedene Aufbauten der Anlage und ler Orientierung zum Raum wiedert. Die in die Abbildungen eingeigenen experimentellen Werte $|E/E_0|^2$ id Mittelwerte aus diesen Messungen, en relativer Fehler bis zu $\pm 10\%$ eragen kann, was einen relativen hler von $\pm 5\%$ in der Amplitude beitet.

Der Vergleich der Meßergebnisse mit Näherungsrechnung zeigt eine recht riedigende Übereinstimmung beider, gesehen von dem Feldverlauf längs Symmetrielinie des Rechtecks, die krecht zum E-Vektor der einfallen Welle liegt. Dort sind die geseenen Interferenzmaxima wesentlich per als die berechneten (Abb. 10 12). Damit erweist sich unsere Nähengslösung auch im Falle der recht-

tigen Öffnung als brauchbar, wenn auch die Überistimmung bei der kreisförmigen Öffnung insgesamt iser ist.

Der Einfluß der Polarisation kommt besonders wilch in Abb. 7 und 8 zum Ausdruck. Wenn der Vektor der einfallenden Welle parallel zu den Rechtseiten ist, deren Abstand variiert wird, schwankt if Amplitude des Feldes im Mittelpunkt der Öffnung zu beträchtlich, und zwar um E_0 als Mittelwert. Für i andere Polarisation sind diese Feldschwankungen int sehr ausgeprägt, und der sich einstellende Mittel-

wert hängt vom jeweils festen Abstand der zu $\overrightarrow{E^{\varepsilon}}$ parallelen Rechteckseiten ab. Dieser Befund läßt sich anschaulich erklären durch die Annahme, daß das Feld in der Öffnung durch Überlagerung der einfallenden ebenen Welle und einer "Randwelle" zustande

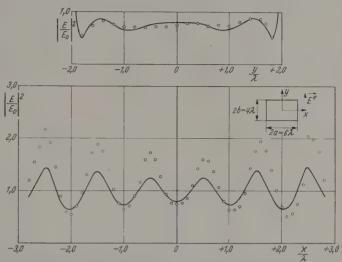


Abb. 10. Mittleres relatives Amplitudenquadrat der elektrischen Feldstärke längs der beiden Symmetrielinien der rechteckigen Öffnung mit den Seitenlängen 6 λ und 4 λ, gerechnet (——) und gemessen (⊙). E-Vektor der einfallenden Welle parallel zur kleineren Seite

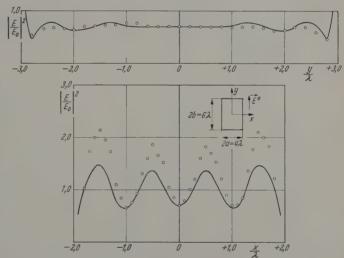


Abb. 11. Mittleres relatives Amplitudenquadrat der elektrischen Feldstärke längs der beiden Symmetriefinien der rechteckigen Öffnung mit den Seitenlängen 6 λ und 4 λ , gerechnet (——) und gemessen (O). E-Vektor der einfallenden Welle parallel zur größeren Seite

kommt und die Phase der Randwelle sich mit dem Abstand der Rechteckseiten vom Aufpunkt ändert. Nach Ausweis von Abb, 7, 8, 10 und 11 leisten die zum E-Vektor der einfallenden Welle senkrechten Seiten keinen wesentlichen Beitrag zur Randwelle und damit zum Feld. Dies kommt vor allem in der großen Ähnlichkeit der Kurven von Abb. 7 zum Ausdruck, die sich untereinander und von der entsprechenden Kurve für den unendlich langen Spalt 1 kaum unterscheiden.

¹ Das zweidimensionale Beugungsproblem wurde in gleicher Näherung gelöst wie das der rechteckigen Öffnung.

Bei dem zu Abb. 8 gehörigen Feldverlauf in der spaltförmigen Öffnung $(2a \rightarrow \infty)$ sind Feldschwankungen kaum noch wahrnehmbar und E/E_0 ist praktisch gleich 1. Abb. 13 zeigt den Einfluß jedes der beiden

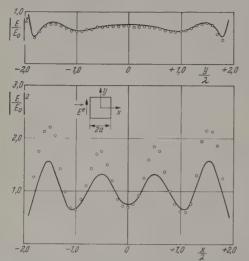


Abb. 12. Mittleres relatives Amplitudenquadrat der elektrischen Feldstärke längs der beiden Symmetrielinien der quadratischen Öffnung mit der Seitenlänge 2a – 4 Å. gerechnet (——) und gemessen (O)

Kantenpaare der rechteckigen Öffnung auf die Amplitude der Randwelle für beide Polarisationsrichtungen. Der Rechnung lag Gl. (9) zugrunde, wobei die einfallende Welle weggelassen wurde.

Zur Klärung der in Abb. 9 bis 11 auftretenden Abweichungen der Rechnung vom gemessenen Feldver-

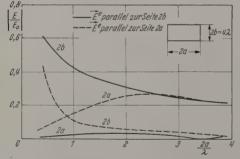


Abb. 13. Beiträge der beiden Kantenpaare der rechteckigen Öffnung zum Feld im Mittelpunkt der Öffnung für beide Polarisationsrichtungen

lauf wäre eine Näherung höherer Ordnung wünschenswert, wie sie z.B. von Braunbek [14] vorgeschlagen und auf akustische Beugungsprobleme mit Erfolg angewandt [15] worden ist. Dabei werden zur Verbesserung der Kirchhoffschen Näherung in einem an die Öffnungsbegrenzung anschließenden schmalen Saum Ersatzrandwerte benutzt, die der Sommerfeldschen strengen Lösung der Beugung an der vollkommen leitenden Halbebene entnommen werden. Dieses Verfahren wurde später auf elektromagnetische Wellen ausgedehnt und auf das Beugungsproblem der ideal leitenden Kreisscheibe und der kreisförmigen Öffnung angewandt [16]. Wir haben die entsprechende Rechnung für die rechteckige Öffnung nicht durchgeführt,

sondern uns mit dem numerisch einfacheren, das Wesentliche zeigenden Fall der Halbebene begnügt. Nach den obigen Ausführungen tragen praktisch nur die Kanten der rechteckigen Öffnung zum Beugungsfeld bei, die parallel zum E-Vektor der einfallenden Welle liegen. Daher sind die zwischen Näherungsrechnung und Messungen beobachteten Diskrepanzen in ähnlicher Weise auch bei nur einer Kante zu erwarten, wenrman also beim Halbebenenproblem die Näherungsrechnung mit der exakten Lösung vergleicht. Das ist in Abb. 14¹ geschehen [17], und die Abweichungen liegen tatsächlich in derselben Richtung wie in den

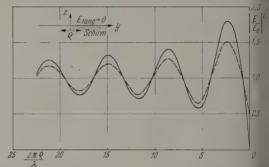


Abb. 14. Beugung an der vollkommen leitenden Halbebene. Feldverlauf im offenen Teil der Schirmebene, exakt (——) und näherungsweise (—) gerechnet. E-Vektor der einfallenden Welle parallel zur Schirmkante

Abb. 9 bis 11. Daß sie dem Betrage nach bei der rechteckigen Öffnung größer sind, mag an dem Vorhandensein von zwei Kanten liegen, deren Beiträge sich in den Interferenzmaxima addieren.

Zusammentassung

Die Beugung einer ebenen elektromagnetischen Welle an rechteckigen Öffnungen verschiedener Größe im vollkommen leitenden Schirm wurde untersucht. Messungen des Feldes im Mittelpunkt, längs der Mittelnormalen und den Symmetrielinien der rechteckigen Öffnung wurden zur Prüfung eines bekannten Näherungsverfahrens herangezogen. Dieses hatte sich bereits bei kreisförmigen Öffnungen bewährt und erweist sich nunmehr auch für rechteckige Öffnungen als brauchbar, wenn die linearen Abmessungen größer als 2 bis 3 Wellenlängen sind. Es zeigt sich, daß die zum E-Vektor der einfallenden Welle senkrechten Kanten des Rechtecks praktisch keinen Einfluß auf die Struktur des Beugungsfeldes haben. Dieses Ergebnis mag von einigem praktischen Interesse für rechteckige Umlenkspiegel sein. Es wäre interessant zu untersuchen. wie sich das Interferenzfeld ändert, wenn man einen Saum an den Kanten, die parallel zum E-Vektor der einfallenden Welle liegen, mit einem geeigneten Dämpfungsmaterial belegt.

Die Arbeit wurde in den Jahren 1954/55 im III. Physikalischen Institut der Universität Göttingen unter Contract No. AF 61 (514)—799 des Air Research and Development Command, European Office, Brüssel ausgeführt. Herrn Prof. Dr. phil. Dr. Ing. e.h. E. Meyer danken wir für sein stets förderndes Interesse.

¹ Die numerische Auswertung hierfür besorgte Herr Dipl-Physiker F. Höring.

Literatur: [1] Franz, W.: Theorie der Beugung elektrognetischer Wellen. In: Erg. der angew. Math., Bd. 4, Berlin: ringer 1957. — [2] M.I.T.-Radiation Laboratory Series, .12 u. 13. New York: McGraw-Hill, 1949 u. 1951. — Severin, H.: Z. Physik 129, 426 (1951). — [4] Severin, H.: Nuovo Cim. Suppl. 9, 381 (1952). — [5] Severin, H.: Lurforsch. 1, 487 (1946). — [6] Andrews, C. L.: J. Appl. ys. 21, 761 (1950). — [7] Severin, H.: Z. angew. Phys. 499 (1950). — [8] Bereff, G.: J. Appl. Phys. 24, 1123 53). — [9] Buchsbaum, S. J., A. R. Milline, G. C. Hogg, Bekeff and G. A. Woonton: J. Appl. Phys. 26, 706 55). — [10] Andrejewski, W.: Z. angew. Phys. 5, 178 53). — [11] Severin, H.: Beugung elektromagnetischer llen an vollkommen leitenden symmetrischen Schirmen.

Göttingen 1954. Bisher nicht veröffentlicht. — [12] STENZEL, H.: Acustica 2, 263 (1952). — [13] MEYER, E., G. KURTZE, H. SEVERIN U. K. TAMM: Acustica 3, 409 (1953). — [14] BRAUNBEK, W.: Z. Physik 127, 381 (1950). — [15] BRAUNBEK, W.: Z. Physik 127, 405 (1950); 138, 80 (1954). — [16] FRAHN, W. E.: Z. Physik 156, 78, 99 (1959). — [17] SEVERIN, H.: Beugung elektromagnetischer Wellen an der vollkommen leitenden und an der absorbierenden Halbebene. Göttingen 1958. Bisher nicht veröffentlicht.

Prof. Dr. H. SEVERIN,
Philips Zentrallaboratorium, Hamburg
Dipl.-Phys. Dr. K. KÖRPER,
Max-Planck-Institut für Physik, München

Zur Herstellung von Siliziumeinkristallen nach dem Czochralsky-Verfahren

Von Gottfried Greger

Mit 11 Textabbildungen

(Eingegangen am 10. August 1960)

Einleitung

In der Halbleitertechnik werden an das einkristalAusgangsmaterial für Transistoren und hocherrende Gleichrichter besonders strenge Forderunn gestellt. Abgesehen von einem möglichst fehlertien Aufbau des Kristallgitters soll der spezifische
derstand längs und über den Querschnitt des Krills weitgehend der gleiche sein. Hinzu kommt die
rderung, daß das Material frei sein soll von unliebnen Störstoffen, die die Lebensdauer der Minoritätsger ungünstig beeinflussen oder bei Wärmebehandigen, wie sie später im Verarbeitungsprozeß unervorrufen.

Im folgenden wollen wir uns mit den bei der Herflung von Kristallen hoher Qualität auftretenden belemen und den Möglichkeiten, sie zu lösen, näher schäftigen. Wir beschränken uns dabei auf das von CHRALSKY angegebene Ziehverfahren von Einstallen: Das in einem geeigneten Tiegel erschmolzen Material wird so weit abgekühlt, daß ein Keim in Schmelze eingetaucht werden kann. Während des Ichließenden langsamen Herausziehens, zumeist tierend, wächst das Material beim Erstarren einstallin am Keim an und die Schmelze wird in einen toförmigen Einkristall übergeführt.

Experimentelles

Experimentelle Anordnungen zum Ziehen von kristallen zeigen die ersten beiden Abbildungen. Unterschiede sind lediglich durch die Heizvorrichgen bedingt. Abb. 1 gibt eine Ziehvorrichtung für chfrequenzheizung wieder, wie sie allgemein veridet wird. Es bestehen dabei zwei Möglichkeiten: HF-Energie kann direkt die Schmelze aufheizen d damit auch gleichzeitig einen gewissen Rührkt bewirken. Dieses Verfahren soll im folgenden (A1) bezeichnet werden. Umständlich ist hierbei glich der Zündvorgang. Da das Material in kaltem tand zu hochohmig ist, muß es auf andere Weise bis in den Eigenleitungsbereich erhitzt werden, or die HF-Heizung wirksam wird. Diese Schwieeit umgeht man durch Umkleidung des Schmelzels mit einem Graphitmantel hoher Reinheit,

dessen Leitfähigkeit zum "Zünden" ausreicht (Verfahren A2 der Abb.1). Das dritte Verfahren (A3) beruht auf Widerstandsheizung: ein stromdurchflossener Graphitkörper geeigneter Formgebung [1] wird auf die nötige Temperatur gebracht (Abb. 2).

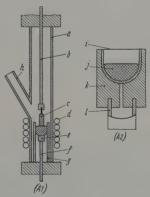


Abb. 1. Schematische Darstellung einer Kristallziehanlage mit Hochfrequenzheizung. (A1) ohne, (A2) mit Graphitmantel. a Quarzrohr, b Welle mit Keimhalter, c Kristall, d Heizspule, wassergekühlt, e Graphitsupport, entfernbar, f Keramikstütze, g Quarzrohr zur Tiegelhalterung, h Einblickstutzen, i Quarztiegel, j Schmelze, k Graphitmantel, l Koramikhalterung

Alle drei Verfahren können unter Schutzgas (Wasserstoff oder Argon), aber auch im Hochvakuum durchgeführt werden. Die Einkristalle werden vorzugsweise in (111)-Richtung gezogen. Von entscheidender Bedeutung ist die Wahl des Tiegelmaterials, das sich der Schmelze gegenüber inert verhalten soll. Bislang hat sich nur hochreiner Quarz als brauchbar erwiesen. Selbst dieses Material wird jedoch merklich durch die sehr reaktionsfreudige Schmelze aufgelöst nach der Reaktionsgleichung:

Si (flüssig) + SiO₂ (fest) = 2 SiO (gasförmig bei Schmelzpunkt des Siliziums).

Die Prüfmethoden

Um bei unseren Untersuchungen den Einfluß der Ziehbedingungen auf die Qualität der Kristalle studieren zu können, wurden die nachfolgend erwähnten Prüfmethoden für das einkristalline Silizium angewendet. Die Homogenität des Widerstandes der gezogenen Einkristalle kann durch die bekannte 2-oder 4-Sondenmethode überprüft werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, eventuelles nichtohmsches Verhalten des Materials zu messen, da dieses

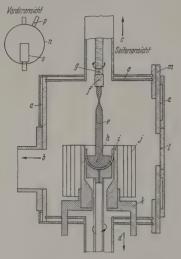


Abb. 2. Schematische Darstellung einer Kristallziehanlage mit Widerstandsheizung (43) für Arbeiten im Hochvakuum, a Wasserkühlung, b zur Diffusionspumpe, e zur Dreh- und Ziehvorrichtung, d zur Drehvorrichtung für den Tiegel, e Kristall, f Keimhalter, g Weile, h Tiegel mit Schmeilze, e Graphitheizer (in Wendelform), j Strahlungsschirmbleche, k wassergekühlte Stromzuführungen, l Quarzfenster, m Abschlußdeckel, n äußerer gekühlter Mantel, o Tiegel- und Heizeranordnung, p Einblickstutzen mit Quarzfenster

über das Vorhandensein von Stellen anderen Leitfähigkeitstyps Aufschluß gibt. Von Interesse sind weiterhin Potentialmessungen, bei denen eine Sonde

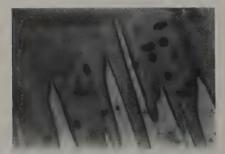


Abb. 3. Mit Dash-Lösung angeätzter Längsschliff eines in H₂ gezogenen Si-Kristalls. Die dunklen Streifen (Randzone) deuten p-leitendes, sauerstofffreies Material an (mit einzelnen "etch-pits"). Das helle Gebiet (Innenbereich) ist n-leitend. 200fach vergrößert

festgehalten und die zweite längs des Kristalls bewegt wird. Bei homogener Widerstandsverteilung ist ein stetiger Anstieg der Spannung zu erwarten.

Der Leitfähigkeitstyp kann beispielsweise durch Thermokraftmessungen an der leicht angeschmirgelten Oberfläche des Kristalls ermittelt werden.

Sind Dotierungsschwankungen auf den Gehalt an Sauerstoff zurückzuführen, so kann deren Nachweis durch Ätzen erfolgen [2].

Zur Prüfung der Versetzungsdichte wurde die von Dash angegebene Ätzmethode mit einem CH₃COOH— HNO₃—HF-Gemisch verwendet [3]. Nähere Ausführungen über die Anwendbarkeit dieser Methode können der Literatur [4] entnommen werden¹.

Die Orientierung des Kristalls oder die verschiedenen Bereiche bei Orientierungsänderung wurden durch Anätzen mit NaOH oder KOH unter Zuhilfenahmeeines Theodolithgoniometers festgelegt.

Methoden zur Erreichung homogener Widerstandsverteilung

Der Ziehprozeß muß im Hinblick auf die erforderliche Reinheit und die hohe Schmelztemperatur des Siliziums (1420°C) im Hochvakuum oder in einer inerten Gasatmosphäre definierter Zusammensetzung erfolgen. Das ist notwendig, um die Schmelze von Verunreinigungen, wie etwa Sauerstoff, frei zu halten. Kaiser und Breslin [13] stellten durch Versuche mit in hochreinen Siliziumstäben aufgeschmolzenen Zonen fest, daß zwischen dem Sauerstoffpartialdruck im Schutzgas p_0 , und der Sauerstoffkonzentration in der Schmelze C_0 die folgende Beziehung besteht:

$$C_{\text{O Schmelze}} = K \cdot p_{\text{O}_2}$$
.

Diese Proportionalität gilt bis zu einem Partialdruck von etwa 8 Torr. Bei höheren Drucken wird die Sättigungskonzentration erreicht und die Schmelze überzieht sieh mit einer Oxydschicht. Der Verteilungskoeffizient $k = C_{\rm fest}/C_{\rm flüssig}$ ist etwa 1. Naheliegend als Schutzgas sind nachgereinigter Wasserstoff und Argon. Stickstoff seheidet wegen Nitritbildung (Si $_3$ N $_4$) bei der hohen Temperatur aus. Es soll zunächst über Ergebnisse mit H $_2$ berichtet werden.

Die in H₂ gezogenen Kristalle wiesen in den meister Fällen kein ohmsches Verhalten auf. Wurde eine Sonde festgehalten und die zweite längs des Kristalls verschoben, so müßte ein stetiger Spannungsanstieg festzustellen sein, was jedoch nicht der Fall war.

Die Vermutung, daß in diesem Fall eine p-n-Querstruktur die Ursache sein konnte, wurde durch Atzversuche an einem Längsschliff bestätigt. Das hochohmige p-Material wurde von n-leitenden Streifen durchzogen, wie sich ebenfalls direkt durch Typbestimmung zeigen ließ. Wir machten dabei die überraschende Feststellung, daß solche Kristalle zumeist nur eine p-leitende Randschicht schwankender Dicke besaßen, während der innere Bereich n-leitend war (Abb. 5). Wie bereits von Fuller und Logan [5] beschrieben wurde, ist durch Temperversuche nachweisbar, daß Sauerstoff die n-Dotierung bewirkt. Da Bereiche mit unterschiedlichem Sauerstoffgehalt verschieden stark angeätzt werden, ist es möglich, die schwankende Konzentration dieser Verunreinigung sichtbar zu machen. Die Ätzversuche bieten also eine Möglichkeit, die Abhängigkeit der Sauerstoffkonzentration von der Zieh- und Rotationsgeschwindigkeit sowie vom Kristalldurchmesser zu verfolgen. So deuten z.B. Unregelmäßigkeiten der Streifung auf stärkere Temperaturschwankungen in der Schmelze hin, wenn die Kristalle nach dem Verfahren (A1) gezogen wurden (Abb. 3).

 $^{^1}$ Die Ätzlösung bestand aus 3 Vol. Teilen HNO $_3$ (65%). 1 Volumteil HF (50%) und 10 Volumteilen CH $_3$ COOH (96%). Die Ätzdauer betrug 4 bis 8 Std. Die Schliffe wurden zuvormit Karborundpulver, Körnung 2000, geschmirgelt und mit CP8 (HNO $_3$:HF:CH $_5$ COOH = 5:3:3 Volumteile) blankgeätzt. Zur Beleuchtung diente eine Tischlampe.

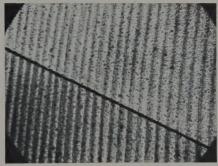
Eine Verminderung dieser Inhomogenitäten brachdas Verfahren (A2). Durch die Graphitumkleidung ar es möglich, die Temperaturverhältnisse so zu benflussen, daß die streifige Struktur verschwand. Nur ischlechter Zentrierung traten wieder Dotierungshwankungen auf, wie an einem Längsschliff in bb. 4 gut zu erkennen ist. Der entsprechende Querhliff wird in Abb. 5 gezeigt.

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, daß trotz des uerstofffreien Schutzgases ($\rm H_2$) [16] der aus dem iegelmaterial von der Schmelze aufgenommene uerstoff in solchen Mengen eingebaut wurde, daß er ch elektrisch bemerkbar machte und die Inhomogeniten verursachte. Es ist bekannt, daß O₂ bis zu onzentrationen von $10^{18}/\rm cm^3$ aufgenommen werden nn, wie durch Absorptionsmessungen im Ultraroten i 9,1 μ von Kaiser, Keck und Lange [6] bewiesen urde.

H2 als Schutzgas erwies sich also als ungeeignet, da nerseits die Homogenität der Kristalle fraglich erhien und andererseits nachfolgende Wärmebehandngen auch den Widerstand unkontrollierbar veradern konnten [5]. Als Ursache wurde der Sauerstoffhalt nachgewiesen. Um die Konzentration dieses örstoffs weitgehend herabzusetzen, mußte auf hutzgas überhaupt verzichtet werden, da auch bei rgon die gleichen Schwierigkeiten auftraten. Wentlich günstigere Ziehbedingungen waren unter ochvakuum zu erwarten. Nach Schäfer und ÖRNLE [14] beträgt der Dampfdruck von SiO bei 12° C, dem Schmelzpunkt von Silizium, bereits etwa Torr, so daß sich eine Verdampfung von SiO aus er Schmelze beim Ziehen der Kristalle unter Schutzs bei Atmosphärendruck bereits bemerkbar macht [5]. So ist die Bildung der p-Haut auf den Siliziumistallen mit hoher Sauerstoffkonzentration, die zur vpumkehr im Innern der Kristalle führt, darauf rückzuführen. Wie Kaiser und Breslin zeigten, ht die Gleichgewichtseinstellung des Sauerstoffs vischen Gasphase und Schmelze über die Verbinmgsbildung SiO, so daß bei Erhöhung der Vermpfungsgeschwindigkeit von SiO durch Druckniedrigung eine wirksamere Reduzierung der Saueroffkonzentration zu erreichen ist.

Die Herstellung der Kristalle geschieht am zweckäßigsten im Hochvakuum von 10^{-4} bis 10^{-5} Torr. Es nnen hierfür zwar die Anlagen A1 und A2 verendet werden. Da bei den niedrigen Drucken aber ch Silizium merklich verdampft und in der Nähe findliche Apparateteile mit Schichten bedeckt, die i größeren Dicken abzuplatzen beginnen und die hmelze stören, wurde die entsprechend dimensioerte Apparatur A3 (Abb. 2) benutzt. Der Übergang der Widerstandsheizung brachte den Vorteil mit h, daß durch Strahlenschutzbleche die Wärmerteilung der Si-Schmelze in gewünschtem Maße einflußt werden konnte. Durch geeignete Führung s Ziehprozesses (Umdrehungszahl, Ziehgeschwindigit, Durchmesser des Kristalls) war es in dieser Anlage iglich, die Sauerstoffkonzentration so weit zu senken, ß Widerstandsänderungen nicht mehr festzustellen ren. Die Folge war eine homogene Widerstandsrteilung über den gesamten Querschnitt.

Mit der Vakuumanlage konnte auch die Frage der inheit von anderen Störstoffen geklärt werden. Absehen vom durch das Vakuumziehen stark reduzierten Sauerstoffgehalt gelangen auch andere Störstoffe durch Auflösung des Tiegels in die Schmelze. Es ist vor allem Bor, das p-dotierend wirkt und wegen



Abb, 4. Querstreifung als Folge von Dotierungsschwankungen auf einem geätzten Längsschliff eines in H, mit Graphitmantel gezogenen Sillzium kristalls. 70fach vergrößert



Abb. 5. Widerstandsschwankungen, sichtbar gemacht auf einem angeätzten Querschliff, zum Kristall in Abb. 4 gehörend. 70fach vergrößert

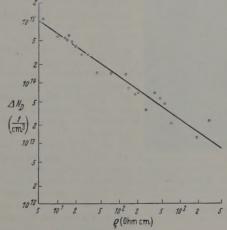


Abb. 6. Donatorenzunahme AN_D durch Temperung als Funktion des Ausgangswiderstandes ϱ von in H, gezogenen Si-Kristallen. Temperung 2 Std bel 450° C in H $_2$ -Atmosphäre

seines Segregationskoeffizienten von etwa 0,9 sich beim langsamen Erstarren des Kristalls nur geringfügig entmischt und in der Restschmelze anreichert. Die maximale Reinheit der Einkristalle ist also bei sehr hochohmigem Ausgangsmaterial durch die Tiegelverunreinigungen bedingt. Mit den heute erhältlichen Quarztiegeln waren spezifische Widerstände bis etwa

 $1000~\Omega \mathrm{cm}$ erreichbar. Andere dotierend wirkende Störstoffe (Al, P) sind weniger von Einfluß. Einerseits entmischen sie wesentlich besser wegen eines um Zehnerpotenzen kleineren Verteilungskoeffizienten und andererseits ist die Verdampfungsgeschwindigkeit im Hochvakuum sehr groß, wie von Bradshaw und Mlawsky [7] nachgewiesen wurde.



Die auch stets zu beobachtende Widerstandserhöhung von in ${\rm H_2}$ gezogenen Kristallen durch Temperung bei 450° C kann auf eine Donatorbildung durch den im Kristallgitter eingebauten Sauerstoff [6] zurückgeführt werden. Der

Vorgang hierbei und die Natur der Störzentren ist bis jetzt noch nicht völlig geklärt. Die Konzentrationszunahme der Donatoren erwies sich nun als sehr stark von der Borkonzentrationabhängig. In Abb. 6 wurde die Donatorzunahme durch eine 2stündige Temperung bei 450° C als Funktion des spezifischen Widerstandes vor der Temperung aufgetragen. Man ersieht daraus, daß Bor bei der Donatorbildung durch den Sauerstoff beteiligt ist. FULLER und DOLEIDEN [10] sowie ROBERTS und WILSON [11] nehmen zur Er-

Abb. 7. Unter Beleuchtung bei Zimmertemperatur ange-

bei Zimmertemperatur angeätzter Si-Kristall. Der helle Streifen kennzeichnet eine Zwillingsbildung, Gegen das Kristallende zu ist der Übergang zu polykristallinem Wachstum zu erkennen. klärung ihrer Versuchsergebnisse ebenfalls eine Wechselwirkung zwischen Sauerstoff und Bor sowie zwischen Sauerstoff und Verunreinigungen von Schwermetallen an, die als Rekombinationszentren wirken. Ebenso wurde über eine Verbindungsbildung zwischen Lithium und Bor von Reiss u. Mitarb. berichtet [9].

$Die\ Versetzungsdichte$

Der zweite wichtige Gesichtspunkt bei der Si-Einkristallzucht ist die Störungsfreiheit des Gitteraufbaus. Es sind Kristalle erwünscht, die möglichst

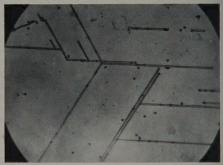


Abb. 8. Nachweis von Gleitlinien und Versetzungen auf einem Querschlift eines in (111)-Richtung gezogenen Si-Kristalls. 70fach vergrößert



Abb. 9. Ausbildung von Versetzungen als Folge einer stärkeren Erschütterung der Schmelze. 100fach vergrößert

niedrige Dichten von Stufenversetzungen aufweisen, ganz abgesehen von polykristallinen Störungen. Von Dash wurde berichtet, daß es gelungen ist, versetzungsfreie Kristalle herzustellen, allerdings mit sehr geringem Durchmesser [12].

Die beschriebenen Ziehverfahren eignen sich in recht verschiedener Weise zum Ziehen möglichst störungsfreier Kristalle. Das Hauptproblem besteht darin, die Wachstumsfläche eben zu halten, um die Bildung von Versetzungen durch thermische Spannungen während des Abkühlprozesses zu verhindern. Es gelten hier dieselben Überlegungen wie sie bei der Zucht von Germaniumeinkristallen bereits diskutiert wurden [8]. Die Anlage A3, die hochfrequente Störungen ausschloß und die geeignetste Wärmeverteilung zu ermitteln gestattete, erwies sich als sehr brauchbar und es war möglich, Versetzungsdichten bis zu etwa 100 pro cm² herab bei Durchmessern von 10 bis 12 mm zu erhalten.

Zur Prüfung der Versetzungsdichte erwies sich das etwas modifizierte Ätzverfahren von Dash als ganz sonders günstig. Durch Hinzunahme einer geeignen Beleuchtung konnten nicht nur die Ätzgruben, also e Durchstoßpunkte der Stufenversetzungen durch



b. 10. Sichtbarmachung dreier verschieden orientierter Bereiche in em Siliziumkristall durch Beleuchtung während des Ätzens mit der Dash-Lösung. 70fach vergrößert

e Oberfläche, reproduzierbar sichtbar gemacht weren, sondern auch Gleitlinien, Zwillingsbildungen w. [4]. Einen Eindruck dieser Methode möge die bb. 7 vermitteln. Sie zeigt deutlich alle diese Stöngen. Gleitlinien werden in der Abb. 8 veranschauht. Man beachte, daß sie jeweils von zwei durch zegruben angezeigte Versetzungslinien begrenzt erden.

Neben der ebenen Wachstumsfläche (in Abb. 7 als uerstreifung zu erkennen) ist eine unerläßliche Vorassetzung für das ungestörte Wachstum eine weithende Erschütterungsfreiheit, die bei der Anlage (3) leicht realisiert werden konnte. Abb. 9 zeigt die ark erhöhte Versetzungsdichte nach einer stärkeren rschütterung.

Abschließend sei noch ein Vergleich zwischen den vei üblichen Nachweismethoden für plötzliche Orienerungsänderungen wie z.B. Zwillingsbildungen anführt. Abb. 10 gibt eine Stelle im Kristall wieder, i der drei verschieden orientierte Bereiche zusamengestoßen und polykristallin weitergewachsen sind. ie unter dem Mikroskop nach der Dash-Ätzung verhieden hell erscheinenden Bereiche lassen sich gut nterscheiden. Gleichzeitig zeigen auch hier die tzgruben die Stufenversetzungen an. Unter diesen tzbedingungen sind die freigelegten Kristallebenen ihrer Flächenausdehnung zu klein, um die Orienerung der Bereiche mittels Goniometer messen zu onnen. Anders liegen die Verhältnisse bei der bevorigend ätzenden NaOH-Lösung, die größere (111)lächen frei legt, wie aus Abb. 11 zu entnehmen ist. ie verschiedenen Bereiche können hier gut unterschieden und zur Orientierung herangezogen werden. Allerdings müssen wir dabei auf die gleichzeitige Sichtbarmachung von Versetzungen verzichten.

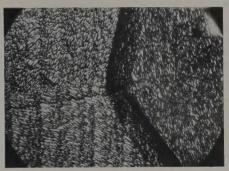


Abb. 11. Sichtbarmachung dreier verschieden orientierter Bereiche durch Anätzen mit NaOH. 70fach vergrößert

Zusammentassung

Es werden Ergebnisse der Siliziumeinkristallzucht aus dem Tiegel diskutiert im Hinblick auf die Homogenität des spezifischen Widerstandes und die niedrige Versetzungsdichte. Es zeigte sich, daß Schutzgase zugunsten des Hochvakuums abgelehnt werden müssen. Nur unter dieser Bedingung sind Forderungen, wie höchste Reinheit und homogene Widerstandsverteilung längs des Kristalls und über den Querschnitt, erfüllbar. Die zur Prüfung erforderlichen Methoden werden diskutiert und über eine Verfeinerung des Ätznachweises von Versetzungen und anderen Störungen des Kristallgefüges berichtet.

Literatur: [1] Marshall, K. H. J. C., and R. Wickham: J. Sci. Instrum. 35, 121 (1958). — [2] Logan, R. A., and A. J. Peters: J. Appl. Phys. 28, 1419 (1957). — [3] Dash, W. C.: J. Appl. Phys. 27, 1193 (1956); 29, 228, 736 (1958). — [4] Greger, G.: Z. phys. Chem., N.F. 22, 313 (1959). — [5] Fuller, C. S., and R. A. Logan: J. Appl. Phys. 28, 1427 (1957). — Kaiser, W., and C. D. Thurmond: J. Appl. Phys. 30, 427 (1959). — [6] Kaiser, W., Keck and Lange: Phys. Rev. 101, 1264 (1956). — [7] Bradshaw, S. E., and L. J. Mlavsky: J. Electronics 2, 134 (1956). — [8] Penning, P.: Philips Res. Rep. 13, 79 (1958). — [9] Reiss, H., C. S. Fuller and A. J. Pietreuskiewicz: J. Chem. Phys. 25, 650 (1956). — [10] Fuller, C. S., and F. H. Doledden: J. Appl. Phys. 29, 1264 (1958). — [11] Roberts, D. H., and B. L. H. Wilson: J. Appl. Phys. 30, 448 (1959). — [12] Dash, W. C.: J. Appl. Phys. 29, 736 (1958). — [13] Kaiser, W., and J. Breslin: J. Appl. Phys. 29, 1292 (1958). — [14] Schäfer, H., u. R. Hörnle: Z. anorg. alg. Chem. 263, 261 (1950). — [15] Kaiser, W.: Phys. Rev. 105, 1751 (1957). — [16] Beschreibung des Reinigungsverfahrens bei: F. R. Meyer u. G. Range, Angew. Chem. 52, 637 (1939).

 $\begin{array}{c} \text{Dr. Gottfried Greger,} \\ \text{Standard Elektrik Lorenz AG., Bauelementewerk SAF,} \\ \text{Nürnberg} \end{array}$

Zur Einleitung des elektrischen Überschlags im Vakuum

Von Wolfgang Edgar Meyer

(Eingegangen am 8. August 1960)

Die Frage nach dem Einleitungsprozeß für elekische Überschläge im Hochvakuum ($p < 10^{-3}$ Torr) ird bis heute von verschiedenen Autoren recht unter-

schiedlich beantwortet. In einer ausführlichen neueren Arbeit von A.S. Denholm [1] werden unter anderem einige der vorgeschlagenen Mechanismen verglichen und an Hand fremder und eigener Meßergebnisse geprüft. Dabei erweist sich eine einfache, von L. CRAN-BERG [2] entwickelte Arbeitshypothese als recht tragfähig.

Cranberg nimmt an, daß kleine leitende Partikel unter der Wirkung des elektrischen Feldes von einer Elektrode zur anderen gezogen werden und dort die Aufschlagstelle so stark erhitzen, daß sie zum Ausgangspunkt eines Funkens wird. Zur Deutung des Prozesses geht er von der Annahme aus, daß ein Überschlag dann entsteht, wenn die vom Teilchen pro Flächeneinheit übertragene Energie W einen kritischen Betrag W_{kr} überschreitet. Die Energie W ist gegeben als Produkt aus der durchlaufenen Spannung U und der Flächenladungsdichte Q des Teilchens. Q ist proportional der Feldstärke E an der Ausgangselektrode, so daß als Zündbedingung gilt

$$UE \ge C \quad \text{mit} \quad C \sim W_{kr}.$$
 (1)

Für ein annähernd homogenes Feld zwischen Elektroden mit dem Abstand d ergibt sich daraus

$$U^2 \ge Cd. \tag{2}$$

Aus Messungen zahlreicher Autoren erhält Cranberg eine gute Bestätigung dieses Zusammenhanges über einige Größenordnungen von U und d mit dem Zahlenwert

$$C \approx 6 \cdot 10^{10} \, \frac{\mathrm{V}^2}{\mathrm{cm}} \,. \tag{3}$$

Im folgenden soll die quantitative Durchführung der Hypothese in dem Sinn verbessert werden, daß die zunächst willkürliche Annahme einer kritischen Energie pro Flächeneinheit vermieden und die Größenordnung von C aus dem Modell selbst abgeschätzt wird.

Die Oberflächenladung eines leitenden Teilchens im elektrischen Feld ist gegeben durch

$$q=\varepsilon_0 \smallint_f \mathfrak{E}\, d\mathfrak{f}\,.$$

Für eine auf einer ebenen Elektrode aufsitzende Halbkugel vom Radius R kann q streng berechnet werden (leitende Kugel im homogenen Feld). Ist E die ungestörte, makroskopische Feldstärke, so erhält man

$$q = \varepsilon_0 \, 3\pi \, R^2 E$$
.

Für eine auf der Elektrode aufsitzende Vollkugel liefert eine grobe Abschätzung

$$q = \varepsilon_0 \, 4\pi \, R^2 E. \tag{4}$$

Nicht zu große Abweichungen von der Kugelform sowie Oberflächenrauhigkeiten ändern (4) nur geringfügig. Man erhält damit für die Energie des Teilehens nach Durchlaufen der Spannung ${\cal U}$

$$w_1 = \varepsilon_0 \, 4\pi \, R^2 \, UE. \tag{5}$$

Beim Auftreffen wird zunächst die Berührungsfläche zwischen Teilchen und Elektrode erhitzt um eine Temperaturdifferenz ΔT . Ist Δl die Dicke der

erhitzten Schicht, e die mittlere spezifische Wärme von Teilchen- und Elektrodenmaterial und ϱ die mittlere Dichte, so wird zur Erhitzung die Energie

$$w_2 = 2\pi R^2 c \rho \Delta l \Delta T \tag{6}$$

benötigt. Dabei wurde die erhitzte Fläche zu $2\pi R^2$ angenommen, was vermutlich ein zu kleiner Wert ist. Nimmt man an, daß die gesamte Energie des Teilchens für die Erhitzung verbraucht wird, setzt man also $w_1=w_2$, so folgt

 $UE = \frac{c \varrho \, \Delta l \, \Delta T}{2 \, \varepsilon_0} \,. \tag{7}$

Soll sich ein Funken von der Aufschlagstelle aus entwickeln, so muß die Temperaturdifferenz ΔT unmittelbar nach dem Aufschlag sicher so hoch sein, daß die verdampfenden Atome wenigstens teilweise ionisiert sind. Aus der Saha-Gleichung erhält man dafür Temperaturen um $10\,000^{\circ}$ C. Die Dicke Δl der erhitzten Schicht muß wenigstens einige Atomlagen, also etwa 10^{-7} cm betragen. Mit den z.B. für Eisen geltenden Werten $c \approx 0,1$ cal/g·Grad und $\varrho \approx 8$ g/cm³ ergibt sich dann aus Vergleich von (1) und (7)

$$C \gtrsim \frac{c \varrho \, \varDelta \, l_{\rm min} \, \varDelta \, T_{\rm min}}{2 \, \epsilon_0} \approx 2 \cdot 10^{10} \, \frac{\rm V^2}{\rm cm} \, . \tag{8}$$

Der Vergleich mit (3) zeigt die größenordnungsmäßige Übereinstimmung mit dem empirischen Wert.

Das Modell von Cranberg liefert also außer dem richtigen Zusammenhang zwischen U und E (wobei E immer die höchste makroskopische Feldstärke zwischen den Elektroden ist) auch eine relativ gute numerische Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen.

Für vorbehandelte (geglühte und abgefunkte) Elektroden liegt der empirische Wert von C merklich höher. Dies wird von Denholm so gedeutet, daß sich bei sauberen Elektroden kleine Partikel aus mikroskopischen Vorsprüngen der Oberfläche unter der Wirkung von Vorstrom-Erhitzung und Zug des elektrischen Feldes neu bilden und schließlich ablösen. Dazu bedarf es höherer Feldstärken und einer gewissen "Inkubationszeit". Die oft recht stark verzögerten Überschläge nach Anlegen der Spannung an vorbehandelte Elektroden werden auf diese Weise verständlich.

Zusammenfassung

Ein Modell von Cranberg zur Deutung der Spannungs- und Feldstärke-Abhängigkeit von Überschlägen im Vakuum wird präzisiert. Eine grobe Abschätzung der charakteristischen Konstanten $C \le UB$ liefert einen Wert in der empirisch gefundenen Größenordnung.

Literatur: [1] Denholm, A. S.: Canad. J. Phys. 36, 476 (1958). — [2] Cranberg, L.: J. Appl. Phys. 23, 518 (1952)

Dipl.-Phys. Wolfgang Edgar Meyer, VALVO-GmbH., Bildröhrenfabrik, Aachen-Rothe Erde